



ใบรับรองวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ

เรื่อง การใช้คลิปไมโครเวฟเหนี่ยวนำให้เกิดการแอดไไมเซลลาร์ พอลิเมอร์เชิงของพอลิไอโซพรีนสำหรับการปรับปรุงผิวชิลิกา
โดย นายธีรศักดิ์ ใจซื่อตรง

ได้รับอนุมัติให้นับเป็นล้านหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเดิม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(อาจารย์ ดร. มงคล หวังสติตย์วงศ์)

13 ตุลาคม 2549

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิรอาช พงศ์ประภูร)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรพร ผลการกุล)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวิตร จันทรานุภาพ)

การใช้คลื่นไมโครเวฟเหนี่ยวนำให้เกิดการแอดไไมเซลลาร์ พอลิเมอร์ เชือข้องพอลิไอโซพรีน
สำหรับการปรับปรุงผิวชิลิกา

นายธีรศักดิ์ ใจซื่อตรง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวกรรมเคมี ภาควิชาชีวกรรมเคมี
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2549
ISBN 974-19-0847-7
ลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อ : นายธีรศักดิ์ ใจฟื้นดวง
ชื่อวิทยานิพนธ์ : การใช้คลีนไมโครเวฟเหนี่ยวนำให้เกิดการแอดไไมเซลาร์ พอลิเมอร์เชชันของพอลิไอโซพրีนสำหรับการปรับปรุงผิวชิลิกา
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มิราภูร์ พงศ์ประยูร
ปีการศึกษา : 2549

บทคัดย่อ

ชิลิกานิยมใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ เชิงกลโดยผิวของชิลิกาประกอบด้วยหมู่ไฮโลกเซนและไซเลนอลซึ่งมีคุณสมบัติทำให้พื้นผิวมีความเป็นข้าและเป็นการดีทำให้ดูดซับความชื้นได้ดีและส่งผลกระทบต่อการยับยั้งการวัลภาในร์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการเคลือบผิวชิลิกาด้วยนาโนฟิล์มพอลิไอโซพรีนโดยอาศัย คลีนไมโครเวฟให้ความร้อนแก่ระบบ สำหรับเทคนิคแอดไไมเซลาร์พอลิเมอร์เชชัน โดยชิลิกา ที่ทำการปรับปรุงผิวจะนำมาวิเคราะห์สมบัติทางเคมีต่างๆ ได้แก่ การทดสอบไฮdrophobicity (Hydrophobicity Test) พูเรียร์ทรายฟอร์มอินฟราเรดスペคโตรสโคป (FTIR) สะแกนนิ่ง อิเล็คตรอนไมโครสโคป (SEM) ทรายสมิชันอิเล็คตรอนไมโครสโคป (TEM) ยูวีสเปคโตรสโคป (UV) และวิเคราะห์การสกัดด้วยตัวทำละลาย (Extraction Analysis) จากผลการวิเคราะห์สมบัติ ทางเคมีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการสังเคราะห์ฟิล์มพอลิไอโซพรีนบนผิวชิลิกา เมื่อทำการเปรียบเทียบผลที่ได้กับการปรับปรุงผิวของชิลิกาโดยใช้การให้ความร้อน พบว่า การใช้คลีนไมโครเวฟส่งผลทำให้ปริมาณการใช้ตัวเริ่มและเวลาการทำปฏิกิริยาลดลง โดยปริมาณการเกิดฟิล์มพอลิไอโซพรีนบนผิวชิลิกาที่ใช้การฉายคลีนไมโครเวฟเป็นตัวเหนี่ยวน้ำ มีค่ามากสุดเท่ากับ 35.3 % เมื่อใช้ปริมาณไอโซพรีน 0.8 มิลลิลิตร ที่กำลังการฉายคลีนไมโครเวฟ 850 วัตต์เป็นเวลา 30 วินาที ในขณะที่ระบบที่ใช้การให้ความร้อนจะให้ปริมาณการเกิดฟิล์ม พอลิไอโซพรีนบนผิวชิลิกาเท่ากับ 17% ที่ปริมาณไอโซพรีน 0.8 มิลลิลิตร

นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ผ่านการปรับปรุง ผิวโดยใช้การฉายคลีนไมโครเวฟเป็นตัวเหนี่ยวน้ำเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติที่ผ่านชิลิกา ที่ผ่านการปรับปรุงผิวโดยใช้การให้ความร้อน โดยสมบัติเชิงกลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ เวลา ในการคงรูป การวัดแรงฉีกขาด การวัดแรงดึงจนขาด ค่า 300% โมดูลัส ระยะยืดจนกระแท้ขาด และค่าการสูญเสียเนื่องจากการขัดถู พบว่ายางธรรมชาติที่ผ่านชิลิกาที่ผ่านการปรับปรุงผิว โดยใช้การฉายคลีนไมโครเวฟเป็นตัวเหนี่ยวน้ำจะมีค่าสมบัติเชิงกลดังนี้ เวลาในการคงรูป เท่ากับ 3.01 นาที ค่าแรงฉีกขาดเท่ากับ 55.25 กิโลกรัม/เซนติเมตร ค่าการวัดแรงดึงจนขาด เท่ากับ 109.93 กิโลกรัม/เซนติเมตร² ค่า 300% โมดูลัสเท่ากับ 28.83 กิโลกรัม/เซนติเมตร²

ระยะีดจันกระทั้งขาดเท่ากับ 670.33% และค่าการสูญเสียเนื่องจากการขัดถูเท่ากับ 155.63 มิลลิเมตร³ แสดงว่าการใช้เทคนิคแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชันโดยการเหนี่ยวนำด้วยการฉาบเคลือบไมโครเวฟเพื่อให้เกิดพิล์มพอลิไอโซพรีน สามารถพัฒนาสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติได้ดีกว่าการให้ความร้อนในแบบเดิม

(วิทยานิพนธ์มีจำนวนทั้งสิ้น 111 หน้า)

คำสำคัญ : แอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน, การฉาบเคลือบไมโครเวฟ, ศิลปะปรับปรุงผิว,
ยางธรรมชาติ



อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Name : Mr.Teerasak Jaisuetong
Thesis Title : Microwave Radiation Induced Admicellar Polymerization of Polyisoprene for Silica Surface Modification
Major Field : Chemical Engineering
King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
Thesis Advisor : Assistant Professor Dr.Thirawudh Pongprayoon
Academic Year : 2006

Abstract

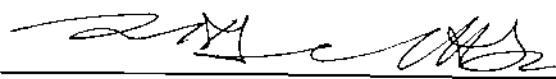
Silica is a basic filler for natural rubber products in order to enhance the mechanical properties. The siloxane and silanol groups of silica deactivate the vulcanization of natural rubber and make the mixing difficult because of the incompatibility between the polar silica surface and the hydrophobic natural rubber surface. To solve these problems, polyisoprene, which has a similar chemical property to the main component of natural rubber (cis-polyisoprene), was coated on the silica surface by microwave radiation induced admicellar polymerization. The modified silicas were characterized by Hydrophobicity Test, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), Ultraviolet Spectroscopy (UV) and Extraction Analysis. In addition, the results confirm that polyisoprene was successfully coated on silica surface by microwave radiation induced admicellar polymerization. The results of silica modified by microwave radiation induced admicellar polymerization were compared with those of silica modified by conventional heating. The results showed that microwave was induced to initiate the admicellar polymerization in order to shorten the reaction time and uniformly generate heat in the system and silica surface modified by microwave radiation induced admicellar polymerization was coated with polyisoprene approximately 35.3% using 0.8 ml isoprene at microwave radiation power 850 watt, 30 second. While the silica surface modified by conventional heating was coated with polyisoprene approximately 17% using 0.8 ml isoprene.

Moreover, the mechanical properties of natural rubber mixed with silica modified by microwave radiation induced admicellar polymerization were examined and compared with those of natural rubber mixed with silica modified by conventional heating induced admicellar polymerization. The cure time, tear strength, tensile strength,

300% modulus, elongation at break and abrasion loss was determined. The properties of the natural rubber mixed with silica modified by microwave radiation induced admicellar polymerization were 3.01 min of cure time, 55.25 kg/cm² of tear strength, 109.93 kg/cm² of tensile strength, 28.83 kg/cm² of 300% modulus, 670.33% of elongation at break and 155.63 mm³ of abrasion loss. Silica surface modified by microwave radiation induced admicellar polymerization of polyisoprene offers greater overall improvements in rubber compound performance than that modified by conventional heating.

(Total 111 pages)

Keywords : Admicellar Polymerization, Microwave Radiation, Modified Silica,
Natural Rubber

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. M. C. A. S."

Advisor

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรารุษ พงศ์ประยูร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนคำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้มาโดยตลอด อีกทั้งยังให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลกรกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวิตร จันทรานุภาพ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการสอบ รวมถึงแก้ไขวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาศิวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ รวมทั้ง นางสาวสุปราวี แสงทอง นักศึกษาภาควิชาศิวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ ที่มีส่วนช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

ขอขอบคุณบริษัท บ้านแพนรีเซอร์ชแล็บบอรา托รี่ จำกัด และ คุณสุภาพ สงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริษัทที่ให้คำปรึกษาช่วยออกแบบแบบสูตรผสมเคมียาง ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ ย่างธรรมชาติ และเครื่องมือทดสอบสมบัติยาง และยังอำนวยความสะดวกที่ในการทดสอบ สมบัติยางธรรมชาติ

ขอขอบคุณ บริษัท สยามชิลิกา จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์สารชิลิกาเพื่อใช้ในโครงการวิทยานิพนธ์นี้

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนจากทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ

ท้ายนี้ผู้วิจัยได้ขอกราบขอบพระคุณมิດ้า มารดา ที่ให้กำลังใจ และให้ความสนับสนุน ในด้านทุนการศึกษามาโดยตลอด หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้ใด ผู้วิจัย ขอขอบความดีทั้งปวงให้แก่มิດ้า มารดา และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ช่วยส่งเสริมให้ผู้วิจัย มีความรู้ ความสามารถ จนสำเร็จการศึกษา

ธีรศักดิ์ ใจชื่อธรรม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๙
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑
กิตติกรรมประกาศ	๒
สารบัญตาราง	๓
สารบัญภาพ	๔
บทที่ ๑ บทนำ	๑
1.1 ปัญหาและที่มา	๑
1.2 วัตถุประสงค์	๒
1.3 ขอบเขตงานวิจัย	๒
1.4 ประโยชน์ของการวิจัย	๓
บทที่ ๒ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๕
2.1 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)	๕
2.2 ซิลิกา (Silica)	๑๑
2.3 สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)	๑๓
2.4 ปฏิกิริยาแอดเมิลลาร์โพลิเมอร์ไซซ์ัน (Admicellar Polymerization)	๑๖
2.5 ไมโครเวฟ (Microwave)	๒๐
2.6 งานวิจัยที่ผ่านมา	๒๓
บทที่ ๓ อุปกรณ์ และวิธีการดำเนินงานวิจัย	๓๓
3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี	๓๓
3.2 วิธีการดำเนินงานวิจัย	๓๕
3.3 การพิสูจน์คุณลักษณะและลักษณะพื้นผิวของซิลิกาที่ได้รับการปรับปรุง ผิวด้วยกระบวนการ แอดเมิลลาร์ พолิเมอร์ไซซ์ัน	๓๗
3.4 วิธีการเตรียมขั้นตอนการสกัดฟิล์มที่เคลือบบนพื้นผิวซิลิกา	๓๘
3.5 วิธีการเตรียมขั้นตอนการผสมเคมียางและขึ้นรูปยาง	๓๙
บทที่ ๔ ผลและวิเคราะห์ผลการทดลอง	๔๑
4.1 ผลของการศึกษาปัจจัยที่มีต่อการกระจายตัวของพอลิเมอร์บนผิวซิลิกา	๔๑
4.2 ผลของการพิสูจน์การมีอยู่ของฟิล์มพอลิไอโซพรีนบนผิวซิลิกา	๔๘
4.3 ผลของการทดสอบสมบัติจำเพาะของยางธรรมชาติ	๕๗
บทที่ ๕ สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	๕๕
5.1 สรุปผลการทดลอง	๕๕
5.2 ข้อเสนอแนะ	๖๖

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
เอกสารอ้างอิง	69
ภาคผนวก ก	73
การศึกษาการดูดซับของสารละลายน้ำที่มีโครงสร้างเคมีในรูปแบบพิเศษและไม่เป็นโครงสร้างเคมี	73
บนผิวชิลิกา	74
ภาคผนวก ข	77
วิธีคำนวณการเตรียมปริมาณสารเคมี	78
ภาคผนวก ค	81
ข้อมูลจากการทดลอง	82
ภาคผนวก ง	95
มาตรฐานการทดสอบย่างวัสดุค้าน้ำ	96
ประวัติผู้วิจัย	111

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 การจัดกลุ่มของย่างตามค่าความด้านทานต่อการขัดถู	
3-1 ปริมาณสารเคมีของการปรับปรุงผ้าชิลิกาในระบบการใช้ความร้อน	36
3-2 ปริมาณสารเคมีของการปรับปรุงผ้าชิลิกาในระบบการฉายคลื่นไมโครเวฟ	36
3-3 ปริมาณสารเคมีของการปรับปรุงผ้าชิลิกาในระบบการเปลี่ยนความเข้มข้น มอนโนเมอร์และตัวริเริ่มที่สภาวะการฉายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที	37
3-4 สูตรปริมาณสารในขั้นตอนการผสมเคมีย่าง	39
3-5 สมบัติในการวิเคราะห์ความจำเพาะของย่างธรรมชาติที่ผสมชิลิกาปรับปรุงผ้า	40
ก-1 ค่าการดูดซับของสารละลายเซทิลไตรเมทธิลแอมโมเนียมในรูปแบบพื้นผิวชิลิกา (CTAB Adsorption Isotherm on Hi-Sil 255) เมื่อใช้ชิลิกา 1 กรัมในระบบของ สารละลาย 20 มิลลิกรัม ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 8 (pH 8)	74
ก-1 แสดงค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่สภาวะด่างๆ ของระบบการใช้ความร้อน	84
ก-2 แสดงค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่สภาวะด่างๆ ของระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ	85
ก-3 แสดงค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่สภาวะต่างๆ ของระบบการใช้กำลังการฉายคลื่น ไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที	85
ก-4 แสดงผลการทดสอบสมบัติการคงรูปของย่างที่ส่วนผสมต่างๆ	90
ก-5 แสดงผลการทดสอบความด้านทานต่อการขัดถูของย่างที่ส่วนผสมต่างๆ	90
ก-6 แสดงผลการทดสอบสมบัติความด้านทานแรงดึงของย่างที่ส่วนผสมต่างๆ	91
ก-7 แสดงผลการทดสอบสมบัติความด้านทานต่อการฉีกขาดของย่างที่ส่วนผสมต่างๆ	91
ก-8 แสดงค่าเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปของชิลิกาที่ผ่านกระบวนการแยกไม่เซลลาร์ พอลิเมอร์เซชันในระบบความร้อนโดยอาศัย การสกัดด้วยตัวทำละลาย THF และ โกลูอีน	92
ก-9 แสดงค่าเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปของชิลิกาที่ผ่านกระบวนการแยกไม่เซลลาร์ พอลิเมอร์เซชันในกระบวนการฉายคลื่นไมโครเวฟโดยอาศัยการสกัดด้วยตัวทำละลาย THF และ โกลูอีน	93
ก-10 แสดงค่าเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปของชิลิกาที่ผ่านกระบวนการแยกไม่เซลลาร์ พอลิเมอร์เซชันในระบบที่เปลี่ยนความเข้มข้นมอนโนเมอร์และตัวริเริ่มที่สภาวะ การฉายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาทีโดยอาศัยการสกัดด้วย ตัวทำละลาย THF และ โกลูอีน	94

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 สูตรໂຄຮ່າງສ້າງທາງເຄີມຂອງຍາງຮຽມຈາດແລະຍາງສັງເກະບໍ່	8
2-2 ການເຊື່ອມໂຍງຂອງໜູ້ອິລິນອລຕ້ວຍພັນະໄໂໂໂຣເຈັນ	13
2-3 ກາຮົກແສດງຜລກາຮູດຫັນຂອງປະຈຸໃນສາງຄົດແຮງດຶງຜົວບັນພື້ນຜົວສັມຜັສທີ່ມີປະຈຸ ຕຽບກັນຫັນ	14
2-4 ລັກນະກາກເກີດ Solubilization	16
2-5 ລັກນະກາກເກີດ Adsolubilization	16
2-6 ຫັນດອນການສັງເກະບໍ່ພິລົມນາງພອລິເມອ່ຈ້າຍປົງກິຈົກຍາ ແລ້ວໄມ່ເໜີລາວົາພອລິເມອ່ ໄຮເຫັນ	17
2-7 ຄຸນສົມບັດຂອງຄລື່ນແມ່ເໜີລົກໄຟຟ້າ	20
2-8 ສປັດຮັມຂອງແສງອາທິດຍີ	21
2-9 ປະເກາຫຂອງຄລື່ນແມ່ເໜີລົກໄຟຟ້າ	21
2-10 ກາພດັດຂວາງກາຍໃນເດາອັນໄມໂຄຣເວັບ	23
3-1 ອລອດທດລອງແລະເຕາອັນໄມໂຄຣເວັບ ຮຸນ MW 102w ຂອງ ທັນຈຸງ	37
4-1 ກາຮົກແສດງຄວາມສັມພັນຮ່ວມກຳກັນກ່າວກາຮູດຄລື່ນແສງຢູ່ວີ ກັບຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນ ມອນອເມອ່ຮ່ວມກຳຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນຂອງດ້ວຍເຮີມຕ່າງໆ ໃນຮະບນການໃຊ້ຄວາມຮັອນ	42
4-2 ກາຮົກແສດງຄວາມສັມພັນຮ່ວມເປົ້ອງເຫັນດີ້ນ້ຳໜັກທີ່ຫຍາຍໄປກັບຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນ ມອນອເມອ່ຮ່ວມກຳຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນຂອງດ້ວຍເຮີມຕ່າງໆຂອງສປາວະການໃຊ້ຄວາມຮັອນໂດຍໃຊ້ THF ເປັນສາງສັກດ	42
4-3 ກາຮົກແສດງຄວາມສັມພັນຮ່ວມເປົ້ອງເຫັນດີ້ນ້ຳໜັກທີ່ຫຍາຍໄປກັບຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນ ມອນອເມອ່ຮ່ວມກຳຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນຂອງດ້ວຍເຮີມຕ່າງໆ ຂອງສປາວະການໃຊ້ຄວາມຮັອນ ໂດຍໃຊ້ Tolueneເປັນສາງສັກດ	43
4-4 ກາຮົກຄວາມສັມພັນຮ່ວມກຳກັນກ່າວກາຮູດຄລື່ນແສງຢູ່ວີ ກັບເວລາກາຈາຍຄລື່ນໄມໂຄຣເວັບ ທີ່ກໍາລັງກາຈາຍຄລື່ນໄມໂຄຣເວັບຕ່າງໆ ໃນຮະບນການໃຊ້ຄລື່ນໄມໂຄຣເວັບ	44
4-5 ກາຮົກຄວາມສັມພັນຮ່ວມເປົ້ອງເຫັນດີ້ນ້ຳໜັກທີ່ຫຍາຍໄປ ກັບເວລາກາຈາຍຄລື່ນ ໄມໂຄຣເວັບທີ່ກໍາລັງກາຈາຍຄລື່ນໄມໂຄຣເວັບຕ່າງໆ ຂອງສປາວະການໃຊ້ຄລື່ນໄມໂຄຣເວັບ ໂດຍໃຊ້ THF ເປັນສາງສັກດ	44
4-6 ກາຮົກຄວາມສັມພັນຮ່ວມເປົ້ອງເຫັນດີ້ນ້ຳໜັກທີ່ຫຍາຍໄປກັບເວລາກາຈາຍຄລື່ນ ໄມໂຄຣເວັບທີ່ກໍາລັງກາຈາຍຄລື່ນໄມໂຄຣເວັບຕ່າງໆ ຂອງສປາວະການໃຊ້ຄລື່ນໄມໂຄຣເວັບ ໂດຍໃຊ້ Toluene ເປັນສາງສັກດ	45

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงยูวี กับความเข้มข้นของมอนอเมอร์ และด้วยเริ่มต่างๆ ของสภาวะการใช้กำลังการฉายน้ำในโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที	46
4-8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปกับความเข้มข้น มอนอเมอร์ที่ความเข้มข้นด้วยเริ่มต่างๆ ของสภาวะการใช้กำลังการฉายน้ำในโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที โดยใช้ THF เป็นสารสกัด	47
4-9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปกับความเข้มข้น มอนอเมอร์ที่ความเข้มข้นด้วยเริ่มต่างๆ ของสภาวะการใช้กำลังการฉายน้ำในโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที โดยใช้ Toluenone เป็นสารสกัด	47
4-10 แสดงผลการอย่าน้ำของชิลิกาปรับปรุงผิว (ก) เปรียบเทียบระหว่างชิลิกาปรับปรุง ผิวระบบที่ใช้ความร้อนและชิลิกาที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว, (ข) เปรียบเทียบระหว่าง ชิลิกาปรับปรุงผิวระบบที่ใช้คลื่นไมโครเวฟและชิลิกาที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว	49
4-11 สเปกตรัม FTIR แสดงหมุนฟังก์ชันอลเคนพะของชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว	50
4-12 สเปกตรัม FTIR แสดงหมุนฟังก์ชันอลเคนพะของชิลิกาที่ที่ปรับปรุงผิวด้วย กระบวนการแอดไม่เซลลาร์พอลิเมอไรเซชันในระบบการใช้ความร้อน	50
4-13 สเปกตรัม FTIR แสดงหมุนฟังก์ชันอลเคนพะของชิลิกาที่ที่ปรับปรุงผิวด้วย กระบวนการแอดไม่เซลลาร์พอลิเมอไรเซชันในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ	51
4-14 สเปกตัม UV แสดงค่าการดูดกลืนแสง (ก) ชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว, (ข) พอลิไอ โซพรินท์ที่ได้จากการสกัดจากยางธรรมชาติ, (ค) ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบ การใช้ความร้อน และ (ง) ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ	52
4-15 ลักษณะการกระจายตัวของฟิล์มพอลิไอโซพรินบนผิวของ (ก) ชิลิกาที่ไม่ปรับปรุง ผิว, (ข) ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้ความร้อนและ(ค) ชิลิกาปรับปรุงผิว ในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ	53
4-16 เบอร์เซ็นต์การบ่อนของชิลิกาที่สภาวะต่างๆ (ก) ชิลิกาที่ไม่ได้ปรับปรุง (ข) ชิลิกา ปรับปรุงผิวในระบบการใช้ความร้อน และ (ค) ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้คลื่น ไมโครเวฟ	54
4-17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปกับเบอร์เซ็นต์การบ่อน ของชิลิกาธรรมชาติที่ไม่ปรับปรุงผิว ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้ความร้อน และ ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ	55

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปกับเบอร์เซ็นต์ การบ่อนของซิลิกาทุกๆ สภาวะ	56
4-19 ขนาดของเม็ดซิลิกา (ก) ซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว, (ข) ซิลิกาที่ปรับปรุงผิวในระบบ ความร้อนและ (ค) ซิลิกาที่ปรับปรุงผิวในระบบการฉายคลื่นไมโครเวฟ	57
4-20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการคงรูปของยางกับยางธรรมชาติ สภาวะต่างๆ	58
4-21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานต่อการดึง (Tensile Strength) กับยางธรรมชาติสภาวะต่างๆ	59
4-22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะยืดจนกระแท้ขาด (Elongation to Break) กับยางธรรมชาติสภาวะต่างๆ	60
4-23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 300% มอดูลัส (300% Modulus) กับยางธรรมชาติ สภาวะต่างๆ	61
4-24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) กับยางธรรมชาติสภาวะต่างๆ	62
4-25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสูญเสียจากการขัดถู (Abrasion loss) กับยางธรรมชาติสภาวะต่างๆ	63
4-26 ลักษณะการยึดเกาะกันระหว่างพิล์มพอลิไอโซพรีนบนผิวซิลิกากับเนื้อยางธรรมชาติ (ก) ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว, (ข) ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุง ผิวในระบบการใช้ความร้อน และ (ค) ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวในระบบ การใช้คลื่นไมโครเวฟ	64
ค-1 FTIR Spectra ของซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการการแอดไนเซลลาร์พอลิเมอ ไรเซชันในระบบความร้อน	82
ค-2 FTIR Spectra ของซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการการแอดไนเซลลาร์พอลิเมอ ไรเซชันในระบบการฉายคลื่นไมโครเวฟ	83
ค-3 FTIR Spectra ของซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการการแอดไนเซลลาร์พอลิเมอ ไรเซชันในระบบกำลังการฉายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์เป็นเวลา 30 วินาที	84
ค-4 SEM Photogram ของซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการการแอดไนเซลลาร์พอลิเมอ ไรเซชันในระบบความร้อน	86
ค-5 SEM Photogram ของซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการการแอดไนเซลลาร์พอลิเมอ ไรเซชันในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ	88

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
ก-6 SEM Photogram ของซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการการแอดไมเมเซลลาร์พอลิเมอ ในเรซันในระบบการใช้กำลังการฉายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที 89	
ก-7 TEM Photogram ของซิลิกา (ก) ไม่ปรับปรุงผิว, (ข) ซิลิกาปรับปรุงผิวด้วย กระบวนการการแอดไมเมเซลลาร์พอลิเมอในเรซันในระบบการใช้ความร้อน และ (ค) ซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการการแอดไมเมเซลลาร์พอลิเมอในเรซันในระบบ การใช้คลื่นไมโครเวฟ	90

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ปัญหาและที่มา

ปัจจุบันความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทยางธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย มีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากยางธรรมชาติมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น มีคุณสมบัติ ด้านทานต่อการฉีกขาดสูงทั้งในอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูง มีคุณสมบัติทนต่อแรงดึงแม่ไม้ได้ เดิมสารเสริมแรง แต่การนำยางธรรมชาติมาใช้ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากยางธรรมชาติมีลักษณะ ทางกายภาพที่ไม่สเกียร์ประกอบกับมีสมบัติเชิงกลที่ดี ด้วยเหตุนี้การใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของยาง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แนวทางหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของยางธรรมชาติคือ การเติมสารเติมแต่ง (Filler)

สารเติมแต่งที่มักใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยางมีหลายชนิด เช่น ผงเข้มดำ (Carbon Black) ผงเข้มขาว หรือ ซิลิกา แต่ส่วนมากนิยมใช้ซิลิกาเป็นสารเติมแต่งเนื่องจากมีคุณสมบัติ ช่วยเพิ่มการเสริมแรงและให้ความยืดหยุ่นแก่โครงสร้างของยาง อีกทั้งยังเป็นสารประกอบที่ไม่ให้สี ซึ่งสารเติมแต่งจำพวกผงเข้มดำไม่สามารถทำได้แต่ปัญหาหลักๆ ของการนำซิลิกามาใช้เป็นสารเติมแต่งคือ ความเป็นรูพูนสูงซึ่งทำให้เกิดการดูดซับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีได้ดี อีกทั้งลักษณะโครงสร้างพื้นผิวของซิลิกา ที่ไม่สามารถสร้างพันธะกับหมุฟังก์ชันในยางธรรมชาติได้ เนื่องจากพื้นผิวของซิลิกาประกอนไปด้วยหมุนผิวซิลินอล ซึ่งมีความเป็นข้าว แนวทางหนึ่งที่จะทำให้ซิลิกาสามารถสร้างพันธะกับหมุฟังก์ชันในยางธรรมชาติ และทำให้ซิลิกากับยางธรรมชาติ สามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้คือ การปรับปรุงพื้นผิวซิลิกาก่อนนำไปผสมในยางธรรมชาติ โดยอาศัยปฏิกิริยาแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์ไซซेशัน (Admicellar Polymerization) และเลือกใช้ไอโซพรีนเป็นมอนомер เนื่องจากในยางธรรมชาติมีองค์ประกอบไฮโดรคารบอนของพอลิไอโซพรีนนิดเส้นตรง (Linear cis-1,4- Polyisoprene) มากถึง 99.99% ดังนั้นการเลือกใช้ไอโซพรีนเป็นมอนomer จึงจะสามารถทำให้ซิลิการ่วมเป็นเนื้อเดียวกับยางได้ดีกว่ามอนอมอร์ชนิดอื่นๆ

โดยทั่วไปการปรับปรุงพื้นผิวซิลิกาที่อาศัยปฏิกิริยาแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์ไซซेशัน นิยมใช้ด้วยวิธีรีเมิ่นสารเคมี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการล้างและขั้นตอนการทำจัดของเสีย ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีหนึ่งของการแก้ไขปัญหานี้คือ การเลือกใช้เทคโนโลยี ไมโครเวฟ (Microwave Technology) เนื่องจากเทคโนโลยีไมโครเวฟสามารถช่วยลดปริมาณ การใช้ด้วยวิธีรีเมิ่นที่เป็นสารเคมีให้น้อยลงได้ และยังสามารถลดเวลาของการทำปฏิกิริยาให้น้อยลง

ได้ออกเช่นกัน เนื่องจากพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟจะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยา โดยไปกระตุ้นตัวรีเริ่มปฏิกิริยาให้เกิดความไวในการทำปฏิกิริยา นับเป็นแนวทางใหม่ที่ยังไม่แพร่หลายนักในการนำมาใช้สำหรับกระบวนการ แอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน ดังนั้นในโรงงานวิจัยนี้ จึงได้เลือกใช้พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟเหนี่ยวนำให้เกิดการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน ของพอลิไอโซพรีนสำหรับการปรับปรุงพื้นผิวชิลิกา

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 ศึกษาและทดลองการปรับปรุงพื้นผิวชิลิกา โดยอาศัยกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน โดยใช้คลื่นไมโครเวฟเป็นตัวเหนี่ยวนำให้เกิดการพอลิเมอไรซ์ที่สภาวะต่างๆ

1.2.2 ศึกษาปัจจัยในการเกิดปฏิกิริยาแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน ที่มีผลต่อการกระจายตัวของพอลิเมอร์บนพื้นผิวชิลิกา

1.2.3 ศึกษาและวิเคราะห์การมีอยู่ของฟิล์มที่เคลือบบนพื้นผิวชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุง

1.2.4 ศึกษาและทดสอบผลการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางกายภาพ ของยางธรรมชาติ ที่เดิมชิลิกาปรับปรุงผิวที่เตรียมได้เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติทั่วไป

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

1.3.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน รวมทั้งผลงานวิจัยที่ผ่านมา

1.3.2 ทำการทดลองปรับปรุงพื้นผิวชิลิกา โดยเปรียบเทียบระบบที่ใช้ความร้อนกับระบบที่ใช้คลื่นไมโครเวฟเหนี่ยวนำให้เกิดกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชันที่สภาวะต่างๆ

1.3.3 ทำการทดลองเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัว ของพอลิเมอร์บนพื้นผิวชิลิกา ประกอบด้วย เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา ความเข้มข้นของตัวเริ่มและกำลังการฉีดคลื่น ไมโครเวฟ

1.3.4 ทำการทดลองเพื่อวิเคราะห์การมีอยู่ของฟิล์มที่เคลือบบนพื้นผิวชิลิกา ที่ได้รับการปรับปรุง ด้วยวิธีต่างๆ เช่น วิเคราะห์ทดสอบความไม่ชอบน้ำ (Hydrophobicity Test) วิเคราะห์ลักษณะหมุนฟังก์ชันด้วย ฟูเรียทรานฟอร์มอินฟาร์สเปคโตรสโคปี (Fourier Transform Infared Spectroscopy : FTIR) วิเคราะห์การดูดกลืนแสงยูวีด้วย ยูวี สเปคโตรสโคปี (UV Spectroscopy) วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวและหาค่าเบอร์เซ็นต์คาร์บอนด้วย สแกนนิงอิเล็คตรอน ในโครงสร้าง (Scanning Electron Microscopy : SEM) วิเคราะห์ขนาดโครงสร้างด้วย ทรานสมิชันอิเล็คตรอนในโครงสร้าง (Transmission Electron Microscopy : TEM) และ วิเคราะห์หาริมาณฟิล์มพอลิไอโซพรีนโดยอาศัยการสกัดด้วยตัวทำละลายต่างๆ

1.3.5 ทำการทดสอบผลการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางกายภาพ ของยางธรรมชาติ ที่เดิมชิลิกาปรับปรุงผิวที่เตรียมได้เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติทั่วไป โดยศึกษา

การเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติต่อไปนี้ แรงที่ใช้ในการฉีกขาด แรงดึง ณ จุดยึดที่กำหนด และในการดึงจนขาด ระยะในการดึงจนกระแท็กขาด การทนต่อการสึกหรอและเวลาที่ใช้ในการคงรูป

1.4 ประโยชน์ของการวิจัย

1.4.1 เป็นการนำเอาเทคโนโลยีในโครงเวฟมาใช้ในการประยุกต์ และขยายขอบเขตของงานในเชิงอุดสาหกรรม เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีคุณภาพดีขึ้น

1.4.2 ทำให้ต้นทุนของวัสดุติดที่ใช้ในการผลิตลดลง เนื่องจากการใช้ในโครงเวฟเป็นตัวเหนี่ยวนำจะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้ตัวริเริ่มที่เป็นสารเคมีได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยการใช้ปริมาณสารเคมีที่น้อยลงนี้จะมีผลทำให้มลพิษที่เกิดขึ้นมีปริมาณลดลง

1.4.3 ทำให้ต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน สำหรับกระบวนการผลิตลดลง เนื่องจากการใช้ในโครงเวฟสามารถช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตได้มากถึง 360 เท่า

1.4.4 ทำให้ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่ผ่านการปรับปรุงมีคุณสมบัติทางกล และทางกายภาพดีขึ้น ส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติมีราคาที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้รายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศมีปริมาณสูงขึ้นตามไปด้วย

บทที่ 2

พฤติกรรมทางวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ยางธรรมชาตินับเป็นวัสดุพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรา และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภcmีความต้องการใช้ยางในรูปแบบ ที่แตกต่างกันออกไป ดังจะพบเห็นผลิตภัณฑ์ของยางในรูปแบบต่างๆ เช่น ถุงมือยาง ยางรัดของ ยางพื้นรองเท้า เป็นต้น แต่การนำยางธรรมชาติมาใช้ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากมีสมบัติเชิงกลต่ำ และมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค แนวทางหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพของยางคือ การเติมสารเติมแต่ง (Filler) จากการศึกษาพบว่า ชิลิกาเป็นสารเติม แต่งที่ให้ความยืดหยุ่นกับโครงสร้างของยางและมีสมบัติที่ไม่ให้สิ่งแข็งเข้ามาร้าบได้ แต่ปัญหาหลักของการนำชิลิกามาใช้เป็นสารเติมแต่งคือ ความเป็นรูพรุนสูงซึ่งทำให้เกิดการ ดูดซับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ประกอบกับลักษณะโครงสร้างของผิวชิลิกาที่ไม่สามารถสร้างพันธะ กับหมุฟังก์ชันในยางธรรมชาติได้ เนื่องจากพื้นผิวของชิลิกาประกอบไปด้วยหมุฟังก์ชันของชิลิกอล ซึ่งมีความเป็นข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการเคลือบผิวชิลิกาด้วยนาโนฟิล์ม พอลิไอโซพրีนเพื่อให้ชิลิกาสามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกับยางธรรมชาติได้ดีขึ้น ซึ่งอาศัย คลื่นไมโครเวฟให้ความร้อนแก่ระบบ สำหรับเทคนิคแอดไมเซลลาร์พอลิเมอร์ไซซัน (Admicellar Polymerization) โดยต่อจากนี้จะขอกล่าวถึงเนื้อหาและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ยางธรรมชาติ ชิลิกา สารลดแรงดึงดูด ปฏิกิริยาแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์ไซซัน คลื่นไมโครเวฟและ งานวิจัยที่ผ่านมา

2.1 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber)

ยางธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ที่มีสมบัติเด่นหลายประการที่วัสดุอื่นไม่สามารถ เก็บนิยมได้โดยเฉพาะสมบัติความยืดหยุ่น (Elasticity) คือ เมื่อให้แรงดึงยางจะสามารถยืดตัว ได้หลายเท่าของความยาวเดิม และเมื่อปล่อยแรงออกยางก็จะกลับคืนสู่รูปร่างและความยาวเดิม นอกจากนี้ยางยังมีสมบัติเด่นอีก อย่าง เช่น มีความเหนียว (Toughness) และความทนทาน ต่อการขัดสี (Abrasion Resistance) สูง สามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำและอากาศได้ มีความสามารถในการยึดติดกับวัสดุอื่นดี เช่น โลหะและสิ่งทอ (เลันไน ผ้าใบ ฯลฯ) ทำให้ สามารถนำยางไปใช้ในงานวิศวกรรมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

องค์ประกอบโดยน้ำหนักของเนื้อยางธรรมชาติคิดเป็น 93-95 % ซีส-1, 4 พอลิไอโซพรีน (cis-1, 4 Polyisoprene), 2-3% โปรตีน, 2 %อะซิโตน-วาชิน ที่ละลายน้ำได้, น้ำ, น้ำตาล และแร่ธาตุเล็กน้อย โดยองค์ประกอบไฮโดรคาร์บอนของยางธรรมชาติประกอบด้วย 99.99 % พอลิไอโซพรีนชนิดเส้นตรง (Linear cis-1,4- Polyisoprene) [1]

2.1.1 สมบัติทั่วไปของยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติมีสมบัติเด่นๆ หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความเหนียวจัดกัน (Tack) ความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength) ความทนทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) หรือ ความยืดหยุ่น (Elasticity) แต่ยางธรรมชาติก็ยังคงมีสมบัติอื่นๆ ที่ทั้งเด่นและด้อยอีกเช่นกัน ดังจะขอกล่าวต่อไปนี้

2.1.1.1 สมบัติเชิงพลวัต (Dynamic Properties) ยางธรรมชาติมีสมบัติเชิงพลวัต ที่ดี ยางมีการสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนต่างระหัวงการใช้งาน นอกจากนี้ยางธรรมชาติ ยังมีความด้านทานต่อการล้าตัว (Fatigue Resistance) ที่สูงมากอีกด้วย [2]

2.1.1.2 Compression Set ยางธรรมชาติมีค่า Compression Set ค่อนข้างต่ำ ที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิสูงปานกลาง อย่างไรก็ตามค่า Compression Set ที่อุณหภูมิต่ำของยางธรรมชาติจะสูงขึ้นเนื่องจากยางอาจเกิดการแตกผลึกทำให้การยืดหยุ่นของยางเริ่มสูญเสียไปในขณะที่ค่า Compression Set ที่อุณหภูมิต่ำของยางธรรมชาติจะมีค่าสูงขึ้น เนื่องจาก ยางธรรมชาติไม่ทนต่อความร้อน ยางจึงเกิดการเสื่อมสภาพ ส่งผลทำให้สมบัติ Compression Set ด้อยลง [2]

2.1.1.3 การกระเด้งกระดอน (Rebound Resilience) ยางธรรมชาติมีสมบัติ การกระเด้งกระดอนสูง แต่ยังด้อยกว่ายางบิวดาไดอิน และในระหว่างการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ยางจะสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนน้อยมาก ยางธรรมชาติจึงมีความร้อนสะสมต่ำเมื่อถูกใช้งานในเชิงพลวัต [2]

2.1.1.4 ความทนทานต่อของเหลวและสารเคมี (Liquid and Chemical Resistance) เนื่องจากองค์ประกอบของยางธรรมชาติเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีข้าว ดังนั้น ยางดิบจึงละลายได้ในตัวทำละลายที่ไม่มีข้าว เช่น โกลูอิน เอกเซน หรือ บีนชิน ความสามารถในการละลายนี้จะลดลงถ้ายางเกิดการคงรูป เนื่องจากการเชื่อมโยงทางเคมีของโมเลกุลเกิดเป็นโครงสร้างตายตัว 3 มิติในยางคงรูปจะไปขัดขวางกระบวนการละลายของยาง ยางคงรูป จึงเพียงแต่เกิดการบรวมตัวในตัวทำละลายเหล่านี้เท่านั้น อย่างไรก็ได้การบรวมตัวของยางดังกล่าว จะทำให้สมบัติเชิงกลของยางด้อยลง ด้วยเหตุนี้ยางธรรมชาติจึงไม่ทนต่อน้ำมันบีโอลีเยมหรือตัวทำละลายที่ไม่มีข้าวต่างๆ แต่ยางจะทนต่อของเหลวที่มีข้าว เช่น อะซิโตน หรือ แอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยางธรรมชาติยังทนต่อกรดและด่างเจือจางได้ดี แต่ไม่ทนต่อกรดในตรีคและการ กำมะถันเข้มข้น [2]

2.1.1.5 การเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อน ไอโ淳 และแสงแดด (Aging Properties) เนื่องจากไม่เกลุขอยางธรรมชาติมีพันธะคู่อยู่มาก ทำให้ยางว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา กับออกซิเจน หรือเรียกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่า ปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยมีแสงแดดหรือความร้อนเป็นตัวร่วงปฏิกิริยา จังหวั้นยางธรรมชาติจะถูกออกซิเดชันได้ด้วย นอกจากนี้ยางธรรมชาติยังไม่ทนต่อไอโ淳 เพราะเมื่อยางถูกยีดและได้รับไอโ淳นานๆ จะเกิดรอยแตกขนาดเล็กจำนวนมากที่บีบร้าวน์พื้นผิวในทิศตั้งฉากกับทิศทางการยืดตัวของยาง ด้วยเหตุนี้ในระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ จึงต้องมีการเติมสารเคมีบางชนิดลงไปเพื่อยืดอายุการใช้งานของยางธรรมชาติ [2]

2.1.1.6 ความด้านทานต่อการขัดถู (Abrasion Resistance) ยางธรรมชาติ มีค่าความด้านทานต่อการขัดถูสูง แต่ยังต้องกว่ายางสไตรีนบิวตาไดอีน (SBR) อ่อนกว่า ไร้ความสามารถ เมื่อเทียบกับยางสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ พนว่า ยางธรรมชาติมีค่าความด้านทานต่อการขัดถูอยู่ในกลุ่มที่สูงมาก [2] ดังแสดงในตารางที่ 2-1

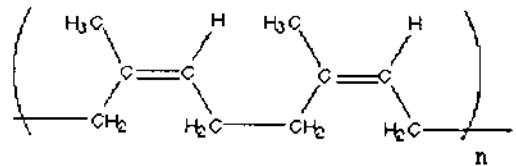
ตารางที่ 2-1 การจัดกลุ่มของยางตามค่าความด้านทานต่อการขัดถู [2]

กลุ่มที่	ความด้านทานต่อการขัดถู	ยาง
1	สูงมาก	ยางโพลิยูเรธาน (AU/EU), ยางบิวตาไดอีน (BR), ยางสไตรีนบิวตาไดอีน (SBR), ยางไนไตรอล (NBR) และยางธรรมชาติ (NR)
2	สูง-สูงมาก	ยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM), ยางคลอรอไพริน (CR)
3	สูง	ยางบิวไทร์ (IIR) และยางเอทธิลไวนิลอะซีเตต
4	ต่ำ	ยางซิลิโคน (Q)

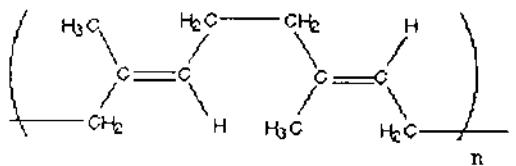
2.1.2 โครงสร้างของยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติมีชื่อทางเคมีคือ ซีส-1, 4-โพลิไอโซพรีน (cis-1, 4-Polyisoprene) กล่าวคือ ในโมเลกุลยาง 1 โมเลกุล จะประกอบด้วยหน่วยของไอโซพรีน (C_5H_8) มาต่อ กันเป็นสายยาวแบบเส้นตรง [1] โดยทั่วไปยางธรรมชาติมีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยอยู่ในช่วง 200,000 ถึง 400,000[2] และมีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลที่กว้างมาก ยางธรรมชาติมีความหนาแน่นเท่ากับ 0.93 g/cm^3 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิของการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Glass Transition Temperature : T_g) ประมาณ -72 องศาเซลเซียส นั่นหมายความว่า

หากนำยางธรรมชาติไปเก็บไว้ที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -72 องศาเซลเซียส สมบัติของยางธรรมชาติจะเปลี่ยนจากที่เคยยืดหยุ่นไปเป็นของแข็งประชันเดียวกันแก้ว



ยางธรรมชาติ (cis-1, 4-Polyisoprene)



ยางสังเคราะห์ (trans-1, 4-Polyisoprene)

ภาพที่ 2-1 สูตรโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ [2]

จากภาพที่ 2-1 จะเห็นว่าใน 1 หน่วยของไอโซพรีน จะมีพันธะคู่และมีหมู่อัลฟามิลีน (α -Methylene) ที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาการคงรูปด้วยกำมะถันออยล์ ดังนั้น พันธะคู่ที่มีอยู่ในโมเลกุลของยางจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคงรูปด้วยกำมะถัน อย่างไรก็ตาม พันธะคู่เหล่านี้ยังทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ได้อีก เช่น ออกซิเจน หรือ โอโซน ทำให้ยางเกิดการเสื่อมสภาพ หรืออาจทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน คลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาง (ที่ดำเนินพันธะคู่) กับสารเคมีต่างๆ เหล่านี้จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

โดยทั่วไปยางธรรมชาติมีโครงสร้างการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบสัมฐาน (Amorphous) แต่ในบางสภาวะ เช่น ที่อุณหภูมิต่ำหรือเมื่อยางถูกยืด โมเลกุลของยางบางส่วนสามารถจัดเรียงตัวได้อย่างชัดเจนเป็นระเบียบ ยางจึงสามารถเกิดผลึก (Crystallize) ได้ การเกิดผลึกเนื่องจากอุณหภูมิต่ำหรือที่เรียกว่า "Low Temperature Crystallization" จะพบในกรณีที่เก็บยางไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานโดยยางจะมีอัตราเร็วในการตกลงผลึกสูงสุดที่อุณหภูมิประมาณ -26 องศาเซลเซียส การตกลงผลึกที่อุณหภูมิต่ำนี้จะทำให้ยางแข็งมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถ捺ยางไปผสมให้เข้ากับสารเคมีหรือสารเติมแต่งอื่นๆ ได้ แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ผลึกที่เกิดขึ้นก็จะถูกทำลาย ยางจะอ่อนตัวลงและกลับสู่สภาพเดิมด้วยเหตุนี้ประเทศในเมืองหนาวจึงต้องนำยางธรรมชาติมาอบที่อุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาเซลเซียส เพื่อทำให้ยางอ่อนก่อนที่จะนำไปใช้ในการกระบวนการผลิตต่อไป ส่วนการเกิดผลึกเนื่องจากการยืดตัวหรือที่เรียกว่า "Strain-Induce Crystallization" จะพบเมื่อยางถูกยืดจนมีความกว้างมากกว่า ความยาวดั้งเดิมประมาณ 2-3 เท่า การเกิดผลึกเนื่องจากการยืดตัวของยาง

จะทำให้ยางมีสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน กล่าวคือ ยางจะเปลี่ยนจากสภาพโปร่งแสง (Transparent) ไปเป็นทึบแสง (Opaque) ซึ่งจะสังเกตได้ง่ายในยางคงรูปที่ไม่มีการเติมสารเติมแต่ง นอกจากนี้การเกิดผลึกเนื่องจากการยืดด้วยการทำให้ยางคงรูปมีสมบัติเชิงกลดีขึ้น นั่นคือยางจะมีความทนทานต่อแรงดึง ความทนทานต่อการฉีกขาด และความด้านทานต่อการขัดถูสูงขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการสังเคราะห์ยาง เพื่อทำการเลียนแบบโครงสร้างให้เหมือนยางธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่า ยางพอลิไอโซพรีน[2] หรือ cis-1, 4-Polyisoprene (IR) เกิดจากความพยายามที่จะสังเคราะห์ยางที่มีโครงสร้างทางเคมีและมีสมบัติเหมือนกับยางธรรมชาติ โดยในปี ค.ศ. 1954 Goodrich ได้ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ยางพอลิไอโซพรีน จากมอนอเมอร์ของไอโซพรีน โดยใช้ด้าวเร่งปฏิกิริยาโพลิเมอร์เซชันชนิด Ziegler-Natta และได้ตั้งชื่อยางชนิดนี้ว่า "Synthetic Natural Rubber" เนื่องจากยางพอลิไอโซพรีนมีโครงสร้างทางเคมีเหมือนยางธรรมชาติยางชนิดนี้จึงมีสมบัติต่างๆ ใกล้เคียงกับยางธรรมชาติมากและสามารถใช้แทนยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ยางชนิดนี้ยังมีหลักการผสมเคมียาง และกระบวนการผลิต เช่นเดียวกับยางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติ ยางพอลิไอโซพรีนจะมีสมบัติเชิงกล เช่น ความทนทานต่อแรงดึงและความทนทานต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายางธรรมชาติเล็กน้อย เพราะยางพอลิ ไอโซพรีนมีสัดส่วนของโครงสร้างแบบ cis- ที่ต่ำกว่ายางธรรมชาติ จึงมีแนวโน้มที่จะแตกผลึกได้น้อยกว่า แต่ข้อดีของยางพอลิไอโซพรีน คือยางมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และยางมีสีขาวสวาย ในขณะที่ยางธรรมชาติ จะมีสีเหลืองอ่อนถึงน้ำตาลเข้มเนื่องจากมีสารเบต้าแครอทีน ทำให้ยางพอลิไอโซพรีนมีราคาที่สูงกว่ายางธรรมชาติ บางครั้งจึงใช้แทนยางธรรมชาติในการผลิตจุกหัวนมและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เพื่อลดอัตราการระคายเคืองของผู้ใช้

2.1.3 การผสมเคมียาง

ยางธรรมชาติโดยทั่วไปแล้วไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้งาน เนื่องจากมีสมบัติเชิงกลต่ำและมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เสถียรซึ่งสมบัติต่างๆ จะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างมาก จึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเนื้อยางโดยการผสมยางกับสารเคมีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยการผสมเคมียางจะเริ่มจาก ขั้นตอนการออกสูตรยาง ขั้นตอนการบดผสมยาง (Mastication : Mixing) หลังจากการผสมเคมียางเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการขึ้นรูปยาง (Forming) และขั้นตอนการทำให้ยางคงรูป (Vulcanization) [2]

2.1.3.1 ขั้นตอนการออกสูตรยาง (Compounding Design)

ขั้นตอนการออกสูตรยางเป็นสิ่งสำคัญมากต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง โดยทั่วไป การออกแบบสูตรยางจะต้องมีความสะดวกและเป็นไปได้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้จึงจะมีคุณภาพดามวิธีการผลิตที่ถูกต้องตลอดจนด้านทุนการผลิตที่ต่ำ ซึ่งอาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่โรงงานอุตสาหกรรมคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปการออกแบบ

สูตรยางจะกำหนดปริมาณสารต่างๆ ในสัดส่วนต่อยาง 100 ส่วน โดยน้ำหนัก และเรียกเป็น phr หรือ pphr (Part per Hundred of Rubber) ซึ่งส่วนผสมหลักๆของการออกสูตรยาง จะประกอบด้วยสารกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สารทำให้ยางคงรูป (Vulcanizing Agent or Curing Agent), สารเติมแต่ง (Filler) นอกนั้นจะเป็นสารช่วยให้ยางมีสมบัติพิเศษอื่นๆ เช่น สารหันไฟ (Flame Retardants), สารป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic Agent) หรือ สารช่วยในการรวมวิธี การผลิต (Processing Aids) เป็นต้น

2.1.3.2 ขั้นตอนการบดผสมยาง (Mastication, Mixing)

เมื่อได้สูตรเคมียางเรียบร้อยก็จะเป็นขั้นตอนการบดผสมยาง ซึ่งยางธรรมชาติมีสมบัติเป็นของแข็งที่มีความเหนียวและความหนืดสูงมาก การผสมสารเคมีให้เข้ากับยางจึงเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ก่อนการผสมสารเคมีจึงต้องทำการบดยางหรือลดความหนืดของยาง โดยการดัดโมเลกุลของยางเพื่อลดน้ำหนักโมเลกุล โดยใช้กระบวนการเชิงกล นั่นคืออาศัยแรงเฉือนในเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง (Two-Roll Mill) ซึ่งขั้นตอนการบดยางเพื่อลดความหนืดของยาง ก่อนผสมเคมียางนี้เรียกว่า “มาสติเคชัน” (Mastication) ปกติการบดยางที่อุณหภูมิต่ำจะให้ประสิทธิภาพการบดที่ดี เพราะยางจะมีความหนืดสูงส่งผลทำให้เกิดแรงเฉือนสูง โมเลกุลยาง ก็จะเกิดการฉีกขาดได้ดีแต่ที่อุณหภูมิสูง ยางจะมีความหนืดลดลง ส่งผลทำให้แรงเฉือนที่เกิดขึ้นในระหว่างการผสมลดลงด้วย ประสิทธิภาพในการบดยางอันเนื่องมาจากแรงเชิงกลจึงลดลง แต่ในบางครั้งก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบดยางที่อุณหภูมิสูงได้เช่นกัน โดยการเติมสารแปปไทด์เซอร์ (Peptizer) ลงไป เพราะสารเคมีดังกล่าวจะไปช่วยทำให้โมเลกุลยางที่ถูกตัดขาดไปแล้วไม่สามารถกลับเข้าไปทำปฏิกิริยารวมตัวกันใหม่ เนื่องจากการบดยางที่มากเกินไป จะทำให้ยางอ่อนเกินไป ส่งผลทำให้ยางไม่สามารถรับสารเติมแต่งได้ในปริมาณมาก ยางคงรูปที่ได้จะมีความยืดหยุ่น สมบัติเชิงกล และสมบัติเชิงพลวัตที่ไม่ดี ดังนั้นการบดยางจึงควรทำเท่าที่จำเป็นหรือใช้เวลาให้น้อยที่สุด

2.1.3.3 ขั้นตอนการขันรูปยาง (Forming) และขั้นตอนการทำให้ยางคงรูป (Vulcanization)

ซึ่งหลังจากการบดและผสมเคมียางเรียบร้อยแล้ว ยางผสมที่ได้นี้จะถูกเรียกว่า ยางคอมโพสต์และจะถูกนำไปขันรูปในแม่พิมพ์ภายใต้ความร้อนและความดัน เรียกกระบวนการนี้ว่า “กระบวนการคงรูปยาง” หรือ “กระบวนการวัลคาไนซ์เซชัน” (Vulcanization) โดยยางที่ผ่านกระบวนการนี้จะเรียกว่า “ยางคงรูปหรือยางสุก” ซึ่งสมบัติของยางคงรูปนี้จะเสถียรขึ้นและมีสมบัติเชิงกลดีขึ้นแม้ว่ายางธรรมชาติสามารถคงรูปได้ด้วยเพอร์ออกไซด์ การใช้รังสีหรือการใช้คลื่นความถี่ที่มีพลังงานสูง แต่ระบบการคงรูปด้วยกำมะถันก็ยังคงเป็นระบบที่ใช้กันมากที่สุด ในอุตสาหกรรมยาง เมื่อเปรียบเทียบกับยางสังเคราะห์ ยางธรรมชาติต้องการปริมาณกำมะถันมากกว่าแต่ต้องการปริมาณสารตัวเร่งปฏิกิริยาน้อยกว่า เพราะในยางธรรมชาติมีสารประกอบอินทรีย์บางตัวที่สามารถเร่งปฏิกิริยาคงรูปได้

2.1.4 การประยุกต์ใช้งาน [2]

ในอดีตยางธรรมชาติจัดเป็นยางเอนกประสงค์ ที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ได้มากมายเนื่องจากยางธรรมชาติมีสมบัติทั้งเชิงกลและพลวัตที่ดี อย่างไรก็ตาม ยางธรรมชาติก็มีข้อด้อยหลักคือ ความไม่ทนต่อความร้อน สภาพอากาศ น้ำมัน หรือสารเคมี อื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ยางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ จึงเริ่มเข้ามา มีบทบาทสำคัญแทนที่ยางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ยางบางประเภทยังคงจำเป็นต้องใช้ยางธรรมชาติเป็นวัสดุในกระบวนการผลิต เนื่องจาก

2.1.4.1 ยางธรรมชาติมีความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Insulation) ที่สูงมาก โดยมีค่าความด้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Specific Resistivity) สูงถึง 10^{15} หรือ 10^{16} ohm.cm จึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น จำนวนหัมสายไฟต่างๆ เป็นต้น

2.1.4.2 ยางธรรมชาติมีสมบัติการกระแทกสะอ่อน (Rebound Resilience) ที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับยางสังเคราะห์ และในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง ยางจะสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนน้อย กล่าวคือ มี Hysteresis ที่ต่ำ จึงทำให้ยางธรรมชาติ มีความร้อนสะสมต่ำ เมื่อถูกใช้งานในเชิงพลวัต ยางชนิดนี้จึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางที่มีขนาดใหญ่ เช่น ยางรถบรรทุกหรือยางล้อเครื่องบิน เพราะหากใช้ยางที่มีความร้อนสะสมสูงก็อาจทำให้ยางเกิดการระเบิดได้ง่าย

2.2 ซิลิกา (Silica)

สารเติมแต่งซิลิกาที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนมากสังเคราะห์มาจากส่วนประกอบของซิลิคอนไดออกไซด์ ซึ่งซิลิกอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติเกิดขึ้นในรูปแบบโครงสร้างผลึกโดยโครงสร้างเป็นลักษณะเรขาคณิต เมื่อทำการระเหยด้วยการเผาซิลิกอนไดออกไซด์จนระเหยเป็นไอ แล้วทำการกลั่นตัวที่อุณหภูมิห้องจะทำให้ได้ซิลิกาที่มีอนุภาคขนาดเล็กมาก เรียกว่าซิลิกา “ฟูม” ส่วนมากซิลิกาฟูมนิยมใช้เป็นสารเสริมแรงในยาง ซึ่งจะทำให้ยางมีสมบัติทันทันต่อการดึงมีสมบัติทันทันต่อการฉีกขาด แต่ข้อด้อยที่พบเมื่อใช้ซิลิกาฟูมในการผสมยางคือ เวลาในการคงรูปนานขึ้น จึงจำเป็นต้องใส่สารเร่งลงไปด้วย นอกจากนี้ยังมีซิลิกาที่ได้จากการตัดตอน ซึ่งจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับซิลิกาฟูม โดยทั่วไปนิยมใช้เป็นสารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการสีหรือโปร่งแสง

2.2.1 กระบวนการผลิต (Precipitated Silica)

โดยทั่วไปซิลิกาที่ได้จากเทคนิคการตัดตอน จะถูกผลิตจากกระบวนการการเปียก (Wet Process) โดยเริ่มต้นจากสารละลายน้ำอัลคาไลน์ซิลิกาต แต่นิยมใช้เดย์มซิลิกาต ซึ่งซิลิกาจะถูกตัดตอนได้โดยการเจิมกรด และควรกว้างพออย่างเร็วในถังทำปฏิกิริยา เพื่อป้องกันการเกิดบริเวณที่มีค่าความเป็นกรด-ต่าง (pH) ต่ำ ซึ่งจะเป็นบริเวณที่จะเกิดเจล (Gelation) ขึ้น

อัตราการเกิดปฏิกิริยาและการเกิดอนุภาค สามารถพิจารณาจากวิธีทางการตัดก้อนในกระบวนการ เมื่อชิ้นกลาสลายจะเกิดเป็นซิลิเกตที่ค่าความเม่นกรด-ด่างสูงกว่า 9 อนุภาค ที่มีขนาดเล็กกว่าจะถูกกลาสลายอย่างต่อเนื่องในระหว่างกระบวนการ ดังนั้นขนาดของอนุภาคที่มีลักษณะเดียวกันจะยังคงอยู่ เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วอนุภาคที่มีขนาดเล็กจะเกิดขึ้นเป็นกลุ่มผ่านโครงสร้างไซโลอกเซน (Siloxane) เกิดเป็นโครงร่างตาข่ายแบบ 3 มิติ ซึ่งจะด้านหน้าต่อแรงอัดในระหว่างการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ และสัดส่วนของสารตั้งต้น เวลาในการทำปฏิกิริยา อุณหภูมิและความเข้มข้น เมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปพื้นที่ผิวของผลิตภัณฑ์ที่ได้จะอยู่ระหว่าง $50-700 \text{ m}^2/\text{g}$ ส่วนโครงสร้างและสมบัติทางเคมี เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความหนาแน่นของหมู่ชิลินอล และสมบัติที่สังเกตได้ด้วยความสามารถควบคุมได้

ส่วนผสมที่ขึ้นชื่อเป็นผลจากการตัดก้อนจะถูกนำไปใช้เครื่องอัดกรอง (Filter Press) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีลักษณะเป็นเค้ก ซึ่งมีของแข็งเป็นส่วนประกอบ 20% โดยน้ำหนัก การเกิดเกลือขึ้นในระหว่างกระบวนการจะถูกกำจัดออกไปในขั้นตอนนี้ด้วย ส่วนน้ำที่หลงเหลืออยู่จะถูกกำจัดออกโดยการระเหย จากนั้นทำให้แห้งโดยการส่งเข้าเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (Spray Driers) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความเป็นทรงกลมมากขึ้น และชิ้นก้อนจะจับตัวกันเป็นกลุ่มหลวมๆ ในที่สุดแล้วผลิตภัณฑ์ที่แห้งแล้วจะถูกนำไปบดและร่อนด้วยตะแกรง เพื่อลดขนาดการเกาะตัวกันของชิลิกาและแยกผลิตภัณฑ์ออกจากสิ่งปนเปื้อน ซึ่งหลังจากการกรอง ล้าง และอบแห้งแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะประกอบไปด้วย 86-88% ชิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) ซึ่งเป็นน้ำ 10-12% โดยครึ่งหนึ่งจะเป็นโครงสร้างทางเคมีของน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของผงแป้งโดยผงอนุภาคชิลิกาจะประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ไมโครเมตร ซึ่งเป็นขนาดการเกาะตัวเป็นกลุ่มของอนุภาคเล็กๆ ขนาด 50 นาโนเมตร

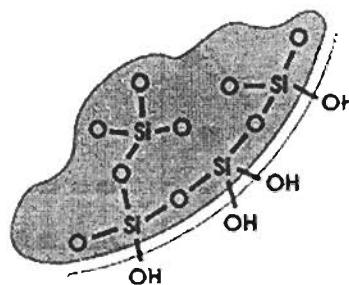
2.2.2 โครงสร้างทางเคมีของชิลิกา (Structure of Silica)

ชิลิกานิยมถูกใช้เป็นสารเติมแต่ง (Fillers) โดยทั่วไปสามารถแบ่งเป็นชิลิกาธรรมชาติ และชิลิกาสังเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย พอลิเมอร์ที่มีความเป็นผลึกสูง (Crystalline Form) และพอลิเมอร์ที่ไม่มีความเป็นผลึกหรืออสัมฐาน (Amorphous Form) ตามลำดับ [3] ซึ่งสารเติมแต่งจำพวกชิลิกาสังเคราะห์ที่ผลิตออกมาจะมีขนาดอนุภาค (Particle Size) และพื้นที่ผิวจำเพาะ (Specific Surface Area) ตามการประยุกต์ใช้งาน

สมบัติที่สำคัญของชิลิกาที่เกี่ยวข้องกับการเสริมแรงในยางคือ ขนาดอนุภาค ชิลิกาที่มีขนาดอนุภาคที่เล็กจะให้ความต้านทานต่อการดึง การฉีกและการเสียดสีที่สูง ขนาดอนุภาคที่แท้จริงต้องน่วຍการเสริมแรงไม่ใช้ขนาดของแต่ละอนุภาค แต่เป็นขนาดของการเกาะตัวกันเป็นกลุ่มอนุภาคที่มีขนาดเล็กจะให้การเกาะตัวกันเป็นกลุ่มที่เล็ก ในขณะที่อนุภาคที่มีขนาดใหญ่จะให้การเกาะตัวเป็นกลุ่มที่ใหญ่ ส่วนความชื้นหรือพันธะไฮดรอกซิลของน้ำ เป็นสมบัติที่สำคัญ

รองลงมาของซิลิกา ซึ่งจะอยู่ในรูปของความหนาแน่นของหมู่ซิลินอลหรือช่องว่างอิสระสำหรับความชื้น

ซิลิกาสามารถพิจารณาเป็นพอลิเมอร์ของกรดซิลิซิก (Silicic Acid) ได้โดยโครงสร้าง 3 มิติ จะเป็นลักษณะการเชื่อมกันของ SiO_4 แบบเตต拉ヘಡรัล (Tetrahedrals) โครงสร้างบริเวณพื้นผิว จะประกอบไปด้วยหมู่ไซโลกเซน (Siloxane : -Si-O-Si) และหมู่ซิลินอล (Silanol : -Si-OH) [3] ดังแสดงในภาพที่ 2-2



ภาพที่ 2-2 การเชื่อมโยงของหมู่ซิลินอลด้วยพันธะไฮโดรเจน [3]

2.3 สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)

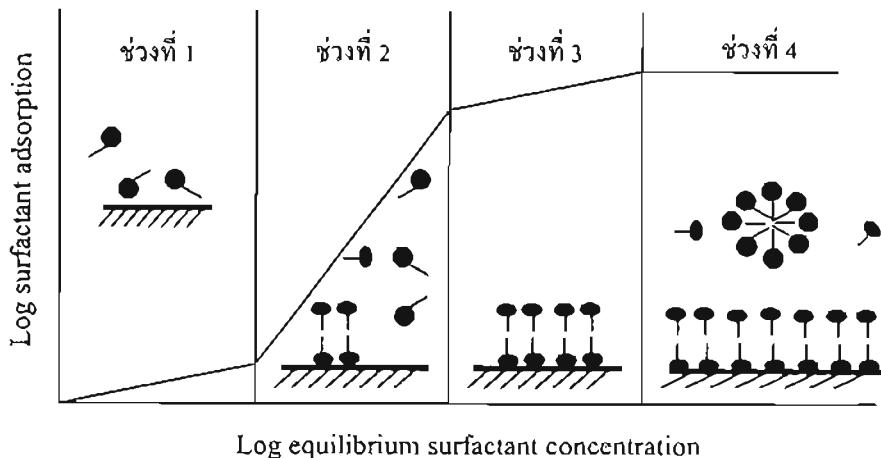
ไม่เลกุลของสารลดแรงตึงผิวประกอบด้วยส่วนหัวที่มีสภาพความเป็นข้าว ประกอบด้วย พากที่สามารถละลายน้ำได้ดี และส่วนหางที่ไม่มีสภาพความเป็นข้าว ประกอบด้วยพากสารอินทรีย์ โดยสารลดแรงตึงผิวสามารถแบ่งตามลักษณะทางธรรมชาติของส่วนที่มีสภาพความเป็นข้าวได้ดังนี้คือ สภาพประจุลบ (Anionic), สภาพประจุบวก (Cationic) และสภาพไร้ประจุ (Nonionic, Zwitterionic) สารลดแรงตึงผิวชนิดสภาพประจุบวกยังสามารถแบ่งกลุ่มได้อีก 2 ประเภท คือ พากที่มีสภาพความเป็นกลาง (Neutral) และพากที่มีสภาพความเป็นกรด (Acidic) [4] โดย เชทิลไตรเมทิลแอมโนเนียมโบโรไนต์ ก็จัดอยู่ในสารลดแรงตึงผิวชนิดสภาพความเป็นกลาง

2.3.1 การดูดซับของสารลดแรงตึงผิว

การดูดซับของประจุในสารลดแรงตึงผิวนั้นผูกพันผูกพังผสานกันข้ามมีผลเกี่ยวข้อง กับหลายกลไก ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดูดซับได้ดังนี้ (1) สภาพโครงสร้าง ตามธรรมชาติบนพื้นผิวที่ใช้สำหรับดูดซับ (2) โครงสร้างทางโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับ (3) สภาวะแวดล้อมของสารละลาย เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง

โดยทั่วไปข้อมูลจากการทำการทดลองเรื่องการดูดซับ จะแสดงผลเป็นกราฟการดูดซับที่ อุณหภูมิคงที่ (Adsorption Isotherm) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนสารลดแรงตึงผิวที่ถูกดูดซับ และค่าความเข้มข้นที่สมดุลของสารลดแรงตึงผิวในสถานะของเหลว

กราฟแสดงผลการดูดซับของประจุ ในสารลดแรงตึงผิวน้ำพื้นผิวสัมผัสที่มีประจุตรงกันข้าม จะมีลักษณะเป็นรูปตัวเอส (S-Shaped) โดยสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ช่วง อาย่างดังเจนดังแสดงในภาพที่ 2-3



ภาพที่ 2-3 กราฟแสดงผลการดูดซับของประจุในสารลดแรงตึงผิวน้ำพื้นผิวสัมผัสที่มีประจุตรงกันข้าม [4]

ช่วงที่ 1 ในช่วงเริ่มดันนี้จะมีค่าความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวในสารละลายต่ำมาก ดังนั้นสารลดแรงตึงผิวจะมีการดูดซับต่ำมากด้วยเช่นกัน โดยส่วนมากจะใช้กฎของเอนริในการอธิบายกราฟการดูดซับช่วงนี้ เนื่องจากแรงกระทำระหว่างโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวมีอยู่เล็กน้อย สารลดแรงตึงผิวที่ถูกดูดซับในช่วงที่ 1 นี้จะเป็นการดูดซับอย่างเดียว ไม่เกิดการเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน

ช่วงที่ 2 จะมีลักษณะเด่นคือ ความเข้มข้นของเส้นกราฟจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบ กับความชันของกราฟในช่วงที่ 1 จากรูปจะแสดงให้เห็นถึงการเริ่มเกิดแรงกระทำระหว่างโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวที่อยู่ข้างๆ กัน ซึ่งส่งผลให้สารลดแรงตึงผิวที่ถูกดูดซับเกิดการเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนเรียกว่า แอดมิเซลล์ (Admicelle) หรือ เอมิไมเซลล์ (Hemimicelle) ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการเกาะตัวว่าเป็นแบบ 2 ชั้น (Bilayer) หรือชั้นเดียว (Monolayer) แอดมิเซลล์ (Admicelle) ลักษณะโครงสร้างจะเป็นการดูดซับบนพื้นผิวแบบ 2 ชั้น (Bilayer) โดยหมู่ฟังก์ชันที่มีข้อตรงส่วนหัว (Head Groups) ของชั้นที่อยู่ด้านล่างจะเป็นส่วนที่ถูกดูดซับบนพื้นผิวสัมผัส และฟังก์ชันที่มีข้อตรงส่วนหัวของชั้นที่อยู่ด้านบนจะเป็นส่วนที่สัมผัสถกับสารละลาย ส่วนเอมิไมเซลล์ (Hemimicelle) ลักษณะโครงสร้างจะเป็นการดูดซับแบบชั้นเดียว (Monolayer) โดยส่วนของฟังก์ชันที่มีข้อตรงส่วนหัวจะถูกดูดซับบนพื้นผิวสัมผัส ในขณะที่ส่วนหมู่ไอกอร์บอนที่ไม่มีข้อของส่วนหัว (Tail Groups) จะเป็นส่วนที่สัมผัสถกับสารละลาย

การเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ 1 สู่ช่วงที่ 2 จะแสดงถึงความเข้มข้นที่จุดสมดุลซึ่งเป็นจุดแรกที่ทำให้เกิดการจับตัวเป็นกลุ่มก้อนของสารลดแรงดึงผิวที่ถูกดูดซับเรียกว่า The Critical Admicelle Concentration (CAC) หรือ The Hemimicelle Concentration (HMC) ขณะที่เกิดการเกาเต้ากันนั้นประจุของพื้นผิวในตอนแรกจะหายไปในสภาพเป็นกลาง (Neutralized) และในที่สุดก็จะเปลี่ยนไปเป็นตรงกันข้าม (Reversed) ดังนั้นในตอนท้ายของช่วงที่ 2 นี้พื้นผิวของแข็งก็จะประจุชนิดเดียวกับอิอนของสารลดแรงดึงผิว

ช่วงที่ 3 ความเข้มของกราฟ Adsorption Isotherm จะลดลงอย่างกะทันหัน การลดลงของความเข้มเนื่องจากแรงผลักดันระหว่างประจุที่เหมือนกัน ของพังก์ชันที่มีขั้วดרגส่วนหัวบนพื้นผิว ดังนั้นจึงเป็นการยกที่จะเพิ่มปริมาณการดูดซับบนพื้นผิว

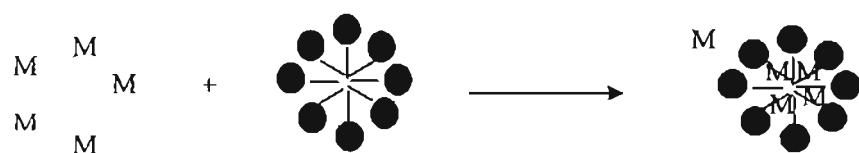
ช่วงที่ 4 เป็นช่วงที่มีการดูดซับเพียงเล็กน้อย อัตราการดูดซับของสารลดแรงดึงผิว เกือบจะคงที่ในขณะที่ความเข้มข้นของสารลดแรงดึงผิวเพิ่มขึ้น จุดเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ 3 สู่ช่วงที่ 4 จะแสดงถึงความเข้มข้นที่จุดสมดุลที่ทำให้เกิดการก่อตัวของไมเซลล์ เรียกว่า The Critical Micelle Concentration (CMC) [5]

2.3.2 ความสามารถในการละลาย

สามารถแบ่งกล่าวเป็น 2 ส่วนคือ ความสามารถการละลายในไมเซลล์ (Solubilization) และความสามารถการละลายในแอดไมเซลลาร์ (Adsolubilization)

2.3.2.1 ความสามารถการละลายในไมเซลล์

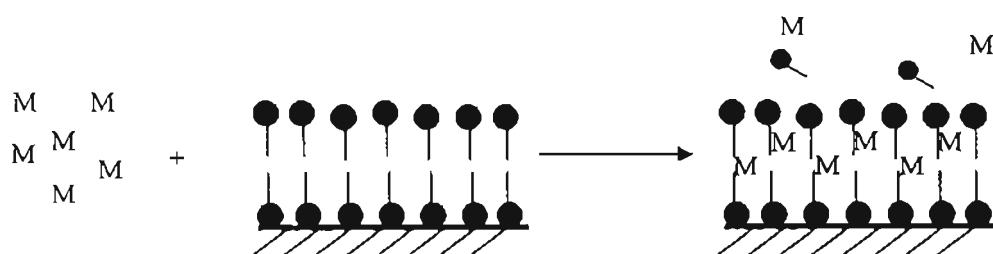
หมายถึงความสามารถในการละลายของสารดังด้าน เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Substance) ทั้งสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของสารลดแรงดึงผิว ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดไมเซลล์ ความเข้มข้นของสารลดแรงดึงผิวที่สูงกว่าจุด CMC จะสามารถละลายได้ค่อนข้างมากในสารละลายอินทรีย์ (Organics) ได้มากกว่าในน้ำ หรือสารละลายของสารลดแรงดึงผิวที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าจุด CMC ซึ่ง Rosen (1989) [6] ได้นิยามความหมายของ Solubilization ว่า “การละลายของสารตั้งต้น (ของแข็ง, ของเหลว หรือก๊าซ) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนแปลงสมดุลเทอร์โมไดนามิกส์ในสารละลายที่อุณหภูมิคงที่ ด้วยการลดการเคลื่อนไหวของสมดุลเทอร์โมไดนามิกส์ของความสามารถในการถูกละลายของวัตถุ” ฉะนั้นวัตถุที่ไม่สามารถละลายได้ในน้ำ ที่อยู่ในสารละลายเจือจางของสารลดแรงดึงผิวจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อความเข้มข้นของสารลดแรงดึงผิวได้ผ่านจุด CMC ไปแล้ว ซึ่งความสามารถในการละลายจะเพิ่มขึ้น โดยแปรผันตามความเข้มข้นของสารลดแรงดึงผิวที่สูงกว่า CMC



ภาพที่ 2-4 ลักษณะการเกิด Solubilization [6]

2.3.2.2 ความสามารถการละลายในแอดไมเซลลาร์

จะมีลักษณะคล้ายกับการละลายของสารอินทรีย์เข้าไปในไมเซลล์ ซึ่งโมเลกุลของสารอินทรีย์จะเข้ารวมตัวกันในสารลดแรงตึงผิวที่เกาะกลุ่มกันที่ถูกดูดซับบนพื้นผิว โดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Adsorubilization โดย Scamehorn และ Harwell [7] ได้นิยามความหมายว่า “การรวมตัวกันของสารประกอบเข้าไปในสารลดแรงตึงผิว ที่รวมตัวกันถูกดูดซับบนพื้นผิว ซึ่งสารประกอบจะไม่มีปริมาณมากเกินพอบริเวณผิวสัมผัส ระหว่างของแข็งกับของเหลวที่ไม่มีสารลดแรงตึงผิวยู่” ดังแสดงในภาพที่ 2-5 ซึ่งคำนิยามนี้ได้ถ่ายทอดแนวความคิดที่ว่า ตัวถูกละลายที่สนใจจะไม่ถูกดูดซับลงบนพื้นผิวของตัวดูดซับด้วยตัวของมันเอง หรืออาจจะถูกดูดซับได้น้อยมาก การกำจัดตัวถูกละลายในเฟสสารละลายเกิดขึ้นเนื่องจากการมีกลุ่มของสารลดแรงตึงผิวที่ถูกดูดซับ และการรวมตัวของตัวถูกละลายเข้าเป็นกลุ่ม

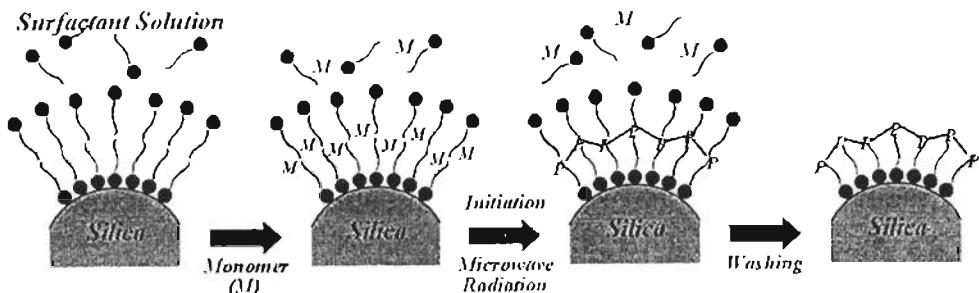


ภาพที่ 2-5 ลักษณะการเกิด Adsorubilization [7]

2.4. ปฏิกิริยาแอดไมเซลลาร์โพลิเมอร์ไซซ์ัน (Admicellar Polymerization)

ปฏิกิริยาแอดไมเซลลาร์โพลิเมอร์ไซซ์ัน เป็นปฏิกิริยาในกลุ่มของปฏิกิริยา In-situ Polymerization โดยเกิดภายในขั้นการดูดซับแบบ 2 ชั้น บนพื้นผิวต่างๆ และมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาคือ ค่าความเป็นกรด-ด่างของระบบ ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว (The Surfactant's Critical Micelle Concentration : CMC) หรือ ชนิดของสารลดแรงตึงผิว เป็นต้น

2.4.1 ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาแอดไมเซลลาร์โพลิเมอร์ไซซ์ัน [8]



ภาพที่ 2-6 ขั้นตอนการสังเคราะห์ฟิล์มบางพอลิเมอร์ด้วยปฏิกิริยา แอดไดเมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน [8]

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการเกิดแอดไดเมเซลล์ โดยสารลดแรงดึงผิวจะถูกดูดซับแบบ 2 ชั้น (Surfactant Bilayer) บนพื้นผิวที่รองรับ ซึ่งการดูดซับจะเกิดขึ้นได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเลือกใช้สารลดแรงดึงผิวที่เหมาะสมสมภายในได้สภาวะที่เหมาะสม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สารลดแรงดึงผิวคือ 1. การเลือกใช้ดัริเริม (Initiator) ให้เหมาะสมกับระบบของการเกิดพอลิเมอไรซ์ 2. สมบัติทางเคมีของมอนอเมอร์ (Monomer) ที่เลือกใช้ และ 3. จุดที่ประจุรวมเป็นศูนย์ (Point of Zero Charge : PZC) ของพื้นผิวที่รองรับ จากการศึกษาเกี่ยวกับค่า PZC ของพื้นผิวที่รองรับที่ช่วงค่าความเป็นกรด-ด่างๆ ในสารละลายของสารลดแรงดึงผิว ทั้งที่เป็นชนิดประจุบวก (Cationic) หรือชนิดประจุลบ (Anionic) พบว่า ที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต่ำกว่าจุด PZC ของพื้นผิว ลักษณะของพื้นผิวจะมีอนุภาคของอะ-domกลาญเป็นประจุบวก และจะมีประจุที่เป็นนาากมากขึ้น ที่ค่าความเป็นกรด-ด่างสูงกว่าจุด PZC ของพื้นผิว ลักษณะของพื้นผิวจะมีอนุภาคของอะ-domกลาญเป็นประจุลบ เช่น พื้นผิวรองรับที่เป็นชิลิกาจะมีค่า PZC อยู่ระหว่าง 2-3 หมายความว่า พื้นผิวรองรับชิลิกาจะมีสมบัติของประจุเป็นลบเมื่อยูในสารละลายที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างมากกว่า 3 ดังนั้นสารลดแรงดึงผิวชนิดประจุบวก เช่น CTAB จะถูกดูดซับบนพื้นผิวชิลิกาได้ เมื่อยูภายใต้สภาวะของสารละลายที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างมากกว่า 3

ขั้นตอนที่ 2 มอนอเมอร์เกิดการละลายเข้าไปอยู่ในไดเมเซลล์ ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Adsolubilization ซึ่งมอนอเมอร์ส่วนใหญ่จะไม่สามารถละลายในน้ำได ดังนั้นเมื่อมอนอเมอร์ไดเข้าสู่ระบบแล้ว มอนอเมอร์จะคงที่จะเข้าไปอยู่ในส่วนของสารอินทรีย์ที่อยู่ในไดเมเซลล์ การเติมมอนอเมอร์ และสารละลายของสารลดแรงดึงผิว ควรจะเดินไปพร้อมกันหรือติดต่อกัน

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการเกิดปฏิกิริยา พอลิเมอไรซ์ของมอนอเมอร์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยผ่านฟรีเรดิคัล ที่มีความสามารถในการริเริมปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ในบางกรณีความสามารถในการเข้ากันได้ภายในระบบของสารริเริมกับสารลดแรงดึงผิว ทั้งชนิดประจุลบและประจุบวกอาจจะมีผล

ในการเลือกชนิดของสารลดแรงตึงผิว และสภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาด้วย เมื่อปฏิกิริยาเริ่มต้นขึ้นมองเอมอร์ในสารละลาย จะมีการแพร่เข้าไปในแอ๊ดไมเซลล์มากขึ้น ถ้าปฏิกิริยาดำเนินต่อเนื่องไปโดยใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอ ในที่สุดมองเอมอร์ทั้งหมด ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพอลิเมอร์

ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนการล้างผงอนุภาคที่ผ่านการปรับปูรุ่งแล้วด้วยน้ำอุ่นเพื่อกำจัดชั้นของสารลดแรงตึงผิวชั้นนอกออกไปซึ่งทำให้ชั้นพอลิเมอร์ประกอบขึ้น จากนั้นนำผงอนุภาคไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิเหมาะสม เพื่อที่จะระเหยความชื้น

2.4.2 กลไกการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน

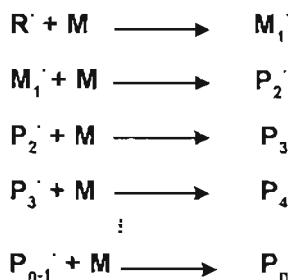
โดยทั่วไปปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ ปฏิกิริยาลูกโซ่ และปฏิกิริยาที่ละขั้น ลักษณะทั่วไปของปฏิกิริยาลูกโซ่คือ การเติบโตของเส้นพอลิเมอร์จะเกิดจากการเติบมอนเอมอร์ที่ลະหน่ายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปฏิกิริยาที่กำลังดำเนินอยู่จึงขึ้นกับขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อน ปฏิกิริยาลูกโซ่อาจเกี่ยวข้องกับ แรดิคัล แคทไอออน หรือแอนไฮเดรต หรืออาจไม่เกี่ยวกับสารตัวกลางเลย แต่เกี่ยวข้องกับโมเลกุลชนิดที่สาม ซึ่งมักเป็นสารเชิงซ้อนของโลหะทำหน้าที่เป็นตัวก่อพันธะระหว่างพอลิเมอร์กับมอนเอมอร์ กระบวนการนี้เรียกว่า “พอลิเมอไรเซชันแบบโคงอร์ดิเนชัน (Coordination Polymerization)”

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซ่แรดิคัล (Radical Chain Polymerization) เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่สำคัญที่สุด ปฏิกิริยานี้ต้องการตัวเริ่มซึ่งเป็นสารที่ไม่ค่อยเสถียรต่อความร้อนหรือแสง เมื่อกูกความร้อนหรือแสงในช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะสมตัวเริ่มจะเกิดการแตกตัวเป็นแรดิคัลอิสระ และเกิดการถ่ายโอนแรดิคัล ทำให้เกิดการเพิ่มน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ขึ้น โดยการเพิ่มนอนเอมอร์เข้าไปที่ปลายโซโนเลกุล ที่มีแรดิคัลเป็นตำแหน่งที่ว่องไว ต่อการเกิดปฏิกิริยาซึ่งกลไกการเกิดพอลิเมอไรเซชันสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน [9] คือ

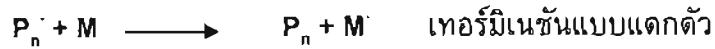
อินิเกชัน (Initiation)



โปรดากेशัน (Propagation)



เทอร์มิเนชัน (Termination)



เมื่อ | คือ ตัวเริ่ม, R คือ พรีแครดิคัล, M คือ มองโนเมอร์, M' คือ แรดิคัลมองโนเมอร์, $P_n \cdot$ คือ สายโซ่โมเลกุลที่มีแรดิคัลตัวอยู่ที่ปลาย

2.4.2.1 อินนิทิเอชัน (Initiation) [9]

เกี่ยวข้องกับการสร้างแรดิคัลซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ประกอบด้วย 2 ขั้น คือ ขั้นแรกโมเลกุลของตัวเริ่ม (I) และตัวให้แรดิคัล (R) และขั้นที่สองแรดิคัลเข้าทำปฏิกิริยากับมองโนเมอร์

ขั้นตอนการแตกตัวของตัวเริ่มมักเกิดผ่านกลไกดังต่อไปนี้

การแตกพันธะเดี่ยวในโมเลกุลของตัวเริ่ม ซึ่งเกิดขึ้นโดยการให้ความร้อนในช่วง 50-100 องศาเซลเซียส มักเกิดกับตัวเริ่มประเภทสารประกอบเบอร์ออกไซด์

การย้ายอิเล็กตรอนเดี่ยวนะห่วงไอออน หรือโมเลกุล เช่น การเกิดปฏิกิริยาเรดอกซ์ มักนิยมใช้มีอัองการให้พอลิเมอไรเซชันเกิดที่อุณหภูมิต่ำ

ขั้นตอนแรดิคัลเข้าทำปฏิกิริยากับมองโนเมอร์

ตำแหน่งที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา เกิดเมื่อพรีแครดิคัลทำปฏิกิริยาผ่านพันธะไฟ (π -Bond) ของมองโนเมอร์

2.4.2.2 propagation (Propagation) [9]

เกี่ยวข้องกับการเติบโตหรือการเพิ่มขนาด ของสายโซ่โมเลกุลพอลิเมอร์อย่างรวดเร็ว โดยมองโน-เมอร์แรดิคัลที่เกิดจากขั้นตอนอินนิทิเอชันเข้าทำปฏิกิริยากับมองโนเมอร์ เกิดเป็นสายโซ่โมเลกุลที่มีแรดิคัลติดอยู่ที่ปลาย (Active Center) และจะเกิดการเพิ่มขึ้นของมองโนเมอร์ ที่ปลายสายโซ่อีกอย่างต่อเนื่อง

2.4.2.3 เทอร์มิเนชัน (Termination) [9]

เป็นขั้นสิ้นสุดการเพิ่มของพอลิเมอร์ โดยมีกลไกการเกิดปฏิกิริยา 2 แบบ คือ เทอร์มิเนชันแบบรวมตัว (Combination) และเทอร์มิเนชันแบบแตกตัว (Disproportionation)

ปฏิกิริยาเทอร์มิเนชันแบบรวมตัว เกิดเมื่อแรดิคัลที่ปลายของ 2 สายโซ่โมเลกุลรวมกัน ทำให้ 2 สายโซ่โมเลกุลรวมเป็น 1 โมเลกุล ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงขึ้น และการรวมกันเป็นแบบ Head to Head

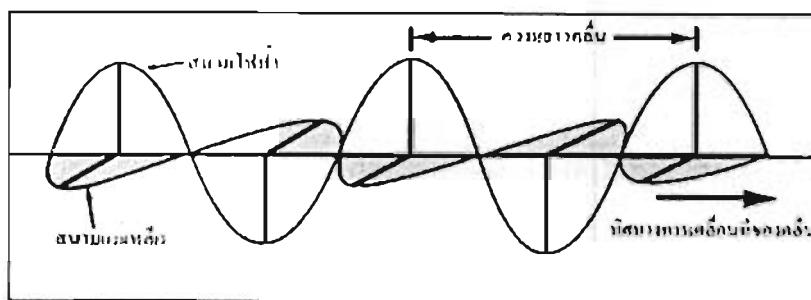
ปฏิกิริยาเทอร์มิเนชันแบบแตกตัว เกิดเมื่อมีการย้ายไฮโดรเจนอะตอมระหว่าง 2 สายโซ่โมเลกุลที่มีแรดิคัล ทำให้ได้พอลิเมอร์ 2 โมเลกุลที่มีความยาวเท่าเดิม โดยปลายของโมเลกุล

ที่ถูกย้ายไส้โดยเจนอะดอมออกไปจะเกิดพันธะคู่ติดอยู่ ส่วนอีกโมเลกุลจะเกิดพันธะเดี่ยวในโครงสร้างเพิ่มขึ้น

2.5 ไมโครเวฟ (Microwave)

2.5.1 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

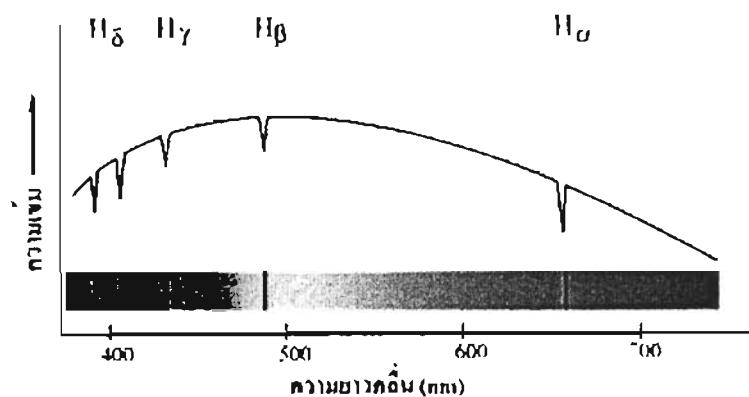
ธรรมชาติของ "แสง" แสดงความประพฤติเป็นทั้ง "คลื่น" และ "อนุภาค" เมื่อกล่าวถึงแสงในคุณสมบัติความเป็นคลื่น เรียกว่า "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" (Electromagnetic Waves) ซึ่งประกอบด้วยสนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้าทำมุ่งดังจากซึ่งเคลื่อนที่ไปในอวากาศด้วยความเร็ว 300,000,000 เมตร/วินาที และเมื่อกล่าวถึงแสงในคุณสมบัติของอนุภาค เราเรียกว่า "โฟตอน" (Photon) เป็นอนุภาคที่ไม่มีมวลแต่เป็นพลังงาน



ภาพที่ 2-7 คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [10]

2.5.2 ประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

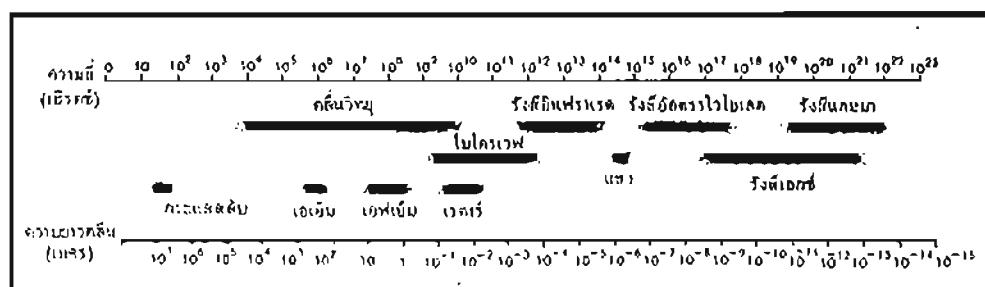
แสงที่ตามองเห็น (Visible Light) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงซึ่งปรสាពด้านของมนุษย์สามารถสัมผัสได้ ซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 400-700 นาโนเมตร หากนำแท่งแก้วบริซิม (Prism) มาหักเหแสงอาทิตย์ ก็จะเห็นว่าแสงสีขาวถูกหักเหออกเป็นสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง คล้ายกับสีของรุ้งกินน้ำ ซึ่งเรียกว่า "สเปกตรัม" (Spectrum) แสงแต่ละสีมีความยาวคลื่นแตกต่างกัน ด้วยย่างเช่น แสงสีม่วงมีความยาวคลื่นน้อยที่สุด ในทางกลับกันแสงสีแดงมีความยาวคลื่นมากที่สุด นักดาราศาสตร์ทำการศึกษาเท่านั้นที่วัดถูกห้องฟ้าโดยการศึกษาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่วัดถูกแผงรังสีอุ่นมา สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เราทราบถึงคุณสมบัติทางกายภาพของดวงดาว อันได้แก่ อุณหภูมิ และพลังงาน (นอกจากนั้นยังบอกถึง ธาตุองค์ประกอบทางเคมี)



ภาพที่ 2-8 สเปกตรัมของแสงอาทิตย์ [10]

สเปกตรัมของแสงอาทิตย์ในภาพที่ 2-8 แสดงให้เห็นถึงระดับความเข้มของพลังงาน ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ จะเห็นได้ว่า ดวงอาทิตย์มีความเข้มของพลังงานมากที่สุดที่ ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร เส้นสีเข้มบนแบบสเปกตรัม หรือ รอยหยักบนเส้นกราฟ แสดงให้เห็นว่า มีร้าดูโอโตรเจนอยู่ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ ดาวแต่ละดวงมีสเปกตรัม ไม่เหมือนกัน จะนั้นสเปกตรัมจึงเป็นสมบูรณ์แบบมีของดาว

นอกจากแสงที่ตามองเห็นแล้วยังมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านิดอื่นๆ ได้แก่ รังสีที่มีความยาวคลื่นถัดจากสีแดงออกไป เราเรียกว่า “รังสีอินฟราเรด” หรือ “รังสีความร้อน” เรามองไม่เห็น รังสีอินฟราเรด แต่เราภรรุสึกถึงความร้อนได้ สัตว์บางชนิด เช่น งู มีประสาทสัมผัสรังสีอินฟราเรด มันสามารถทราบตำแหน่งของเหยื่อได้ โดยการสัมผัสรังสีอินฟราเรดซึ่งแผ่ออกมานะร่างกายของเหยื่อ รังสีที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าแสงสีม่วงเรียกว่า “รังสือุตราชไวโอเล็ต” แม้ว่าเราจะมองไม่เห็น แต่เมื่อเราหากเดินทาง ผิวนั้จะใหม่ด้วยรังสีชนิดนี้ นอกจากรังสีอุตราชไวโอเล็ตและรังสีอินฟราเรดแล้ว ยังมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ซึ่งเรียงลำดับตามความยาวคลื่นได้ดังนี้



ภาพที่ 2-9 ประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [10]

รังสี gamma (Gamma Ray) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 0.01 นาโนเมตร โฟตอนของรังสี gamma มีพลังงานสูงมาก กำเนิดจากแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ เช่น ดาวระเบิด หรือ ระเบิดปรมาณู เป็นอันตรายมากต่อสิ่งมีชีวิต

รังสีเอ็กซ์ (X-Ray) มีความยาวคลื่น 0.01 - 1 นาโนเมตร มีแหล่งกำเนิดในธรรมชาติมาจากการอาทิตย์ เรายังใช้รังสีเอ็กซ์ในการแพทย์ เพื่อส่องผ่านเซลล์เนื้อเยื่อ แต่ถ้าได้รับก็จะเป็นอันตราย

รังสีอุլตราไวโอเล็ต (Ultraviolet Radiation) มีความยาวคลื่น 1 - 400 นาโนเมตร รังสีอุลตราไวโอเล็ตมีอยู่ในแสงอาทิตย์ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่หากได้รับมากเกินไป ก็จะทำให้ผิวไหม้ และอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง

แสงที่ตามองเห็น (Visible Light) มีความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร พลังงานที่แผ่ออกมากจากดวงอาทิตย์ ส่วนมากเป็นรังสีในช่วงนี้ แสงแฉดเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลก และยังช่วยในการสัมเคราะห์แสงของพืช

รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation) มีความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร - 1 มิลลิเมตร โลกและสิ่งชีวิตแผ่รังสีอินฟราเรดออกมามาก ถ้าเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำ ในบรรยากาศคัดขับรังสีไว ทำให้โลกมีความอบอุ่น เหมาะกับการดำรงชีวิต

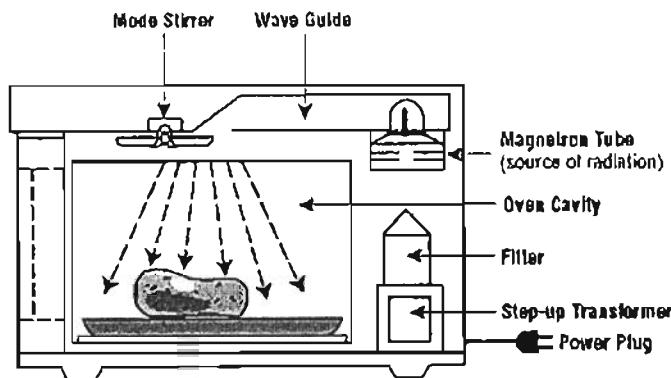
คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) มีความยาวคลื่น 1 มิลลิเมตร - 10 เซนติเมตร ใช้ประโยชน์ในด้านโทรคมนาคมระยะใกล้ นอกจากนั้นยังนำมาประยุกต์สร้างพลังงานในเตาอบอาหาร

คลื่นวิทยุ (Radio Wave) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากที่สุด คลื่นวิทยุสามารถเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศได้ จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม

2.5.3 คลื่นไมโครเวฟ

คลื่นไมโครเวฟจากเตาอบไมโครเวฟเป็นสนามของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานแม่เหล็ก อยู่ด้วยกัน จึงจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเร็วเท่ากับความเร็วแสงมีการแผ่รังสีเหมือนแสง แต่มีพลังงานน้อยกว่า เคลื่อนที่ในรูปแบบคลื่น โดยถูกนำไปใช้ในเตาอบไมโครเวฟจะประกอบไปด้วย

1. แมกนิตรอน (Magnetron)
2. ผู้ควบคุมแมกนิตรอน (โดยทั่วไปเรียกว่า "ไมโครคอนโทรลเลอร์")
3. ท่อนำคลื่น (Waveguide) และ
4. ช่องสำหรับอบอาหาร



ภาพที่ 2-10 ภาพดัดขวางภายในเตาอบไมโครเวฟ [11]

หลักการทำงานของเตาอบไมโครเวฟ [12] คือ การให้ความร้อนกับอาหารโดยการแพร่คลื่นย่างความถี่ไมโครเวฟโดยปกติจะใช้ช่วงความถี่ 2450 เมกะเอิร์ตซ์ หรือ ความยาวคลื่น 12.24 เซนติเมตร ผ่านเข้าไปในอาหาร โมเลกุลของน้ำ ในมัน และ น้ำตาล ที่อยู่ในอาหารจะดูดซับพลังงานของคลื่นที่ผ่านเข้าไปและเกิดเป็นความร้อนขึ้น ในกระบวนการที่เรียกว่า การเกิดความร้อนในสารไดเล็กติก (Dielectric Heating) เนื่องจากโมเลกุลของน้ำส่วนใหญ่นั้นเป็นโมเลกุลที่มีชาร์จไฟฟ้า คือ มีประจุบวก และประจุลบที่ชาร์จตรงกันข้าม เมื่อคลื่นไมโครเวฟซึ่งเป็นสนามไฟฟ้าผ่านเข้าไป โมเลกุลเหล่านี้ก็จะถูกเหนี่ยวแน่นและหมุนขึ้นเพื่อปรับเรียงด้วยความแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้เป็นสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงสลับไปมา จึงส่งผลให้โมเลกุลเหล่านี้หมุนกลับไปมา ทำให้โมเลกุลของน้ำเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกับโมเลกุลอื่นๆ ต่อจนเกิดเป็นพลังงานจลน์และพลังงานจลน์นี้เองจะกลายสภาพเป็นพลังงานความร้อนทำให้เกิดความร้อนขึ้น ซึ่งด้วยจากการให้ความร้อนในแบบเดิม (เบลว่าไฟ, ชุดลวดไฟฟ้า) ซึ่งอาศัยหลัก การนำ การพา และการแผ่รังสี การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟนี้ จะมีประสิทธิภาพในการเกิดความร้อนสูงสุด ในการให้ความร้อนแก่น้ำ และ ประสิทธิภาพต่ำเมื่อให้ความร้อนแก่ ไขมัน น้ำตาล และ น้ำแข็ง

2.6 งานวิจัยที่ผ่านมา

ในการวิจัยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงเนื้อหาข้อมูลของผลงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระ ผลการทดลอง หรือแม้แต่อ้างอิงถึงผลการทดลอง ที่ได้ผลสอดคล้องกัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานวิจัยต่างๆโดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงผิวชิลิก้า ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์เซชัน ตลอดจนถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำคลื่นไมโครเวฟมาใช้ในการนวัตกรรม พอลิเมอร์เซชันต่างๆ

ผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงผ้าชีลิกา ด้วยกระบวนการทางพอลิเมอ-ไโรเชชันต่างๆ สำหรับนำไปใช้เป็นสารเติมแต่งในยางธรรมชาติ ได้แก่

วีรเดช และคณะ [13] ศึกษาถึงผลของปริมาณการเติมสารดัวเดิมชีลิกา และแคลเซียม-คาร์บอนเนต ในยางฟอยม (Cellular Rubber) โดยพิจารณาถึง สมบัติเชิงกล กายภาพ และโครงสร้างจุลภาค รวมถึงปริมาณการดูดซับໂගລູອືນของยางฟอยมที่ผ่านการอัดขึ้นรูป (Compression Mounding) ที่อุณหภูมิคงรูป 160 องศาเซลเซียส และเวลาคงรูป 7 นาที พบร้า ยางฟอยม ที่ปริมาณชีลิกา 20 phr จะให้ปริมาณการดูดซับสารละลายที่สภาวะสมดุลลดลง ส่วนสมบัติ ความทนทานต่อแรงดึง และความทนทานต่อการขัดถูดีขึ้น แต่กลับมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณ ชีลิกางามกว่า 20 phr ทั้งนี้เนื่องจาก เกิดการรวมกลุ่มกันของชีลิกาทำให้ประสิทธิภาพ การกระจายตัวและการเสริมแรงภายในเนื้อยางลดลง และเมื่อผสานแคลเซียมคาร์บอนเนต ในปริมาณระหว่าง 0 ถึง 30 phr ที่ปริมาณชีลิกา 20 phr พบร้า แคลเซียมคาร์บอนเนตที่ปริมาณ 20-30 ให้สมบัติเชิงกลของโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงนัก และเมื่อเพิ่มปริมาณแคลเซียมคาร์บอนเนต มากกว่า 30 phr พบร้า สมบัติเชิงกลลดลง เนื่องจากระบบมีสารดัวเดิมมากเกินไป ในทางกลับกันพบว่า ปริมาณแคลเซียมคาร์บอนเนตที่ผสานกลับไม่มีผลต่อปริมาณการดูดซับ สารละลายที่สภาวะสมดุล

พงษ์ธรา และคณะ [14] ศึกษาประสิทธิภาพในการเสริมแรงของชีลิกาทั้งในยางคลอโรพรีน และในยางผสมระหว่างคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ โดยพิจารณาถึงปริมาณชีลิกา และปริมาณ สารคงรูปเออทิลีนไชโอยูเรีย (Ethylenethiourea : ETU) พบร้า ชีลิกาสามารถช่วยเพิ่ม ความสามารถในการเสริมแรงในยางได้ดี ทั้งยางคลอโรพรีนและยางผสมระหว่างคลอโรพรีนกับ ยางธรรมชาติ สำหรับยางธรรมชาติความสามารถในการเสริมแรงกลับมีผลไม่เปลี่ยนแปลงนัก ทั้งนี้เนื่องจากยางธรรมชาติสามารถดักผลึกได้เมื่อถูกยืด บางจังหวะความต้านทานต่อแรงดึงค่อนข้างสูง ในทางกลับกันเมื่อให้ปริมาณชีลิกาเพิ่มขึ้น พบร้า ยางมีค่าความต้านทานต่อแรงดึงลดลง เนื่องจาก ชีลิกาเกิดการรวมกลุ่มกันทำให้ประสิทธิภาพการกระจายตัว และการเสริมแรงภายในเนื้อยาง ลดลง และเมื่อพิจารณาอย่างผสมระหว่างคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ พบร้า เออทิลีนไชโอยูเรีย สามารถช่วยทำให้ยางผสมระหว่างคลอโรพรีนและยางธรรมชาติดันน์ มีอัตราเร็วในการคงรูปที่สูง เพียงพอที่ไม่ทำให้ยางเกิดการแยกเฟส เนื่องจากยางคลอโรพรีนไม่สามารถคงรูปได้ด้วยกำลังดัน หรือเพอร์ออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการที่อะดอมของคลอรินที่อยู่ในโมเลกุลมีค่าอิเล็กตรอนกาติวตี้ (Electronegativity : EN) สูง ทำให้ไปดึงอิเล็กตรอนที่อยู่ในบริเวณพันธะคู่ ทำให้พันธะคู่ ที่มีอยู่นั้นมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาลดลง เป็นเหตุให้ไม่สามารถคงรูปด้วยกำลังดันได้

Song และ Park [15] ศึกษาการปรับปรุงพื้นผิวของชีลิกาด้วยออกทิลไตรເອກອກ-ซีไซเลน โดยเปรียบเทียบระหว่างการทำปฏิกิริยาในวัฏภาชนะของเหลวและวัฏภาชนะก้าช โดยการทำปฏิกิริยา ในวัฏภาชนะจะใช้เครื่องแอร์ซอลสเปรย์ ซึ่งอนุภาคชีลิกาผสานอยู่ในสารละลายเอทานอล 1% โดยน้ำหนัก โดยโมเลกุลของออกทิลไตรເອກອกซีไซเลน จะทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วกลับไปอยู่

ในรูปของไฮดรอกไซด์ ซึ่งไฮดรอกไซด์นี้จะไปทำปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลบนพื้นผิวชิลิกา โดยจะใช้อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา 100-350 องศาเซลเซียส และความเข้มข้นของออกทิลไดเรอ-เทอกซ์ไซเลนระหว่าง 1.6-13 กรัมต่อชิลิกา 1 กรัม จากนั้นชิลิกาที่ผ่านการปรับปรุงจะถูกเตรียมโดยการนำชิลิกาไปผสมกับออกทิลไดเรอ-เทอกซ์ไซเลนใน Water Bath ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-16 ชั่วโมง อนุภาคชิลิกาที่ผ่านการปรับปรุงผิวจะถูกนำไปล้าง เพื่อกำจัดออกทิลไดเรอ-เทอกซ์ไซเลนที่เหลือจากการทำปฏิกิริยาออก โดยชิลิกาที่ปรับปรุงผิวจะถูกวิเคราะห์ด้วยวิธีฟูเรย์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด (FTIR) พบว่า ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เมื่อความเข้มข้นของออกทิลไดเรอ-เทอกซ์ไซเลนเพิ่มขึ้น จะทำให้ปริมาณไฮดรอกซิลบนอนที่มาเกาะบนพื้นผิวชิลิกาเพิ่มขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 250 องศาเซลเซียส ความหนาแน่นของพีค CH_x Stretching กลับต่ำลง ทั้งนี้เกิดจากการระเหยของสารละลายออกทิลไดเรอ-เทอกซ์ไซเลนเนื่องจากออกทิลไดเรอ-เทอกซ์ไซเลนมีจุดเดือดต่ำกว่าอุณหภูมิของปฏิกิริยา (85 องศาเซลเซียส) ดังนั้นจึงทำให้มีปริมาณอนุภาคของออกทิลไดเรอ-เทอกซ์ไซเลนในปฏิกิริยาลดน้อยลง ในขณะที่เมื่อใช้อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาสูงขึ้น ปริมาณของหมู่ CH_x จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮดรอลิกส์ และการควบแน่นของออกทิลไดเรอ-เทอกซ์ไซเลน มีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีอัตราการเกิดปฏิกิริยา ระหว่างไฮดรอกไซด์ของออกทิลไดเรอ-เทอกซ์ไซเลน และหมู่ไฮดรอกซิลบนพื้นผิวชิลิกามากขึ้น และเมื่อนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคป (SEM) พบว่า เมื่อความเข้มข้นของออกทิลไดเรอ-เทอกซ์ไซเลนเพิ่มขึ้น จะเกิดการเกาะกลุ่มของออกทิลไดเรอ-เทอกซ์ไซเลนในรูปของไฮดรอกไซด์ และเมื่อนำชิลิกาไปวิเคราะห์ ความสามารถในการละลายน้ำด้วยวิธี Ethanol Volume Ratio (EVR) พบว่า ค่า EVR ลดลง เมื่ออุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบค่า EVR ของชิลิกาที่ผ่านการปรับปรุงในวัสดุก้าชจะมีค่าเป็น 2 เท่า ของชิลิกาที่ผ่านการปรับปรุงในวัสดุก้าชของเหลว

Sheng และคณะ [16] ศึกษาผลกระทบของสารเดิมแต่งที่ทำหน้าที่ละลายอย่าง (Multifunction Additive : MFA) ที่มีผลต่อการเชื่อมต่อระหว่างผงเข้มดำและชิลิกาที่เดิมลงในยางธรรมชาติ โดยที่ MFA เป็นสารลดแรงดึงผิวประจุบวกจำพวกเกลือไดแอมมีนของกรดคาร์บอชิลิก ($\text{RNH}_2^+ (\text{CH}_2)_3\text{NH}_3^+ (\text{RCOOO})_2^-$) และเมื่อนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีฟูเรย์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด พบว่า การเชื่อมตอกันระหว่างผงเข้มดำกับยางมีค่าลดลงเมื่อความเข้มข้นของ MFA เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ผงเข้มดำเกาะกันเป็นกลุ่ม ส่งผลให้โมเลกุลของยางธรรมชาติเคลื่อนได้ลดลง (Immobilized) ในทางกลับกัน พบว่า MFA จะช่วยเพิ่มการกระจายตัวของชิลิกาและทำให้พื้นผิวสัมผัสระหว่างชิลิกากับยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น ฉะนั้น การเพิ่ม MFA จะเป็นการช่วยเพิ่มความเป็นข้าวของชิลิกา จึงทำให้ MFA ดูดซับบนพื้นผิวชิลิกาได้ดีกว่าผงเข้มดำ

Nah และคณะ [17] ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัวของชิลิกาหรือพองเขม่าดำเนินยางธรรมชาติ พบว่า การใช้เบนโซไทด์โซลฟานามิด (N-Tertbutyl-2-Benzothiazole Sulfonamide) สามารถช่วยเพิ่มการกระจายตัวของชิลิกาและการคืนสภาพของเนื้อยางธรรมชาติได้ดีในระบบที่ไม่มีการเติมไฮเดนดันบีง ในทางกลับกัน ระบบที่มีการเติมไฮเดนดันบีง พบว่า มีการคืนสภาพของเนื้อยางธรรมชาติลดลง ส่วนระบบที่มีการเติมชิลิกาในยางธรรมชาติที่ผ่านการรักษาในเซชันโดยไม่มีการเติมไฮเดนดันบีง พบว่า ยางธรรมชาติมีค่าความทนทานต่อการตึงสูงขึ้น เมื่อใช้เบนโซไทด์โซลฟานามิดเพิ่มขึ้น

Kim และคณะ [18] ศึกษาการปรับปรุงผิวชิลิกาด้วย Methyl Methacrylate (MMA) ภายใต้การฉายคลื่น Ultraviolet (UV) สำหรับกระบวนการกราฟท์ พอลิเมอร์ไซซ์ชัน (Graft Polymerization) โดยเลือกระยะเวลาการฉายคลื่นยูวีที่ 5 – 40 นาที และความยาวคลื่นที่ 200 - 500 นาโนเมตร จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปี พบว่า ชิลิกาที่ผ่านกระบวนการกราฟท์ พอลิเมอร์ไซซ์ชัน จะมีขนาดอนุภาคเพิ่มขึ้น โดยอนุภาคจะมีขนาดใหญ่ที่สุดที่สภาวะเวลาการฉายคลื่นยูวี 25 นาที โดยมีขนาดเท่ากับ 456 นาโนเมตร ซึ่งมีขนาดเพิ่มขึ้นถึง 78 เบอร์เซ็นต์ และเมื่อให้เวลาในการฉายคลื่นยูวีนานกว่า 25 นาที พบว่า อนุภาคจะมีขนาดลดลงซึ่งเป็นไปตามข้อสรุปของ Kaczmarek et al. โดยอธิบายไว้ว่า สายโซ่ของพอลิเมอร์ที่ได้มีขนาดสั้นลง เป็นผลมาจากการแตกตัวของพันธะคาร์บอนกับคาร์บอน (C-C) ในระหว่างการฉายคลื่นยูวีจึงเกิดการสลายตัวของพอลิเมอร์ และจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีฟูเรียทราฟฟอร์มรามานสเปกตรอสโคปี (FT-Raman Spectroscopy) พบว่า ชิลิกาที่ผ่านกระบวนการกราฟท์ พอลิเมอร์ไซซ์ชันจะเกิดลักษณะเฉพาะที่ความยาวคลื่น 1003 และ 1030 cm^{-1} ซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะของพันธะ Si-O-C หมายถึง การเกาะกันระหว่างพันธะคาร์บอนของ PMMA และพันธะบริเวณผิวชิลิกา ซึ่งแตกต่างจากชิลิกาที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการกราฟท์ พอลิเมอร์ไซซ์ชัน โดยจะพบลักษณะเฉพาะของพันธะ Si-O-H ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบริเวณผิวชิลิกาเท่านั้น

O'Haver และคณะ [19] ศึกษาการพัฒนาปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติโดยผสมชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยโคพอลิเมอร์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ โดยใช้ไอโพรีนและ 1,3-Butadiene ควบคู่กับ Vinyl Acetate, Acrylonitrile, 4-Methoxy-Styrene และ Methyl Methacrylate (MMA) และใช้ CTAB และ AIBN เป็นสารลดแรงตึงผิวและตัวริเริมแก่ระบบ ตามลำดับ โดยทดสอบถึงสมบัติ เวลาการคงรูปของยาง, Break Strength, Tear Energy และ Elongation to Break พบว่า ชิลิกาที่ปรับปรุงผิวด้วยระบบโคพอลิเมอร์ของไอโพรีนและ 1,3-Butadiene จะให้เวลาการคงรูปของยางที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชิลิกาที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว ซึ่งระบบที่ใช้โคพอลิเมอร์ของไอโพรีนกับ 4-Methoxy-Styrene จะให้เวลาการคงรูปของยางต่ำสุดเท่ากับ 1.7 นาที ส่วนระบบที่ใช้โคพอลิเมอร์ 1,3-butadiene กับ MMA จะให้เวลาการคงรูปของยางเท่ากับ 3.1 นาที นอกจากนั้นพบว่า ยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาปรับปรุง

ผิวด้านระบบโคโพลิเมอร์ของไอโซพรีนกับ 4-Methoxy-Styrene และโคโพลิเมอร์ 1, 3-Butadiene กับ MMA จะให้สมบัติ Break Strength, Tear Energy และ Elongation to Break ของยางดีขึ้นเช่นกัน

Che และคณะ [20] ศึกษาการพัฒนาเทอโมพลาสติกของ Polybutylene Terephthalate (PBT) ด้วยการปรับปรุงผิวชิลิกาสำหรับกระบวนการกราฟท์ พอลิเมอไรเซชัน (Graft Polymerization) โดยพิจารณาสมบัติของชิลิกาด้วยการทดสอบ Transmission Electron Microscopy (TEM) และ Atomic Force Microscope (AFM) และสมบัติทางกายภาพของ PBT ด้วยการทดสอบ Tensile Strength, Impact Strength และ Elongation at Break ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ TEM พบว่า ชิลิกาที่ผ่านการกราฟท์ อนุภาคนองชิลิกาจะมีขนาดเพิ่มขึ้นและ มีการกระจายตัวและจัดเรียงตัวในเนื้อ PBT แบบเป็นแนวเส้นตรง และเมื่อวิเคราะห์ด้วย AFM พบว่า ชิลิกาที่ผ่านการกราฟท์จะมีการกระจายตัวได้ดีกว่า ชิลิกาที่ไม่ได้ผ่านการกราฟท์ โดยมีการกระจายตัวและรวมเป็นเนื้อเดียวกัน PBT ได้ดีไม่เกิดการเกาะรวมเป็นกลุ่มก้อน นอกจากนั้นทำการทดสอบสมบัติทางกายภาพของ PBT หลังเติมชิลิกาที่ผ่านการกราฟท์ พบว่า PBT จะมีสมบัติ Tensile Strength, Impact Strength และ Elongation at Break ดีกว่า PBT ที่เติมชิลิกาธรรมชาติ โดย Tensile Strength มีค่าเท่ากับ 56.4 MPa, Impact Strength มีค่าเท่ากับ 50 KJm² และ Elongation at Break มีค่าเท่ากับ 72.3 เปอร์เซ็นต์ ในทางกลับกัน พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณชิลิกาใน PBT เพิ่มขึ้น สมบัติของ Tensile Strength, Impact Strength และ Elongation at Break กลับมีค่าลดลง

Jeon และคณะ [21] ศึกษาการปรับปรุงผิวชิลิกาโดยอาศัยกระบวนการไฮโดรไคลซิส ซึ่งใช้กรดในทริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที และกระบวนการควบแน่น ซึ่งใช้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้สารละลายมอนومอร์ออกไซโลกอฟซิไซเลน (Organoalkoxysilane) และเมื่อนำชิลิกาที่ผ่านกระบวนการมาวิเคราะห์ พบว่า อัตราการเกิดกระบวนการไฮโดรไคลซิสในมอนอมอร์ที่ดีที่สุดคือ เมทกิลไตรเมทอกซิไซเลน (Methyltrimethoxysilane;MTMS) ส่วนมอนอมอร์ที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการควบแน่นคือ ไวนิลไตรเมทอกซิไซเลน

ผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงผิวชิลิกา โดยอาศัยปฏิกิริยา แอดเมิลลาร์พอลิเมอไรเซชัน ได้แก่

O'Haver และคณะ [22] ศึกษาการปรับปรุงผิวของชิลิกาจากปฏิกิริยาแอดเมิลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน โดยใช้มอนอมอร์ 3 ชนิด คือ สไตริน, ไอโซพรีน และบิวตะไดอีน และ ใช้โคโพลิเมอร์ 3 ชนิด คือ สไตรินกับบิวตะไดอีน, สไตรินกับไอโซพรีน และ ไอโซพรีนกับบิวตะไดอีน โดยใช้เขกซ์เดซิลไตรเมทอกซิลแอมโมเนียมโบร์มีด (Hexadecyltrimethylammoniumbromine : CTAB) เป็นสารลดแรงตึงผิว และใช้

2, 2-เอโซบิส-2-โพร์ไฟโอลไนทริล (2,2'-azobis-2-Methylpropionitrile: AIBN) เป็นตัวริเริ่มจากนั้นนำชิลิกาที่ผ่านการปรับปรุง แล้วนำมาผสมกับยางสังเคราะห์แล้วขึ้นรูปนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพของยางสังเคราะห์ เช่น เวลาที่ใช้ในการคงรูป สมบัติการเสริมแรง เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบชิลิกาที่ใช้มอนومอร์ชนิดต่างๆ พบว่า ชิลิกาที่ใช้ บิวตะไดอีนเป็นมอนومอร์ให้สมบัติทางกายภาพของยางดีกว่าการใช้มอนอมอร์ชนิดอื่นๆ ส่วนชิลิกาที่โคมอนอมอร์ระหว่างสไตรีนกับบิวตะไดอีน จะให้สมบัติทางกายภาพที่ดีกว่าการใช้โคมอนอมอร์ชนิดอื่นๆ

Chinpan และคณะ [23] ได้ศึกษาการปรับปรุงผิวชิลิกาโดยอาศัยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน โดยใช้โคมอนอมอร์ 2 ชนิดคือ สไตรีน-บิวตะไดอีน และ สไตรีนไอโซพรีนโดยใช้เอกซ์เดซิลไดรเมทิลแอมโมเนียม เป็นสารลดแรงตึงผิว และใช้ 2, 2-เอโซบิส-2-เมทิลโพร์-พิโอลไนไตร์ เป็นตัวริเริ่ม พบว่า ในขั้นตอนการคงรูปนั้นพอลิเมอร์ที่เคลือบบนชิลิกาสามารถสร้างพันธะกับสารประกอบยางได้ คุณสมบัติทางกายภาพดีกว่า ของยางได้ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้อัตราส่วนของโคอมอนอมอร์กับสารเคลือบผิวที่ต่ำ จะทำให้คุณสมบัติทางกายภาพดีกว่า ของยางมีค่าตี่ที่สุด

Pongprayoon และคณะ [24] ในงานวิจัยนี้จะใช้ชั้นฟิล์มนางเคลือบบน Cotton โดยอาศัยกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน โดยใช้สไตรีนเป็นมอนอมอร์และใช้เคลือบลงบน Cotton จากนั้นจะศึกษาผลกระทบของสารลดแรงตึงผิว สไตรีน ตัวริเริ่มและความเข้มข้นของสารละลายไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน จากนั้นจะศึกษาคุณสมบัติชั้นฟิล์มของพอลิสไตรีนโดยใช้ SEM FTIR และ GPC ชั้นฟิล์มของพอลิสไตรีนที่เคลือบบนผิว Cotton จะไปเพิ่มความไม่มีข้าวให้กับพื้นผิวของ Cotton ทดสอบโดยการ Drop Test ผลการทดลองที่ได้พบว่า ชั้นฟิล์มของพอลิสไตรีนที่เคลือบบนผิว Cotton จะทำให้พื้นผิวของ Cotton มีคุณสมบัติไม่ดูดซับน้ำได้มากกว่า 30 นาที

Nantasorot และคณะ [4] ศึกษาการปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติโดยใช้ชิลิกาที่ผ่านการปรับปรุงแล้วจากปฏิกิริยาแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันแบบระบบต่อเนื่อง ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เอกซ์เดซิลไดรเมทิลแอมโมเนียมไบร์มาด (Hexadecyltrimethylammoniumbromide : CTAB) เป็นสารลดแรงตึงผิวและใช้สไตรีนกับไอโซพรีนเป็นโคอมอนอมอร์ พบว่าชิลิกาที่ผ่านการปรับปรุงแล้วสามารถลดพื้นที่ผิว (BET Surface Area) และเพิ่มค่าเฉลี่ยการเกะด้ว (Mean Agglomerate) เมื่อนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีฟูเรย์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด (FT-IR) แสดงให้เห็นการมีอยู่ของสไตรีนและไอโซพรีน เมื่อนำชิลิกาที่ผ่านการปรับปรุงผิวแล้วไปผสมกับยางจะส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการคงรูป (T_{90} Cure Time) ลดลง รวมทั้งปรับปรุงค่าโมดูลัส ความต้านทานต่อการเสียดสี (Abrasion Resistance) และความต้านการกดอัด (Compression Set) สะท้อนที่ทำให้ได้ผลการวิจัยที่ดีที่สุดคือ ใช้โคมอนโนเมอร์ 5 กรัมต่อชิลิกา 1 กิโลกรัม โดยใช้เวลาในการทำปฏิกิริยา 30 นาที

Chaisirimahamorakot และคณะ [25] ศึกษาการปรับปรุงผิวชิลิกาเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในยางด้วยวิธี แอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์เชชันแบบต่อเนื่อง พบว่า การใช้กระบวนการการแอดไมเซลล์-ลาร์พอลิเมอร์เชชันสามารถทำให้ชิลิกาและยางผสมเข้ากันได้ดี การปรับปรุงผิวชิลิกานี้ทำให้พื้นที่ผิวชิลิกาลดลง และมีค่ากึ่งกลางของขนาดการจับตัวของเม็ดชิลิกาเพิ่มขึ้น ผลกระทบเครื่องสแกนนิ่ง-อิเล็คตรอน ไมโครสโคป พนักงานเพิ่มขึ้นของกระบวนการเกาะตัวกันของเม็ดชิลิกา และผลจากพูเรียทรานฟอร์ม อินฟราเรดสเปกตรอสโคป พนักงานเพิ่มขึ้นของสไตรีน และไอโซพรีนบนผิวชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุง จากนั้นเมื่อพิจารณาถึงปริมาณเมอนอมอร์และเวลาที่ใช้ทำปฏิกริยาต่อกระบวนการการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์เชชัน พบว่า 5 กรัมเมอนอมอร์ต่อ 1 กิโลกรัม ชิลิกา และเวลาการทำปฏิกริยา 60 นาที จะให้ปริมาณพอลิเมอร์สูงที่สุดบนผิวชิลิกา

Sam [26] ศึกษาการปรับปรุงและวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นผิวของสไตรีนบนชิลิกา ทดลองโดยกระบวนการการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์เชชัน : สารริ่มปฏิกริยาพอลิเมอร์เชชันแบบละลายน้ำ (VA-044) และแบบไม่ละลายน้ำ (AIBN) โดยใช้ CTAB เป็นสารลดแรงตึงผิว พบว่า การดูดซับของ CTAB บนชิลิกาชนิดไม่มีรูพรุนมีค่าประมาณ 130 ไมโครโมลาร์ต่อกรัมชิลิกา ในขณะที่แอดไฮดรอเจลของสไตรีนใน CTAB เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณสไตรีนเพิ่มขึ้น ซึ่งเวลาที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแอดไมเซลลาร์คือ 2 ชั่วโมง และเมื่อทดลองเปลี่ยนอัตราส่วนปริมาณเมอนอมอร์ต่อสารก่อปฏิกริยาทั้ง 2 ชนิด จำนวน 8 อัตราส่วน พบว่า สารก่อปฏิกริยานิดละลายน้ำ (VA-044) จะช่วยให้เกิดพอลิเมอร์ฟิล์มที่มีน้ำหนักโนเกลกูลสูงกว่า พอลิเมอร์ฟิล์มที่ได้จากสารก่อปฏิกริยานิดไม่ละลายน้ำ (AIBN) โดยฟิล์มที่เกิดขึ้นมีความหนาอยู่ในช่วง 2 ถึง 15 นาโนเมตร

Aurumruayvan และคณะ [27] ศึกษาผลกระทบความเข้มข้นของดั้วกระตุ้น, จำนวนเมอนอมอร์ และจำนวนสารลดแรงตึงผิว ที่มีต่อคุณสมบัติของพอลิสไตรีนที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยวิธี แอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์เชชันบนผิวชิลิกาที่ไม่มีรูพรุน (Aerosil® OX50) โดยเมื่อใช้เวลาในการทำปฏิกริยาสองชั่วโมง และอัตราส่วนระหว่างดั้วกระตุ้นและเมอนอมอร์ ที่ไม่ควรน้อยไปกว่า 1 : 15 พบว่า อัตราการเกิดพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโนเกลกูลสูงเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น และเมื่อการยึดเกาะของสารลดแรงตึงผิวเพิ่มขึ้น และการละลายในชั้นไมเซลที่ยึดเกาะสไตรีนที่ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวเพิ่มขึ้น จาก 20 ไมโครโมล เป็น 100 ไมโครโมลต่อกรัมชิลิกา พบว่า พอลิสไตรีนที่เกิดบนผิว ชิลิกาจะมีลักษณะแผ่นขยายมากขึ้น และจำนวนพอลิสไตรีนที่เกิดบนผิวชิลิกาจะมีมากขึ้นตามลำดับ

Nantasorn และคณะ [28] ศึกษาการปรับปรุงผิวชิลิกาเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในยางด้วยวิธีแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์เชชันแบบต่อเนื่องของระบบที่ใช้ CTAB เป็นสารลดแรงตึงสไตรีนและไอโซพรีนเป็นโคมเมอนอมอร์ ผิวโดยเปรียบเทียบสมบัติของยางคอมปาวด์ พบว่า การใช้กระบวนการการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์เชชันสามารถทำให้ชิลิกาและยางผสมเข้ากันได้ดี

ซึ่งการปรับปรุงผิวชีลิกาจะทำให้พื้นที่ผิวชีลิกาลดลง และมีค่ากึ่งกลางของขนาดการจับตัวของเม็ดชีลิกาเพิ่มขึ้น โดยชีลิกาที่ปรับปรุงด้วยกระบวนการแอดไมเซลาร์ พอลิเมอไรเซชันสามารถลดเวลาการคงรูปยาง ลดอุดนค่า โนดูลัส และค่าความด้านทานการขัดถู ซึ่งให้ผลที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชีลิกาทั่วไป หรือกับชีลิกาในระบบแบบทั่วไป เนื่องจากระบบแบบต่อเนื่องสามารถคงตัวคุณสมบัติต่างๆ ได้มากกว่าระบบแบบทั่วไปโดยปริมาณมอนомерและเวลาที่ใช้ทำปฏิกิริยาต่อกระบวนการแอดไมเซลาร์ พอลิเมอไรเซชัน พบว่า 5 กวั้นมอนomer ต่อ 1 กิโลกรัม ชีลิกา และเวลาการทำปฏิกิริยา 30 นาที จะให้ปริมาณพอลิเมอร์สูงที่สุดบนผิวชีลิกา

ผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่ศึกษาเกี่ยวกับการนำคลีน์ไมโครเวฟ พอลิเมอไรเซชันต่างๆ ได้แก่

Zhub และคณะ [29] ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาอิมัลชันพอลิเมอไรเซชันของเมทธิลเมทาไครเลต (Methyl Methacrylate : MMA) ภายใต้การฉายคลีน์ไมโครเวฟ (Pulsed Microwave Irradiation : PMI) โดยปัจจัยสำคัญที่ศึกษาคือ เวลาในการทำปฏิกิริยา พบว่า เมื่อใช้เวลาการฉายคลีน์ไมโครเวฟช่วงสั้นๆ อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มสูงขึ้นและน้ำหนักของพอลิเมอร์จะมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการที่ใช้ความร้อนในการทำปฏิกิริยา (Conventional Heating : CH); ความเข้มข้นของตัวเริ่ม พบว่า กระบวนการ Microwave Irradiation (MI) จะใช้ความเข้มข้นของตัวเริ่ม ($0.2\% \text{ wt.}$) น้อยกว่ากระบวนการ CH ($0.4\% \text{ wt.}$) ถึง 2 เท่า และที่ความเข้มข้นของ ตัวเริ่มทุกค่า การฉายคลีน์ไมโครเวฟจะให้ค่า Conversion ที่สูงกว่ากระบวนการที่ใช้ความร้อน โดยที่ความเข้มข้นของตัวเริ่มต่ำ ($0.1\% \text{ wt.}$) กระบวนการ CH เกือบทั้งหมดจะไม่เกิดการ พอลิเมอไรซ์เลย; กำลังในการฉาย พบว่า ที่ค่า Conversion เดียว กัน (90%) กำลังในการฉายคลีน์ไมโครเวฟที่ต่ำ (30.2 kW) จะใช้พลังงานในการฉายคลีน์ไมโครเวฟน้อยกว่ากำลังในการฉายคลีน์ไมโครเวฟที่สูง (120.4 kW) แต่ที่ค่า Conversion เดียว กัน (90%) กำลังในการฉายคลีน์ไมโครเวฟที่ต่ำจะใช้เวลาในการทำปฏิกิริยามากกว่ากำลังในการฉายคลีน์ไมโครเวฟที่สูง

Zhub และคณะ [30] ทำการทดลองปฏิกิริยาอิมัลชัน พอลิเมอไรเซชัน ของสไตร์นสำเร็จ โดยใช้โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต (Potassium Persulfate : KPS) เป็นตัวเริ่มในการเกิดปฏิกิริยา และใช้โซเดียมโดเดคซิลซัลโฟเนต (Sodium Dodecylsulfonate) เป็น Emulsifier ภายใต้กระบวนการ PMI ที่กำลังสูง โดยศึกษาถึงผลของอุณหภูมิ, ความเข้มข้นของตัวเริ่ม, ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการฉายคลีน์ไมโครเวฟ (กำลังในการฉาย, Duty Cycle, พลังงานในการฉาย และ ช่วงของการสั่น) ที่มีต่อกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน โดยเปรียบเทียบกับกระบวนการ CH ผลที่ได้พบว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรซ์ มีส่วนสำคัญที่ทำให้อัตราการแตกตัวของ KPS ($2.4 \text{ เท่า เมื่อเทียบกับกระบวนการที่ใช้ CH}$) เพิ่มขึ้น สำหรับความเข้มข้นของตัวเริ่มใช้

ความเข้มข้นที่ 0.10 และ 0.20 wt% พนว่าให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาภายใต้กระบวนการ MI มีค่าเท่ากับ 129% และ 38% ตามลำดับ ผลของสภาวะที่ใช้กระบวนการ PMI จะมีผลที่ต่างกัน เมื่อเทียบกับกระบวนการ CH ในส่วนของอุณหภูมิการเกิด Glass-Transition (T_g) และ ความสม่ำเสมอของเนื้อพอลิเมอร์ ภายใต้สภาวะ PMI และ CH พนว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งบ่งบอกได้ว่า การใช้สภาวะ PMI มีผลกระทบน้อยต่อสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างของพอลิเมอร์

Chen และคณะ [31] ศึกษาผลการควบคุมการเกิด เรเดคัล พอลิเมอไรเซชัน ของ MMA โดยใช้สารเคมี AIBN/CuBr₂/2,2'-bipyridine (bpy)/CH₃CN & AIBN/CuCL/bpy เป็นตัวเริ่มในการเกิดปฏิกิริยาภายใต้การฉาบคลีนไมโครเวฟพบว่า สามารถควบคุมน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ MMA ได้โดยมีการกระจายตัวของพอลิเมอร์ที่ต่ำ จากนั้นศึกษาผลของเวลาที่ใช้ทำปฏิกิริยา อัตราส่วนการใช้ มองอเมอร์ต่อตัวเริ่ม น้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการ MI เปรียบเทียบกับกระบวนการ CH ในการทำปฏิกิริยาผลที่ได้พบว่า การใช้กระบวนการ MI ให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มสูงขึ้น การกระจายตัวของพอลิเมอร์อยู่ในช่วงแคบๆ และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่น้อยลงกว่าเดิม

Klun และคณะ [32] ศึกษาการสลายตัว (Depolymerization) ของพอลิเอไมด์-6 โดยพิจารณาปริมาณโมเลกุลเส้นตรงของการละหมาดโพรอีด (ϵ -Aminocaproic Acid) ภายใต้การฉาบคลีนไมโครเวฟที่กำลังการฉาบ 200 วัตต์ เป็นระยะเวลา 12 ถึง 23 นาที พนว่า ที่กำลังการฉาบคลีนไมโครเวฟ 200 วัตต์ ที่ระยะเวลา 12 ถึง 15 นาที ปริมาณการเกิดโมเลกุลเส้นตรงเพิ่มสูงขึ้น 35 % ยืนยันถึงการเกิดฟิล์มพอลิเอไมด์ที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อให้เวลาการฉาบคลีนไมโครเวฟนานขึ้นถึง 20 นาที ปริมาณการเกิดโมเลกุลเส้นตรงที่ได้กลับลดลงเกือบถึง 60 % ผลที่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเวลาการฉาบคลีนไมโครเวฟ 23 นาที ปริมาณที่ลดลงของโมเลกุลเส้นตรงการละหมาดโพรอีด ค้าโพรอีด ยืนยันถึงการสลายตัวของพอลิเอไมด์-6 เมื่อใช้เวลาการฉาบคลีนไมโครเวฟนานกว่า 15 นาที

Liu และ Su [33] ศึกษาถึงความเสถียรทางความร้อนของวัสดุนาโนคอมโพสิตที่เตรียมด้วยปฏิกิริยา In-situ พอลิเมอไรเซชัน ของ สไตริน กับ Macromonomer ภายใต้การฉาบคลีนไมโครเวฟ (Microwave Irradiation) พนว่า เปอร์เซ็นต์การกราฟท์ (PG%) ของสภาวะที่ดีที่สุดมีค่าถึง 33.14 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเปอร์เซ็นต์ Conversion (C%) ของสไตรินเท่ากับ 98.92 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวัดน้ำหนักทางความร้อน (Thermogravimetric Analysis : TGA) พนว่า ผลิตภัณฑ์ชิลิกาที่ผ่านการทำปฏิกิริยาโดยพอลิเมอไรเซชันจะมีค่าความเสถียรทางความร้อนดีกว่าชิลิกาที่ไม่ได้ผ่านการทำปฏิกิริยา หรือดีกว่าการใช้พอลิสไตรีนเพียงอย่างเดียว

Zhu และคณะ [34] ศึกษาถึงปฏิกิริยาอิมัลชัน พอลิเมอไรเซชันของสไตริน โดยใช้ไนโตรออกไซด์ (Nitroxide) เป็นสื่อในการทำให้มอนอเมอร์เกิดการแตกตัวภายใต้การฉาบคลีนไมโครเวฟ (Microwave Irradiation) ที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส พนว่า พอลิเมอร์

ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาจะมีน้ำหนักโมเลกุลและมีค่าเปอร์เซ็นต์ Conversion ที่เพิ่มขึ้น และมีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลอยู่ในช่วงที่แคบ โดยคอลลอยด์ที่ได้จะมีลักษณะคล้ายน้ำยาง นอกจากนั้นยังศึกษาถึงความแตกต่างของแหล่งที่ให้ความร้อนแก่ระบบ โดยทำการเปรียบเทียบระบบที่ให้ความร้อนด้วยการฉายคลื่นไมโครเวฟ และระบบที่ให้ความร้อนในแบบธรรมด้า (Conventional Heating) พบว่า อนุภาคของคอลลอยด์ที่ได้จากการบดที่ให้ความร้อนด้วยการฉายคลื่นไมโครเวฟจะมีขนาดอนุภาคและน้ำหนักโมเลกุลที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคของคอลลอยด์ที่ได้จากการบดที่ให้ความร้อนในแบบธรรมด้า

Correa และคณะ [35] ศึกษาถึงปฏิกิริยาอิมัลชัน พอลิเมอร์เรซันของสไตรินภายใต้การฉายคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Irradiation) ซึ่งมี Potassium Persulfate ($K_2S_2O_8$) ความเข้มข้น 0.04 - 0.16% wt ทำหน้าที่เป็นตัวเริ่มโดยใช้กำลังการฉายที่ 175 วัตต์และ 800 วัตต์ สำหรับระยะเวลาการฉาย 360 วินาที พบว่า ที่ค่าเปอร์เซ็นต์ Conversion ของสไตรินเท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์ กำลังการฉายที่ 800 วัตต์ จะใช้ระยะเวลาเพียง 60 วินาทีส่วนกำลังการฉายที่ 175 วัตต์ จะใช้ระยะเวลาถึง 360 วินาที แสดงถึงพลังงานที่มากกว่าที่ไปหนีไยานามोเลกุล จนกลายเป็นความร้อนให้กับระบบได้เร็วกว่า และเมื่อพิจารณาที่ปริมาณความเข้มข้นของตัวเริ่ม พบว่า ที่ระยะเวลาในการฉายคลื่นเดียวกัน ความเข้มข้นของตัวเริ่ม 0.04% wt จะให้ค่าเปอร์เซ็นต์ Conversion น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มข้นของตัวเริ่ม 0.08, 0.12 และ 0.16% wt แต่เมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นของตัวเริ่ม 0.08, 0.12 และ 0.16% wt กลับพบว่า ที่ระยะเวลาในการฉายคลื่นเดียวกันค่าเปอร์เซ็นต์ Conversion ที่ได้กลับมีค่าใกล้เคียงกัน นอกจากนั้นยังศึกษาถึงความแตกต่างของแหล่งที่ให้ความร้อนแก่ระบบ โดยพบว่า ที่ค่าเปอร์เซ็นต์ Conversion เดียวกัน ระบบที่ให้ความร้อนในแบบธรรมด้า (Conventional Heating) ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จะใช้เวลาในการทำปฏิกิริยานานถึง 66 นาที

บทที่ 3

อุปกรณ์ และวิธีการดำเนินงานวิจัย

3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี

3.1.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี สำหรับกระบวนการแอดไม้เซลลาร์ พอลิเมอร์ เชื้อรา

3.1.1.1 เครื่องมือ

ก) เตาอบไมโครเวฟ รุ่น MW102W ยี่ห้อ Samsung

ข) เครื่องวิเคราะห์ลักษณะหมุนฟังก์ชัน (Fourier Transform Infrared Spectrometer) รุ่น Spectrum 2000 ของบริษัท Perkin Elmer

ค) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการดู (Scanning Electron Microscope) รุ่น JSM-5410LV

ง) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่ง(Transmission Electron Microscope) รุ่น AJEM-200CX

จ) เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสง (UV-Visible – Spectrophotometer) รุ่น UV-Vis 500 ของบริษัท Unicam Analtech Co.,Ltd.

ฉ) เครื่องซั่งละเอียดทวนนิยม 3 ตำแหน่ง รุ่น PG 503-S ของบริษัท Mettler Toledo

ช) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH-Meter) รุ่น 1120 ของบริษัท Mettler Toledo

ซ) ตู้อบไฟฟ้า (Hot Air Oven) รุ่น UL40 ของบริษัท Memmert

ญ) ตู้แข็ง (Upright Cooler) รุ่น PT203 ของบริษัท Every Digital

ญญ) ปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump)

3.1.1.2 อุปกรณ์

ก) กระดาษกรองเบอร์ 5 ของบริษัท Wahtman

ข) ชุดกรองดูด (Buchner Funnel)

ค) เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 องศาเซลเซียส (Termometer)

ง) บีกเกอร์ขนาด 1000 ml, 250 ml และ 100 ml

จ) ปีเปต (Pipet) ขนาด 1 ml

ฉ) อุปกรณ์ให้ความร้อน (Hot Plate)

ช) แท่นแก้วกวนสาร

3.1.1.3 สารเคมี

- ก) ซิลิกา Hi-Sil[®] 255 (Silica) ของบริษัท Siam Silica Co.,Ltd
- ข) เชติลไตรเมทิลแอมโมเนียมบอร์ไนเตอร์ (Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide; CTAB)
- ค) ไอโซพรีน (Isoprene)
- ง) โพแทสเซียมเพอร์ซัลฟेट (Potassium Persulfate; K₂S₂O₈)
- จ) เดตร่าไโอลูฟูราณ (Tetrahydrofuran; THF)
- ฉ) น้ำ Deionized Water (DI)
- ช) โซเดียมไฮดรอกไซด์
- ซ) เอทานอล (Ethanol)
- ฌ) ยางธรรมชาติ (Natural Rubber; STR 5L)

3.1.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับกระบวนการการเตรียมและทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง

3.1.2.1 เครื่องมือ

- ก) เครื่องผสมยาง (External Mixer 6") ของบริษัท Lab Tech Engineering Company LTD.
- ข) เครื่องอัดขึ้นรูปยาง (Compression Mold) ของบริษัท DAH TYAN Industrial Co., LTD.
- ค) เครื่องทดสอบการคงรูปของยาง (Rheometer) รุ่น EK 100H ของบริษัท EEKON
- ง) เครื่องวัดความหนา (Gauge) ของบริษัท Teclock Corporation
- จ) เครื่องปั๊มชั้นงาน (Cutting Board and Machine) ของบริษัท CEAST
- ฉ) เครื่องทดสอบความทนต่อการสึกหรอของยาง (Abrasion Tester)

ของบริษัท FRANK

- ช) เครื่องทดสอบวัดแรงดึงจันชาด (Tensile Tester) ของบริษัท Instron

3.1.2.2 สารเคมี

- ก) กรดสเตียริก (Stearic Acid)
- ข) ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide)
- ค) วีดีง (Wax)
- ง) Polyethylene glycol (PEG 400)
- จ) สารด้าเจิม 22CP46
- ฉ) Mercapto Benzothiazyl Disulfide (MBTS)
- ช) TMTM
- ซ) ซัลเฟอร์ (Sulphur)

3.2 วิธีการดำเนินงานวิจัย

3.2.1 วิธีการเตรียมขั้นตอนการดูดซับของ CTAB บนพื้นผิวของชิลิกา

เซทิลไดเรเมทิลแอมโมเนียมไนโตรมีโนร์มาล 1.4 กรัม ละลายใน Deionized Water 100 มิลลิลิตร จากนั้นปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ จนสารละลายมีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 8 เดิมชิลิกาลงในสารละลาย 8 กรัม กวนสารละลายตลอดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3.2.2 วิธีการเตรียมขั้นตอนการปรับปรุงพื้นผิวชิลิกาโดยใช้ความร้อน

เดิมไอโซพริน 0.8 มิลลิลิตร ลงในสารละลาย 3.2.1 กวนสารละลายตลอดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลา เดิมเอทานอล และ โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต ตามปริมาณสารเคมีที่สภาวะต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3-1 จากนั้นกวนสารละลายให้เข้ากันอย่างช้าๆ โดยใช้ Hot Plate ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำสารละลายที่ผ่านการ พอลิเมอไรเซชันไปล้างโดยใช้ชุดกรองดูดกรองตะกอนชิลิกาออกจากสารละลาย จากนั้nl้างตะกอนชิลิกาด้วยน้ำอุ่นและ เอทานอล เพื่อกำจัด CTAB ที่เหลือและ ไอโซพรินที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยาออกจนหมด แล้วจึงนำตะกอนชิลิกาที่ได้ไปอบในเตาอบไฟฟ้าที่ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง

3.2.3 วิธีการเตรียมขั้นตอนการปรับปรุงพื้นผิวชิลิกาโดยใช้คลีนไมโครเวฟ

เดิมไอโซพริน 0.8 มิลลิลิตร ลงในสารละลาย 3.3.1 กวนสารละลายตลอดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลา เดิมเอทานอล 10.02 มิลลิลิตร และโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต 0.22 กรัม จากนั้นนำสารละลายที่ได้เตรียมใส่หลอดทดลอง นำหลอดทดลองที่บรรจุสารละลายวางในชั้นวางไมโครเวฟ แล้วนำเข้าเตาอบไมโครเวฟ โดยเปลี่ยนแปลงกำลังการฉายและเวลาการฉายคลีนไมโครเวฟเพื่อหา สภาวะการฉายคลีนไมโครเวฟที่เหมาะสมตามตารางที่ 3-2 เมื่อครบกำหนดเวลา นำสารละลายที่ผ่านการพอลิเมอไรเซชันไปล้าง ตามขั้นตอนที่ 3.2.2 จากนั้nonจนแห้งแล้วจึงนำไปวิเคราะห์

ตารางที่ 3-1 ปริมาณสารเคมีของการปรับปรุงผิวชิลิกาในระบบการใช้ความร้อน

ปริมาณชิลิกา (กรัม)	ปริมาณ CTAB (กรัม)	ปริมาณ เอทานอล (มิลลิลิตร)	ปริมาณ ไอโซพริน (มิลลิลิตร)	ปริมาณ $K_2S_2O_8$ (กรัม)
8	1.40	10.02	0.27	0.07
				0.22
				0.66

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

ปริมาณซิลิกา (กรัม)	ปริมาณ CTAB (กรัม)	ปริมาณ ເອການອລ (ມີລສິລິດຣ)	ปริมาณ ໄໂໂຫ່ພຣີນ (ມີລສິລິດຣ)	ปริมาณ $K_2S_2O_8$ (กรัม)
8	1.40	10.02	0.8	0.07
				0.22
				0.66
8	1.40	10.02	2.4	0.07
				0.22
				0.66

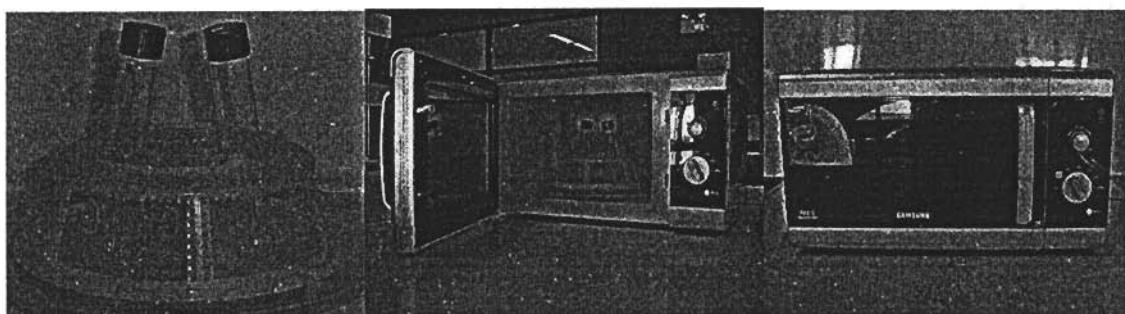
ตารางที่ 3-2 ปริมาณสารเคมีของการปรับปรุงผิวซิลิกาในระบบการจ่ายคลื่นไมโครเวฟ

ปริมาณ ซิลิกา (กรัม)	ปริมาณ CTAB (กรัม)	ปริมาณ ເອການອລ (ມີລສິລິດຣ)	ปริมาณ ໄໂໂຫ່ພຣີນ (ມີລສິລິດຣ)	ปริมาณ $K_2S_2O_8$ (กรัม)	กำลัง การฉาย (ວັດຈີ)	เวลา การฉาย (ວິນາທີ)
8	1.40	10.02	0.8	0.22	180	30
						60
						90
						120
						180
					850	240
						10
						20
						30
						40
						60
						90

เมื่อได้สภาวะการจ่ายคลื่นไมโครเวฟที่เหมาะสมแล้ว จึงทดลองเปลี่ยนแปลงปริมาณ
มอนออมคร์และปริมาณดั่วไวเริ่ม เพื่อหาสภาวะปริมาณสารที่เหมาะสมในการจ่ายคลื่นไมโครเวฟ
ดังแสดงในตารางที่ 3-3 จากนั้nobjnແທ້ແລ້ວຈຶ່ງໄປວິເຄາະໜ້າ

ตารางที่ 3-3 ปริมาณสารเคมีของการปรับปรุงผิวชิลิกาในระบบการเปลี่ยนความเข้มข้น
นอนอเมอร์และดัลวิเริ่มที่สภาวะการจ่ายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา
30 วินาที

ปริมาณ ชิลิกา (กรัม)	ปริมาณ CTAB (กรัม)	ปริมาณ เอทานอล (มิลลิลิตร)	ปริมาณ ไอโซพรีน (มิลลิลิตร)	ปริมาณ $K_2S_2O_8$ (กรัม)
8	1.40	10.02	0.27	0.22
				0.11
				-
			0.8	0.22
				0.11
				-
		2.4	0.22	0.22
				0.11
				-



ภาพที่ 3-1 หลอดทดลองและเตาอบไมโครเวฟ รุ่น MW 102W ของ ซัมซุง

3.3 การพิสูจน์คุณลักษณะและลักษณะพื้นผิวของชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงผิว ด้วยกระบวนการ แอดไฮเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน

3.3.1 การทดสอบสมบัติความไม่ชอบน้ำ (Hydrophobicity Test)

นำชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงผิวประมาณ 1 กรัม ลอกบลนผิวน้ำ เพื่อแสดงลักษณะของ
ความไม่ชอบน้ำและเป็นการยืนยันถึงการมีของพิล์มพอลิไอโซพรีนบนผิวชิลิกา โดยเปรียบเทียบ
กันระหว่าง ชิลิกาที่ไม่ได้รับการปรับปรุง ชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงในระบบการใช้ความร้อน

และชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงในระบบการฉายคลื่นไมโครเวฟ สำหรับกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน

3.3.2 การวิเคราะห์ลักษณะหมุนผังรัชนีเฉพาะบนผิวชิลิกา ด้วยวิธีฟูเรียร์ทรายฟอร์ม อินฟารेट-สเปคโตรสโคปี (Fourier Transform Infrared Spectroscopy : FTIR)

เตรียมสารตัวอย่างด้วยเทคนิคแบบ KBr-pellet โดยนำ KBr มาบดผสมในชิลิกาที่ได้รับ การปรับปรุงผิวที่จะวิเคราะห์ จากนั้นนำไปอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นใส แล้วนำไปวิเคราะห์เพื่อหาหมุนผังรัชนีเฉพาะ โดยเปรียบเทียบกันระหว่างชิลิกาที่ไม่ได้รับการปรับปรุง ชิลิกาที่ได้รับ การปรับปรุงในระบบการใช้ความร้อน และชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงในระบบการฉายคลื่นไมโครเวฟ สำหรับกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน

3.3.3 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวชิลิกาด้วยวิธี สแกนนิ้งอิเล็คทรอนไมโครสโคปี (Scanning Electron Microscope: SEM)

นำชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงผิวมาวางบนแป้นทองเหลืองแล้วนำไปเคลือบทอง จากนั้น นำไปเข้าเครื่อง SEM เพื่อวิเคราะห์ลักษณะผิวและลักษณะการกระจายตัวของพอลิเมอร์บนผิวชิลิกา โดยเปรียบเทียบกันระหว่าง ชิลิกาที่ไม่ได้รับการปรับปรุง ชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงใน ระบบการใช้ความร้อน และชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงในระบบการฉายคลื่นไมโครเวฟ สำหรับ กระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน

3.3.4 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวและขนาดของชิลิกาด้วยวิธี ทรายสมิชันอิเล็คทรอน-ไมโครสโคปี (Transmission Electron Microscope : TEM)

นำชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงผิวมาวางบนกริทแล้วนำไปเคลือบทอง จากนั้นนำไปเข้าเครื่อง TEM เพื่อวิเคราะห์ลักษณะผิวและขนาดของชิลิกา โดยเปรียบเทียบกันระหว่าง ชิลิกาที่ไม่ได้รับ การปรับปรุง ชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงในระบบการใช้ความร้อน และชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุง ในระบบการฉายคลื่นไมโครเวฟ สำหรับกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน

3.4 วิธีการเตรียมขั้นตอนการสกัดฟิล์มที่เคลือบบนพื้นผิวชิลิกา

เตรียมชิลิกาที่ผ่านการอบจนแห้ง 1 กรัม ละลายในเตตระไฮโดรฟูราน หรือ โกลูอิน 22 มิลลิลิตร กวนและให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เมื่อสารละลายอุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง กรองชิลิกาออกจากสารละลาย และ นำสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์การดูดกลืนแสง โดยทดสอบด้วยวิธี UV-Visible Spectrophotometer (UV) ส่วนตากองนชิลิกาที่กรองได้ นำไปอบเพื่อให้ความชื้นจนแห้งแล้ว นำมาคำนวณหา % Weight Loss โดยเปรียบเทียบกันระหว่าง ชิลิกาที่ไม่ได้รับการปรับปรุง ชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงในระบบการใช้ความร้อน และชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุงในระบบ การฉายคลื่นไมโครเวฟ สำหรับกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน

3.5 วิธีการเตรียมขั้นตอนการผสมเคมียางและขึ้นรูปยาง

เตรียมยาง STR 5L ขนาด 100 กรัม ทำการนวดโดยใช้เข้าเครื่องผสมยางเพื่อเป็นการเตรียมยางให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการผสมสารเคมี และยังเป็นการทำยางให้นิ่มเพื่อให้สารเคมีที่จะใส่ลงไปสามารถเกาะติดและผสมลงบนเนื้อยางได้ โดยให้ความร้อนที่สูงกลึงเป็นอุณหภูมิ 60 ถึง 70 องศาเซลเซียส เมื่อนวดยางจนนิ่มแล้ว ให้ส่วนผสมที่จะผสมตามสูตรยางที่กำหนดตามตาราง 3-4 อย่างต่อๆ กัน โดยเริ่มจาก ชิลิกาปรับปรุงผิว, Zinc Oxide, Stearic Acid, PEG 400, 22CP46 และ Wax ตามปริมาณที่กำหนด ตามลำดับ แล้วทำการนวดยางต่อจนกระหึ่งผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทำการใส่สารตัวเร่ง Cure Time โดยใส่ MBT, MBTS, TMTM และ Sulphur ตามปริมาณที่กำหนด ตามลำดับ แล้วทำการนวดยางต่อพร้อมกับกลับเนื้อยาง โดยใช้เหล็กปลายแหลมกรีดแผ่นยางเป็นมุมเฉียง เพื่อกลับเนื้อยางให้ส่วนผสมเข้ากัน เสร็จแล้ว จึงนำไปทดสอบการ Cure Time โดยใช้ Rheometer Tester เพื่อหาระยะเวลาในการอัดขึ้นรูป จากนั้นนำยางที่ได้ใส่แม่พิมพ์และเข้าเครื่องอัดขึ้นรูป ตามระยะเวลาที่ได้จากการทดสอบการ Cure Time เมื่อครบกำหนดเวลานำยางออกมาพักตัวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้แบบยางที่พร้อมนำไปตรวจสอบสมบัติจำเพาะของยาง โดยสมบัติจำเพาะของยางที่จะทดสอบแสดงดังตารางที่ 3-5

ตารางที่ 3-4 สูตรปริมาณสารในขั้นตอนการผสมเคมียาง

ส่วนประกอบ	อัตราส่วน
Natural Rubber	100
Silica	40
Zinc Oxide	3
Stearic Acid	1
Polyethylene glycol	1.2
22CP46	1
Wax	1
MBT	0.4
Mercapto Benzothiazyl Disulphide	0.8
TMTM	0.12
Sulphur	2.5

ตารางที่ 3-5 สมบัติในการวิเคราะห์ความจำเพาะของยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิว

สมบัติในการวิเคราะห์	วิธีการ	เครื่องมือ
Cure Time (t_{90} , min)	ASTM 2084-93 [37]	Rheometer Tester
Tensile Properties (Elongation to Break, %; Modulus, MPa)	ASTM-D 412-92 [38]	Tensile Tester
Tear Strength (N/mm)	ASTM-D 624 [39]	Tear Tester
Abrasion Loss (vol. Loss/kilocycles)	DIN-53516 [40]	Abrasion Tester

บทที่ 4

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะและขั้นตอนของงานวิจัย คือ

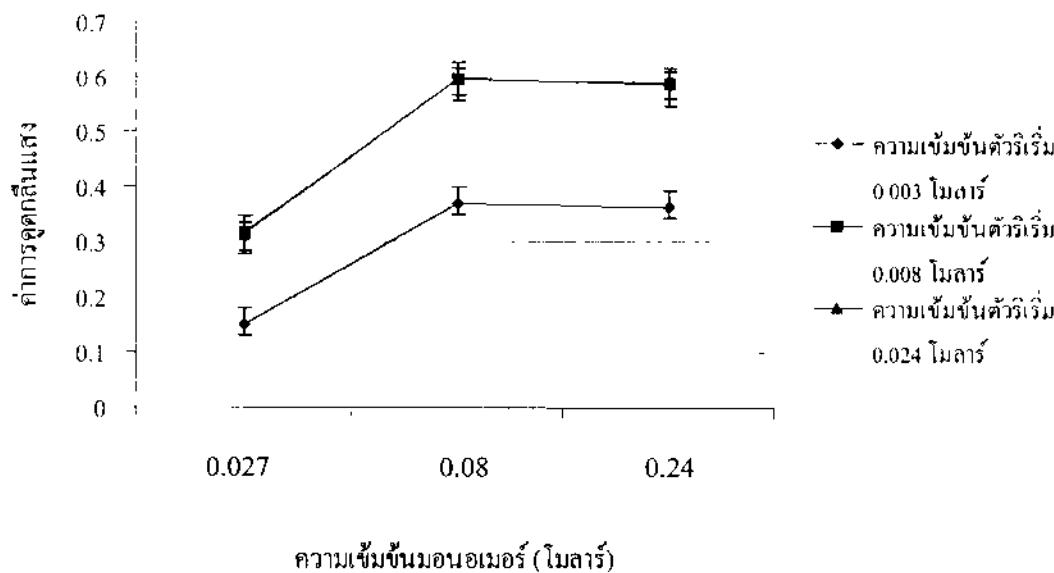
- 4.1 ผลของศึกษาปัจจัยที่มีต่อการกระจายตัวของพอลิเมอร์บนผิวชิลิกา
 - 4.2 ผลของพิสูจน์การมีอยู่ของฟิล์มพอลิไอโซพรีนบนผิวชิลิกา
 - 4.3 ผลของทดสอบสมบัติจำเพาะของยางธรรมชาติ
- ดังมีรายละเอียดของผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลองแต่ละหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

4.1 ผลของศึกษาปัจจัยที่มีต่อการกระจายตัวของพอลิเมอร์บนผิวชิลิกา

การวิจัยได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัวของพอลิเมอร์ บนผิวชิลิกา ที่สภาวะต่างๆ โดยปัจจัยที่ทำการศึกษา คือ ปริมาณความเข้มข้นของมอนอเมอร์ และตัวเริ่มในระบบการใช้ความร้อน ปริมาณกำลังการจ่ายคลื่นในโครเวฟ และเวลาในการทำปฏิกิริยา และปริมาณความเข้มข้นของมอนอเมอร์ และตัวเริ่มในระบบการใช้คลื่นในโครเวฟ

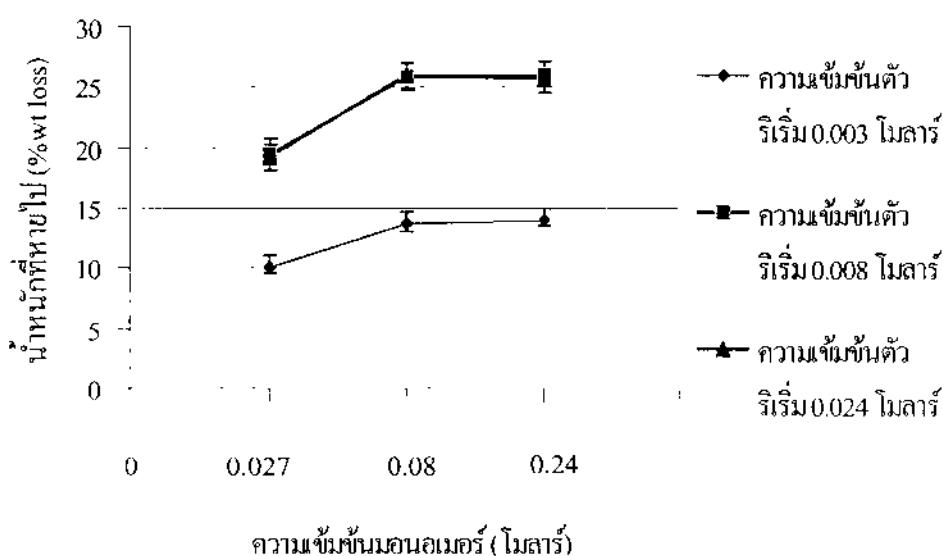
4.1.1 ผลของความเข้มข้นของมอนอเมอร์ และตัวเริ่มที่มีต่อการกระจายตัวของพอลิเมอร์ บนผิวชิลิกาที่เตรียมได้จากการบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน ในระบบการใช้ความร้อน

ผลการทดลองได้ทำการเบรเยนเทียนประสีทชิลิกาการเคลื่อนของพอลิไอโซพรีบนผิวชิลิกาด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี ยูวี สเปกโടสโคป ที่ความยาวคลื่น 236 nm ของสารสกัดด้วย THF ดังแสดงในภาพที่ 4-1 กับ เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปที่ได้จากการสกัดชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยสารสกัด THF ดังแสดงในภาพที่ 4-2 และสารสกัด Toluene ดังแสดงในภาพที่ 4-3

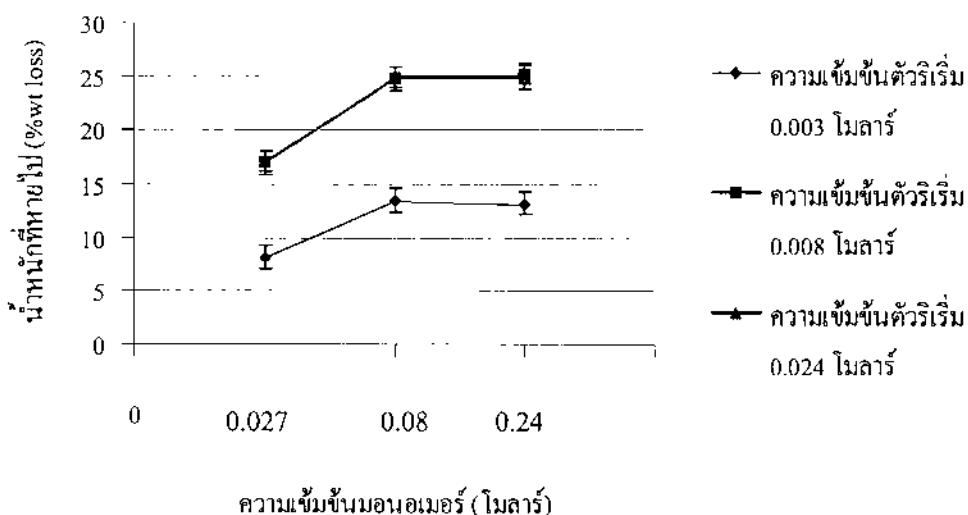


ภาพที่ 4-1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงยูวี กับความเข้มข้นมอนอเมอร์ที่ความเข้มข้นของดั้วยอดเริ่มต่างๆ ในระบบการใช้ความร้อน

จากภาพที่ 4-1 นำค่าการดูดกลืนแสงยูวีของชิ้นก้าที่ผ่านการปรับปรุงผ้าในระบบการใช้ความร้อนมาพล็อตกราฟ พบร้า เมื่อความเข้มข้นของมอนอเมอร์และดั้วยอดเริ่มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าการดูดกลืนแสงยูวีมีค่าเพิ่มขึ้น โดยได้ค่าการดูดกลืนแสงยูวีมากสุด คือ 0.5977 ในสภาวะการใช้ความเข้มข้นมอนอเมอร์ 0.08 โมลาร์ และความเข้มข้นดั้วยอดเริ่ม 0.008 โมลาร์



ภาพที่ 4-2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปกับความเข้มข้นมอนอเมอร์ที่ความเข้มข้นของดั้วยอดเริ่มต่างๆ ของสภาวะการใช้ความร้อน โดยใช้ THF เป็นสารสกัด



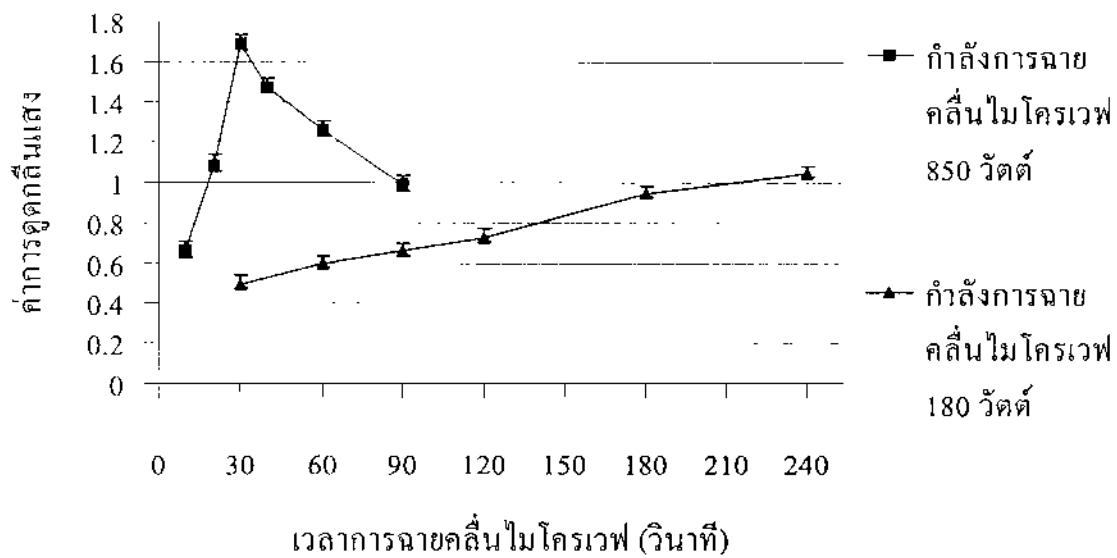
ภาพที่ 4-3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปกับความเสื่อมขั้น
มอนอเมอร์ที่ความเสื่อมขั้นของตัวเริ่มต่างๆ ของสภาวะการใช้ความร้อน⁴
โดยใช้ Toluene เป็นสารสกัด

จากผลของค่าการดูดกลืนแสงยูวี ผลที่ได้สอดคล้องกับเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปจากการนำชิลิกาปรับปรุงผิวระบบการใช้ความร้อนมาสกัดด้วย THF และ Toluene ดังแสดงในภาพที่ 4-2 และภาพที่ 4-3 พบว่า เมื่อความเสื่อมขั้นของมอนอเมอร์และตัวเริ่มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปมีค่าเพิ่มขึ้น โดยสภาวะการใช้ความเสื่อมมอนอเมอร์ 0.08 โมลาร์ และความเสื่อมขั้นตัวเริ่ม 0.008 โมลาร์ คือสภาวะที่ให้เบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปสูงที่สุด คือ 25.8 %wt loss

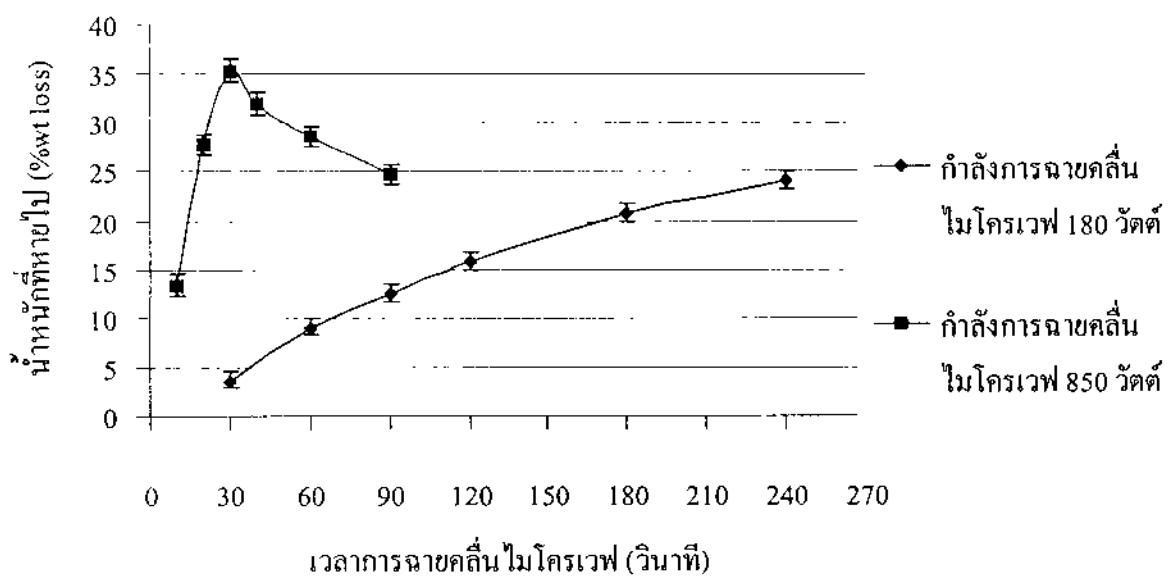
เมื่อทำการเปรียบเทียบเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไป จากการนำชิลิกาปรับปรุงผิวมาสกัดด้วยสารสกัด THF และ Toluene พบว่า ชิลิกาปรับปรุงผิวที่สกัดด้วย THF จะให้เบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปมากกว่าชิลิกาปรับปรุงผิวที่สกัดด้วย Toluene เนื่องจาก THF และ Toluene มีความสามารถในการละลายต่อโพลิไอโซพรีนที่ไม่เท่ากัน โดย THF จะมีความสามารถในการละลายที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Toluene

4.1.2 ผลของกำลังการฉาบเคลือบในครัวเรฟและเวลาในการทำปฏิกิริยาที่มีต่อการกระจายตัวของโพลิเมอร์บนผิวชิลิกา ที่เดรียมได้จากการวนการแอดไมเซลลาร์โพลิเมอไรเซชันในระบบการใช้เคลือบในครัวเรฟ

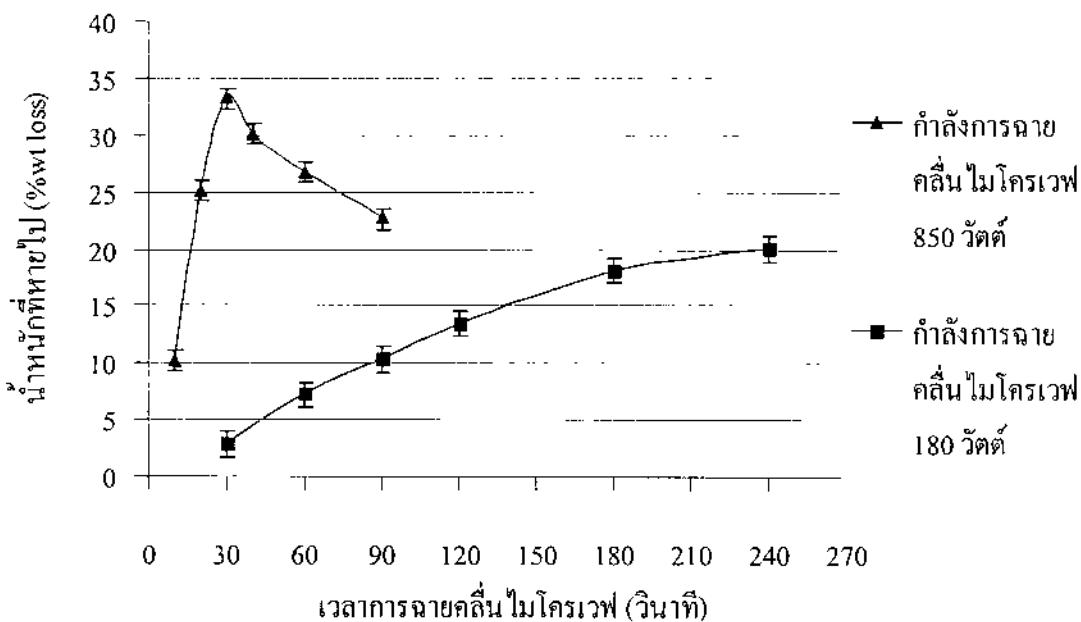
ผลการทดลองได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเคลือบ ของโพลิไอโซพรีนบนผิวชิลิกาด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี ยูวี สเปกโตรสโคปี ที่ความยาวคลื่น 236 nm ของสารสกัดด้วย THF ดังแสดงในภาพที่ 4-4 กับเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปที่ได้จากการสกัดชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยสารสกัด THF ดังแสดงในภาพที่ 4-5 และสารสกัด Toluene ดังแสดงในภาพที่ 4-6



ภาพที่ 4-4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแบ่งยูรี กับเวลาการจ่ายคลื่นไมโครเวฟ ที่กำลังการจ่ายคลื่นไมโครเวฟต่างๆ ในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ



ภาพที่ 4-5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไป กับเวลาการจ่ายคลื่นไมโครเวฟที่กำลังการจ่ายคลื่นไมโครเวฟต่างๆ ของสภาวะการใช้คลื่นไมโครเวฟโดยใช้ THF เป็นสารสกัด



ภาพที่ 4-6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์นำหนักที่หายไปกับเวลาการฉายคลีนไมโครเวฟที่กำลังการฉายคลีนไมโครเวฟต่างๆ ของสภาวะการใช้คลีนไมโครเวฟโดยใช้ Toluene เป็นสารสกัด

จากภาพที่ 4-4 เมื่อนำค่าการดูดกลืนแสงยูวีของชิลิกาที่ผ่านการปรับปรุงผิวในระบบการใช้คลีนไมโครเวฟมาพล็อตกราฟ พบว่า ที่กำลังการฉายคลีนไมโครเวฟ 180 วัตต์ เมื่อให้เวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นจาก 30 วินาที จนถึง 240 วินาที ปรากฏว่าค่าการดูดกลืนแสงยูวีมีค่าเพิ่มขึ้น และที่กำลังการฉายคลีนไมโครเวฟ 850 วัตต์ เมื่อให้เวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นจาก 10 วินาที จนถึง 30 วินาที ปรากฏว่าค่าการดูดกลืนแสงยูวีมีค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยที่สภาวะกำลังการฉายคลีนไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที จะให้ค่าการดูดกลืนแสงยูวีมากสุดถึง 1.6882 ในทางกลับกัน เมื่อให้เวลาในการทำปฏิกิริยามากกว่า 30 วินาที ค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่ได้กลับมีค่าลดลงทั้งนี้เนื่องจาก พลังงานที่ได้จากการใช้กำลังการฉายคลีนไมโครเวฟที่สูงเป็นระยะเวลานานๆ ก่อให้เกิดการสลายตัวของพอลิไอโซพรีน (Depolymerization) จึงทำให้ปริมาณฟิล์มบนพื้นผิวชิลิกาที่ได้ลดลง

จากผลของค่าการดูดกลืนแสงยูวี ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์นำหนักที่หายไปจากการนำชิลิกาปรับปรุงผิว ในระบบการใช้คลีนไมโครเวฟมาสกัดด้วยสารสกัด THF ตั้งแสดงในภาพที่ 4-5 และสารสกัด Toluene ดังแสดงในภาพที่ 4-6

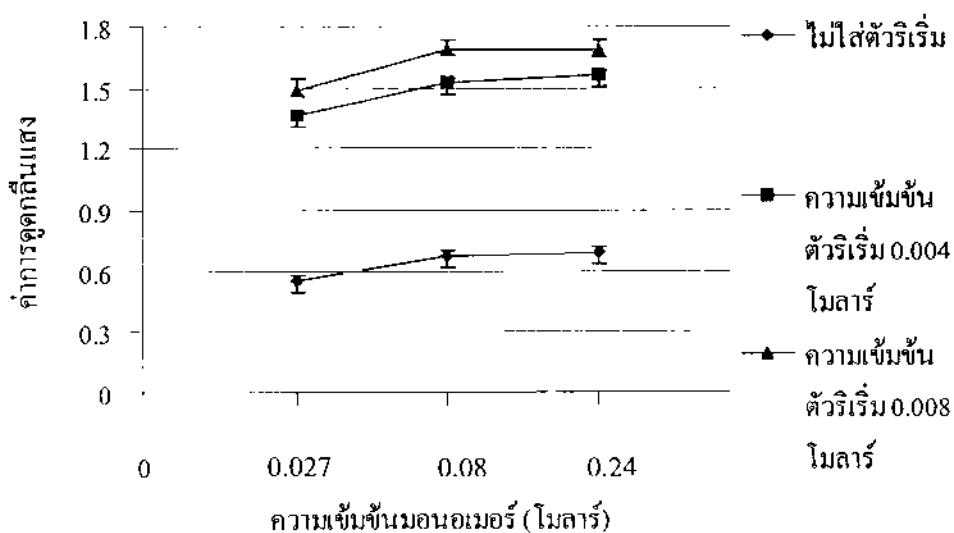
จากภาพที่ 4-5 และภาพที่ 4-6 เมื่อพิจารณากำลังการฉายคลีนไมโครเวฟ พบว่า ที่กำลังการฉายคลีนไมโครเวฟ 180 วัตต์ เมื่อให้เวลาการฉายคลีนไมโครเวฟเพิ่มขึ้นจาก 30 วินาที จนถึง 240 วินาที ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์นำหนักที่หายไปมีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนที่กำลังการฉายคลีนไมโครเวฟ 850 วัตต์ เมื่อให้เวลาการฉายคลีนไมโครเวฟเพิ่มขึ้นจาก 10 วินาที จนถึง 30 วินาที

ปรากฏว่าเบอร์เชินด์น้ำหนักที่หายไปมีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 วินาที ปรากฏว่าเบอร์เชินด์น้ำหนักที่หายไปที่ได้มีค่าลดลงเข่นกัน ซึ่งสภาวะการใช้กำลังการฉายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที จะเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับในการวิจัยครั้งนี้ โดยให้เบอร์เชินด์น้ำหนักที่หายไปมากที่สุดคือ 35.3%wt loss

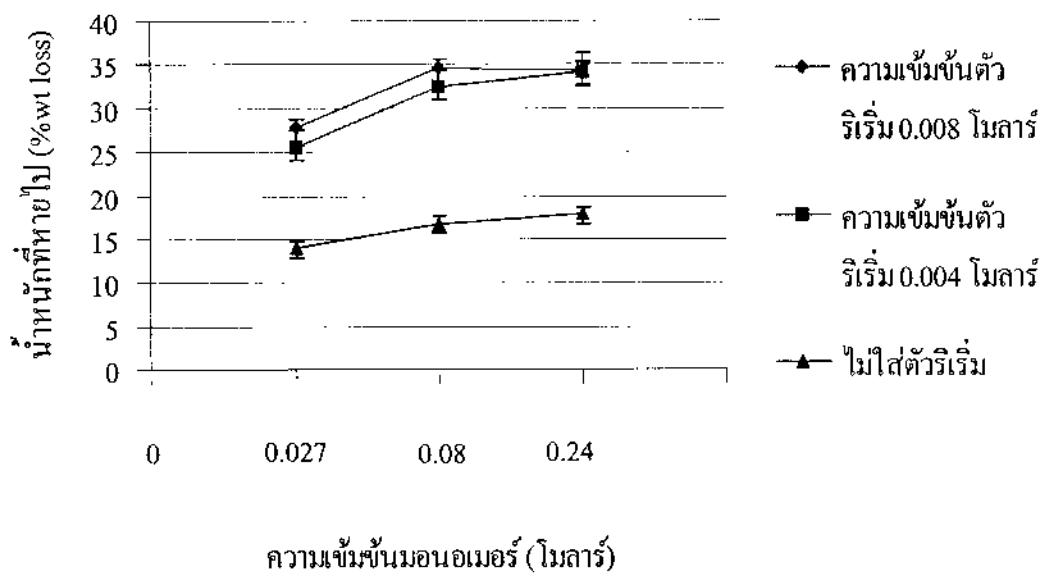
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเวลาในการทำปฏิกิริยา ระหว่างระบบการใช้ความร้อนที่ใช้เวลาในการทำปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง กับระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟที่ใช้เวลาในการทำปฏิกิริยา 30 วินาที พนบว่า ระบบที่ใช้คลื่นไมโครเวฟ สามารถลดเวลาการทำปฏิกิริยาได้ถึง 360 เท่า เนื่องจากการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ เป็นการให้ความร้อนแก่มโนเลกูลโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากการให้ความร้อนทั่วไปที่อาศัยหลักการนำ การพา จึงทำให้การใช้คลื่นไมโครเวฟ มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า

4.1.3 ผลของความเข้มข้นของมอนอเมอร์ และตัวเริ่มที่มีต่อการกระจายตัวของพอลิเมอร์ บนผิวซิลิกาที่เตรียมได้จากการวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน ในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ โดยใช้กำลังการฉายที่ 850 วัตต์ เป็นระยะเวลา 30 วินาที

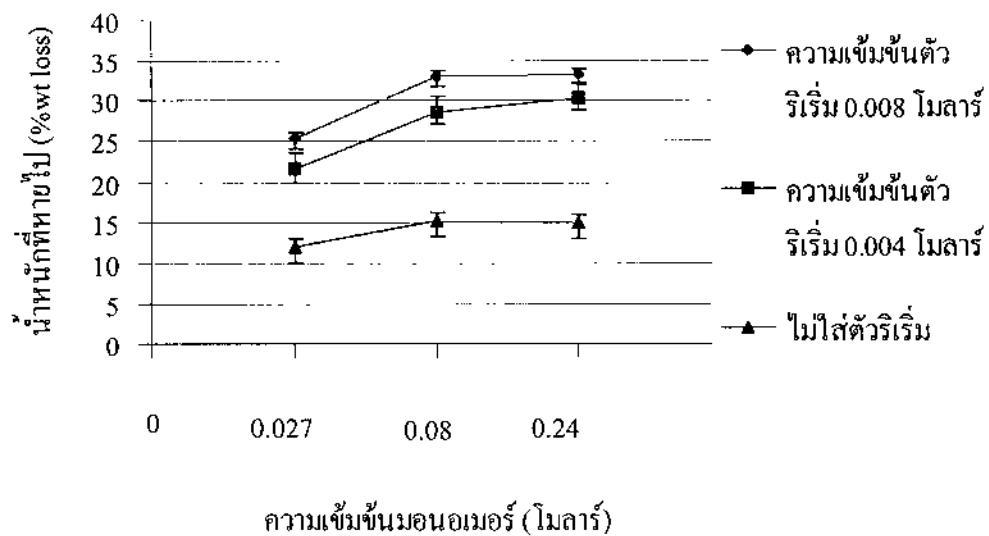
ผลการทดลองได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเคลือบของพอลิไอโซพրีนบนผิวซิลิกาด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี ยูวี สเปกโตรสโคปี ที่ความยาวคลื่น 236 nm ของสารสกัดด้วย THF ตั้งแสดงในภาพที่ 4-7 กับเบอร์เชินด์น้ำหนักที่หายไปที่ได้จากการสกัดซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยสารสกัด THF ตั้งแสดงในภาพที่ 4-8 และสารสกัด Toluene ตั้งแสดงในภาพที่ 4-9



ภาพที่ 4-7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงยูวี กับความเข้มข้นของมอนอเมอร์และตัวเริ่มต่างๆ ของสภาวะการใช้กำลังการฉายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์เป็นเวลา 30 วินาที



ภาพที่ 4-8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เช็นต์น้ำหนักที่หายไปกับความเข้มข้นมอนอเมอร์ที่ความเข้มข้นตัวริเริ่มต่างๆ ของสภาวะการใช้กำลังการฉายคลื่นในໂຄຣເວີມ 850 ວັດຕໍ່ເປັນເວລາ 30 ວິນາທີ ໂດຍໃຊ້ THF ເປັນສາງສັກດັບ



ภาพที่ 4-9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เช็นต์น้ำหนักที่หายไปกับความเข้มข้นมอนอเมอร์ที่ความเข้มข้นตัวริเริ่มต่างๆ ของสภาวะการใช้กำลังการฉายคลื่นในໂຄຣເວີມ 850 ວັດຕໍ່ເປັນເວລາ 30 ວິນາທີ ໂດຍໃຊ້ Toluene ເປັນສາງສັກດັບ

จากภาพที่ 4-7 เมื่อนำค่าการดูดกลืนแสงยูวีของชิลิกาที่ผ่านกระบวนการแอดไมเนลาร์ พอลิเมอไรซ์ันในระบบการใช้กำลังการฉายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที มาพล็อตกราฟเพื่อดูลักษณะแนวโน้มปริมาณการเกิดฟิล์มพอลิไอโซพรีน พบว่า เมื่อความเข้มข้น มองเอมอร์เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าการดูดกลืนแสงยูวีมีค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน

เมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นของตัวริเริ่ม พบว่า สภาวะที่ไม่ใส่ตัวริเริ่มค่าการดูดกลืน แสงยูวีที่ได้มีค่าน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ สภาวะที่ใส่ตัวริเริ่ม และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ สภาวะที่ใส่ตัวริเริ่มระหว่างการใช้ความเข้มข้นตัวริเริ่ม 0.004 โมลาร์ กับการใช้ความเข้มข้น ตัวริเริ่ม 0.008 โมลาร์ พบว่า ที่สภาวะการใช้ความเข้มข้นตัวริเริ่ม 0.008 โมลาร์ จะให้ค่า การดูดกลืนแสงยูวีสูงที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.6882 ส่วนที่สภาวะการใช้ความเข้มข้นตัวริเริ่ม 0.004 โมลาร์ ค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับสภาวะการใช้ความเข้มข้นตัวริเริ่ม 0.008 โมลาร์

จากค่าการดูดกลืนแสงยูวี ผลที่ได้สอดคล้องกับเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปจากการนำ ชิลิกาปรับปรุงผิวระบบการใช้กำลังการฉายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที มาสักัดด้วยสารสกัด THF ดังแสดงในภาพที่ 4-8 และสารสกัด Toluene ดังแสดงในภาพที่ 4-9 พบว่า

จากภาพที่ 4-8 และ ภาพที่ 4-9 เมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นของตัวริเริ่ม พบว่า สภาวะ ที่ไม่ใส่ตัวริเริ่ม เบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปมีค่าน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ สภาวะที่ใส่ตัว ริเริ่ม เนื่องจากเมื่อระบบปราศจากตัวริเริ่มซึ่งเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา เป็นผลทำให้การเกิด ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้การเกิดพอลิไอโซพรีนเกิดได้ในปริมาณที่น้อย จึงทำให้ ปริมาณพอลิไอโซพรีนที่สกัดได้มีปริมาณที่น้อยเช่นกัน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสภาวะ ที่ใส่ตัวริเริ่มระหว่างการใช้ความเข้มข้นตัวริเริ่ม 0.004 โมลาร์ กับการใช้ความเข้มข้นตัวริเริ่ม 0.008 โมลาร์ พบว่า ที่สภาวะการใช้ความเข้มข้นตัวริเริ่ม 0.008 โมลาร์ จะให้เบอร์เซ็นต์น้ำหนัก ที่หายไปมากที่สุด คือ 34.5%wt loss แสดงให้เห็นถึงปริมาณพอลิไอโซพรีนที่สกัดได้มีปริมาณ ที่มาก แต่ในทางกลับกันที่สภาวะการใช้ความเข้มข้นตัวริเริ่ม 0.004 โมลาร์ เบอร์เซ็นต์น้ำหนัก ที่หายไปกลับมีค่าใกล้เคียงกับสภาวะการใช้ความเข้มข้นตัวริเริ่ม 0.008 โมลาร์ เนื่องจาก การทำงานปฎิกริยาโดยการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ สามารถเหนี่ยวนำตัวริเริ่มให้เกิด การกระตุ้นปฏิกิริยาได้อย่างเต็มที่ ถึงแม่ว่าจะมีปริมาณความเข้มข้นตัวริเริ่มลดลงก็ตาม จึงอาจกล่าวได้ว่า การใช้คลื่นไมโครเวฟเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาแอดไมเนลาร์ พอลิเมอไรซ์ัน สามารถลดปริมาณตัวริเริ่มได้ถึง 50 เบอร์เซ็นต์

4.2 ผลของการพิสูจน์การมีอยู่ของฟิล์มพอลิไอโซพรีนบนผิวชิลิกา

การวิเคราะห์พื้นผิวของชิลิกาที่ได้รับการปรับปรุง และพิสูจน์การมีอยู่ของฟิล์ม พอลิไอโซพรีนบนผิวชิลิกา ทำได้โดยศึกษาจากคุณลักษณะความไม่ชอบน้ำและจากการทดสอบ

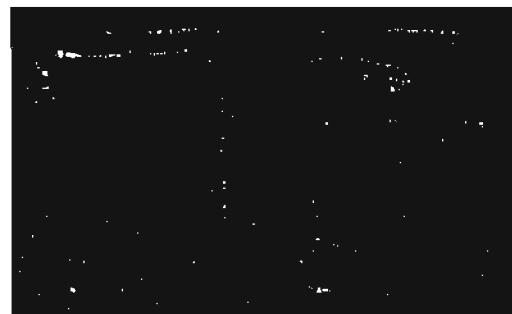
ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องมือวิเคราะห์ฟูเรียทรายฟอร์มอินฟารेड สเปคโตรสโคป (Fourier Transform Infared Spectroscopy : FTIR) เครื่องมือวิเคราะห์ ยูวี สเปคโตรสโคป (UV-Spectroscope) เครื่องมือวิเคราะห์สแกนนิ่งอีเล็คทรอนไมโครสโคป (Scanning Electron Microscope : SEM) และ เครื่องมือวิเคราะห์ทรายสมิธชันอีเล็คทรอน-ไมโครสโคป (Transmission Electron Microscope: TEM)

4.2.1 วิเคราะห์สมบัติความไม่ชอบน้ำ

กระบวนการแอดไไมเซลลาร์ พอยลิเมอร์ เช่นของระบบที่ใช้ความร้อนและระบบที่ใช้คลื่นไมโครเวฟเป็นตัวหนึ่งที่บันทึกปฏิกิริยานั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวชิลิกา ทำให้พื้นผิวของชิลิกามีสมบัติเปลี่ยนไปจากสมบัติมีข้าว (Hydrophilic) เป็นเปลี่ยนไปเป็นสมบัติไม่มีข้าว (Hydrophobic) โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกวิธีการลองน้ำ จากราฟที่ 4-10 แสดงผลการลองน้ำ ของชิลิกาที่ปรับปรุงผิวทั้งระบบที่ใช้ความร้อน และระบบที่ใช้คลื่นไมโครเวฟเบรียบเทียบกับชิลิกาที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว พบว่า ชิลิกาที่ไม่ได้ปรับปรุงผิวด้วยปฏิกิริยาแอดไไมเซลลาร์ พอยลิเมอร์ เช่นจะมีผลลัพธ์ของการลองน้ำ ในทางกลับกัน ชิลิกาที่ปรับปรุงผิวทั้งระบบที่ใช้ความร้อนและระบบที่ใช้คลื่นไมโครเวฟโดยการเคลือบฟิล์มพอยลิไอโซพรีน สามารถลองด้วยขุบวนพื้นผิวหน้าได้นานกว่า แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงพื้นผิวชิลิกาด้วยปฏิกิริยา แอดไไมเซลลาร์ พอยลิเมอร์ เช่น สามารถทำให้พื้นผิวของชิลิกามีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากสมบัติมีข้าวเปลี่ยนไปเป็นสมบัติไม่มีข้าว



(ก)

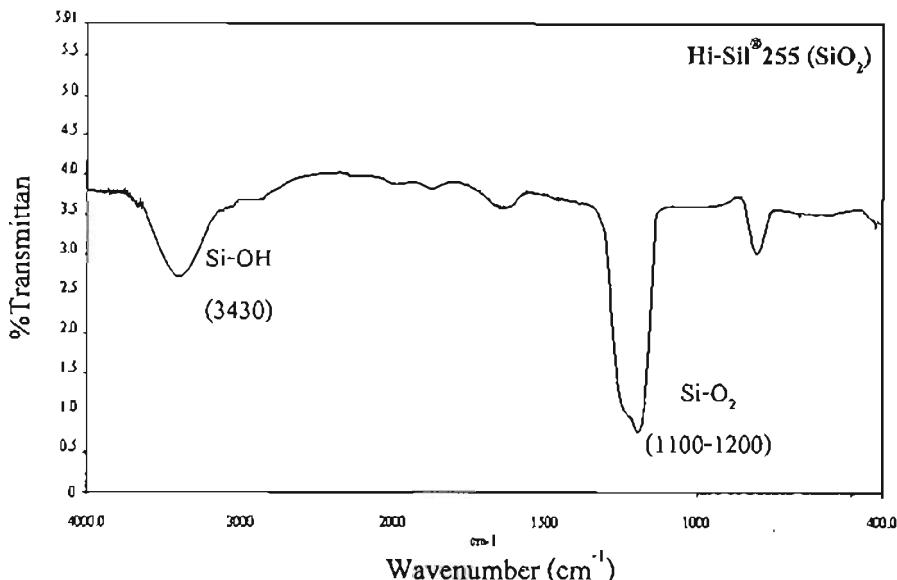


(ข)

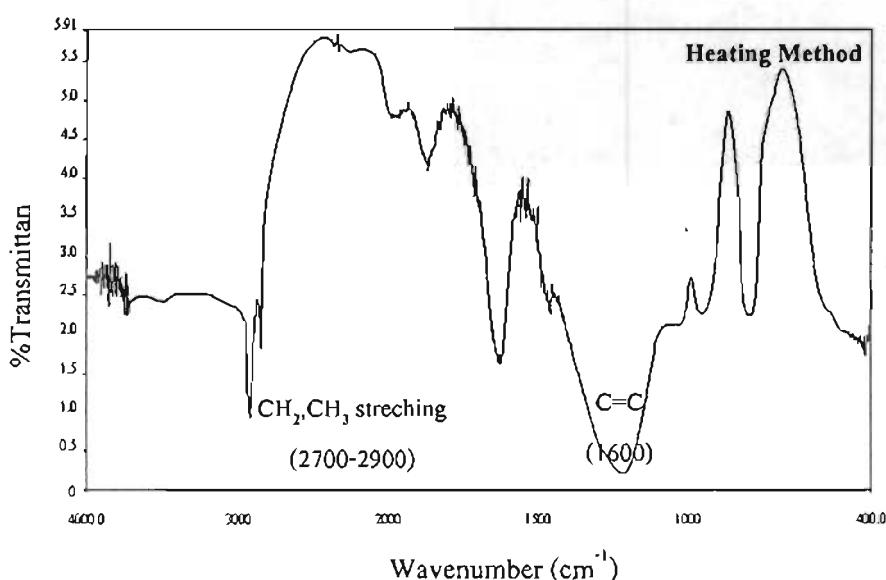
ภาพที่ 4-10 แสดงผลการลองน้ำของชิลิกาปรับปรุงผิว (ก) เบรียบเทียบระหว่างชิลิกา ปรับปรุงผิวระบบที่ใช้ความร้อนและชิลิกาที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว,
(ข) เบรียบเทียบระหว่างชิลิกาปรับปรุงผิวระบบที่ใช้คลื่นไมโครเวฟและ ชิลิกาที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว

4.2.2 วิเคราะห์ลักษณะหมู่ฟังก์ชันเฉพาะด้วยวิธีฟูเรียทรายฟอร์มอินฟารेड สเปคต์โรสโคปี (Fourier Transform Infared Spectroscopy: FTIR)

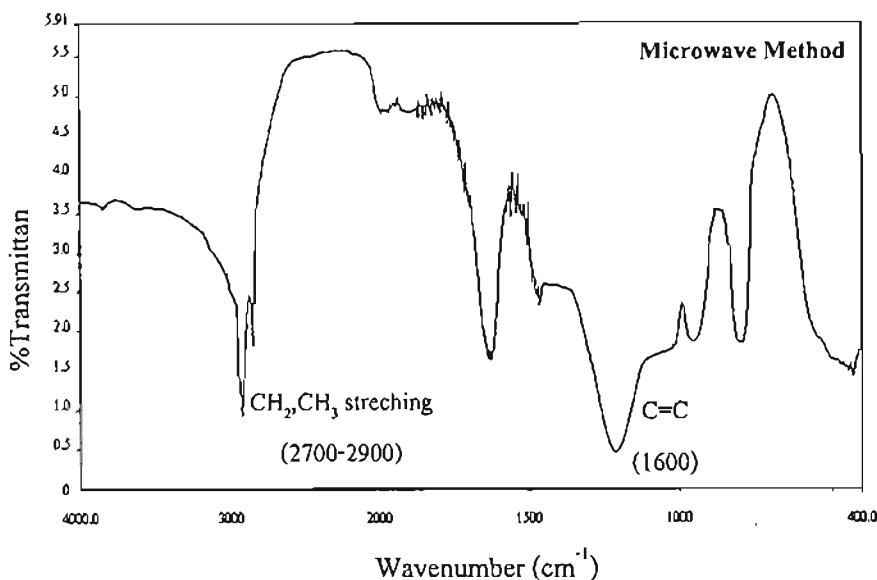
การวิเคราะห์ด้วยวิธีฟูเรียทรายฟอร์มอินฟารेडสเปคต์โรสโคปี เป็นการวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันอลเพื่อบ่งบอกลักษณะเฉพาะของชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว ชิลิกาที่ปรับปรุงผิวในระบบความร้อน และชิลิกาที่ปรับปรุงผิวในระบบการถ่ายคลื่นไมโครเวฟ ดังแสดงในภาพที่ 4-11 ถึงภาพที่ 4-13



ภาพที่ 4-11 สเปกต์รัม FTIR แสดงหมู่ฟังก์ชันอลเฉพาะของชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว



ภาพที่ 4-12 สเปกต์รัม FTIR แสดงหมู่ฟังก์ชันอลเฉพาะของชิลิกาที่ที่ปรับปรุงผิว
ด้วยกระบวนการ การแอดไนเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันในระบบการใช้ความร้อน

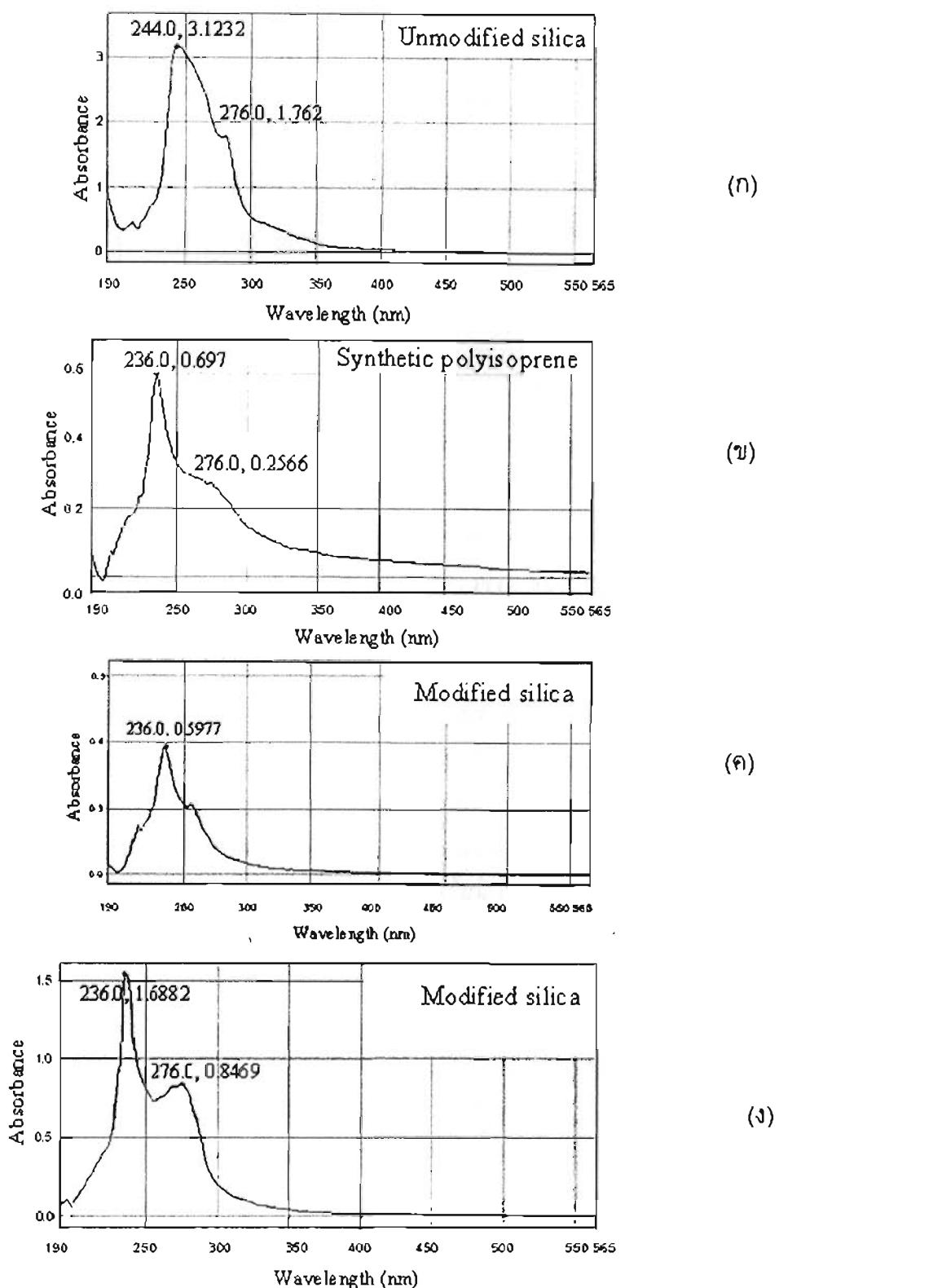


ภาพที่ 4-13 สเปกตรัม FTIR แสดงหมู่พังก์ชันนอลเฉพาะของชิลิกาที่ที่ปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไนเซลลาร์พอลิเมอไรเซ็นในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ

จากภาพที่ 4-11 ถึง ภาพที่ 4-13 พบว่า สเปกตรัมที่แสดงลักษณะเฉพาะของชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิวจะพบลักษณะเฉพาะที่ความยาวคลื่น 3430 cm⁻¹ และ 1100-1200 cm⁻¹ โดยหมายถึงลักษณะเฉพาะของหมู่ชิลินอล และหมู่ไซลอกเซน ตามลำดับ ส่วนสเปกตรัมที่แสดงลักษณะเฉพาะของชิลิกาที่ปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไนเซลลาร์ พอลิเมอไรเซ็นในระบบการใช้ความร้อนและในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ พบว่า หมู่ชิลินอลที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิวนั้นหายไป แต่จะพบลักษณะสเปกตรัมเฉพาะที่ความยาวคลื่น 1600 cm⁻¹ และ 2700-2900 cm⁻¹ โดยหมายถึงลักษณะเฉพาะของพันธะคู่ carbon (C=C) และหมู่เมทธิล (CH₃, CH₂) ซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะของพอลิไอโซพรีนหรือฟิล์มพอลิไอโซพรีนที่เคลือบอยู่บนผิวชิลิกา

4.2.3 วิเคราะห์การดูดกลืนแสงยูวีด้วยวิธี บูรี สเปกโตรสโคปี (UV-Spectroscopy)

การวิเคราะห์ด้วยวิธีบูรีสเปกโตรสโคปี เป็นการวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงยูวีเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว ชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไนเซลลาร์ พอลิเมอไรเซ็นในระบบการใช้ความร้อนและชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไนเซลลาร์ พอลิเมอไรเซ็นในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ โดยพิจารณาที่ช่วงความยาวคลื่น 190-565 nm ตั้งแสดงในภาพที่ 4-14



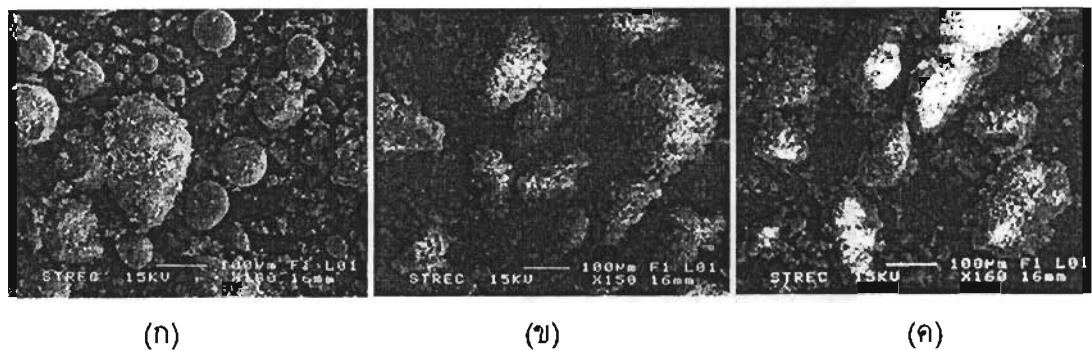
ภาพที่ 4-14 สเปกตัม UV แสดงค่าการดูดกลืนแสง (ก) ชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว,
 (ข) พอลิไอโซพเรนที่ได้จากการสกัดจากยางธรรมชาติ, (ค) ชิลิกาปรับปรุง
 ผิวในระบบการใช้ความร้อน และ (จ) ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้
 คลื่นไมโครเวฟ

สเปกตรัมที่แสดงลักษณะเฉพาะของชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว จะพบลักษณะเฉพาะที่ความยาวคลื่น 244 nm ซึ่งแตกต่างจากสเปกตรัมของพอลิไอโซพรีนที่ได้จากการสกัดจากยางธรรมชาติ โดยจะพบลักษณะเฉพาะที่ความยาวคลื่น 236 nm ในทำนองเดียวกัน สเปกตรัมที่แสดงลักษณะเฉพาะของชิลิกาที่ปรับปรุงผิว ด้วยกระบวนการแอดไมเนชลาร์พอลิเมอไรเซชัน ทั้งในระบบการใช้ความร้อนและในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ จะพบลักษณะเฉพาะที่ความยาวคลื่น 236 nm เช่นเดียวกัน

4.2.4 วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวและเปอร์เซ็นต์คาร์บอนในโคโรสโคป (Scanning Electron Microscopy : SEM)

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง สำหรับการทดสอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สแกนนิ่ง-อิเล็กตรอนในโคโรสโคป ได้จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ดังนี้

4.2.4.1 ผลของการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยวิธีสแกนนิ่งอิเล็กตรอนในโคโรสโคป การวิเคราะห์ลักษณะผิวชิลิกาด้วยวิธีสแกนนิ่งอิเล็กตรอนในโคโรสโคป เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงลักษณะการกระจายตัวของพอลิไอโซพรีนบนผิวชิลิกา ทั้งชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว, ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้ความร้อน และชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ ดังแสดงในภาพที่ 4-15

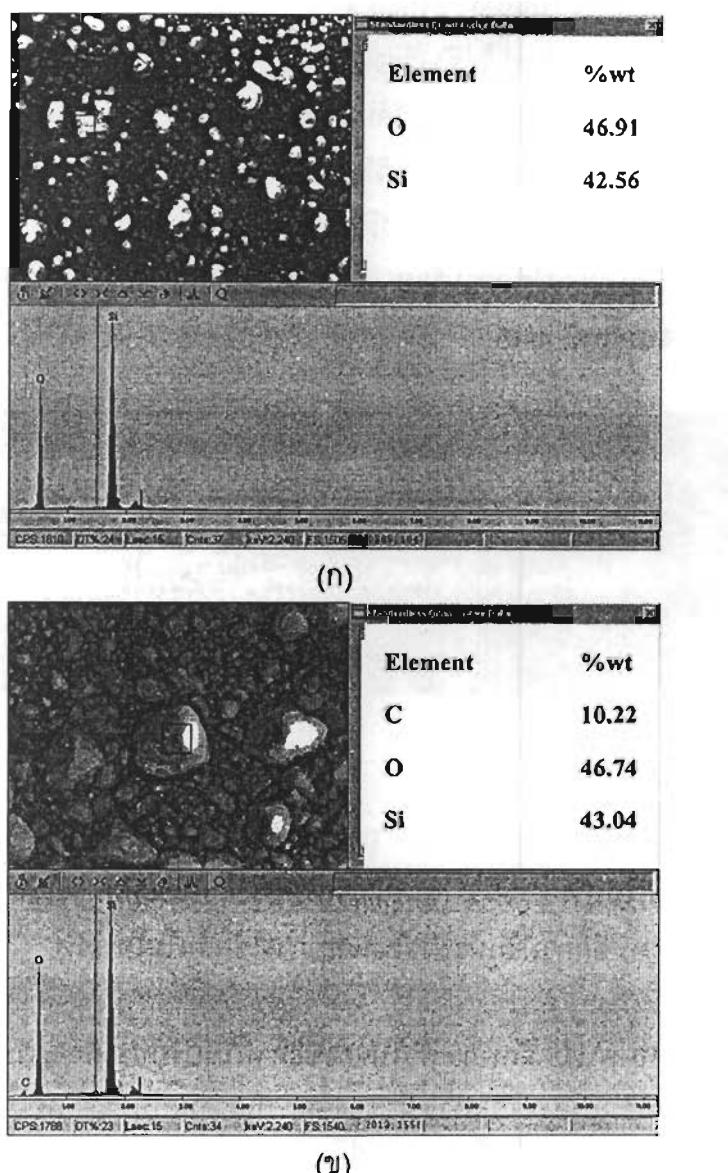


ภาพที่ 4-15 ลักษณะการกระจายตัวของฟิล์มพอลิไอโซพรีนบนผิวของ (ก) ชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว, (ข) ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้ความร้อนและ (ค) ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ

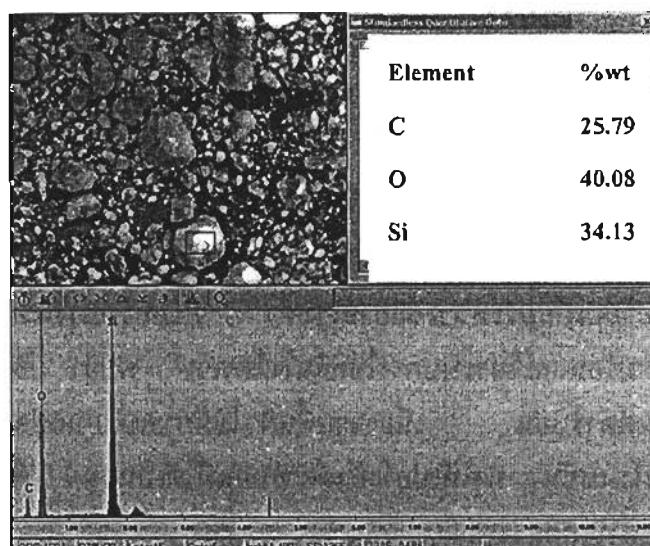
จากภาพที่ 4-15 พบว่า ลักษณะทั่วไปของชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิวจะพบลักษณะเฉพาะของ การเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนเนื่องจากสภาพผิวของชิลิกามีความเป็นข้าว เพราะมีองค์ประกอบของ หมู่ไฮลานอลจึงทำให้ดูดซับความชื้นได้ดี ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของชิลิกาที่ปรับปรุงผิวด้วย กระบวนการแอดไมเนชลาร์ พอลิเมอไรเซชันในระบบการใช้ความร้อนและในระบบการใช้คลื่น ไมโครเวฟ โดยจะพบลักษณะเฉพาะของเม็ดชิลิกามีการกระจายตัว ลักษณะแบบนี้แสดงให้เห็น ถึงสภาพผิวที่ไม่ดูดซับความชื้นจากการถูกเคลือบด้วยฟิล์มพอลิไอโซพรีน

4.2.4.2 ผลของการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์คาร์บอน ด้วยวิธีสแกนนิ่งอิเล็คตรอน ไมโครสโคป

การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์คาร์บอนบนผิวชิลิกา เป็นการวิเคราะห์เพื่อดูถึงปริมาณคาร์บอน อยู่บนผิวชิลิกา โดยจะพิจารณาวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์คาร์บอนบนผิวชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว ชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน ในระบบการใช้ความร้อนและชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน ในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ ดังแสดงในภาพที่ 4-16



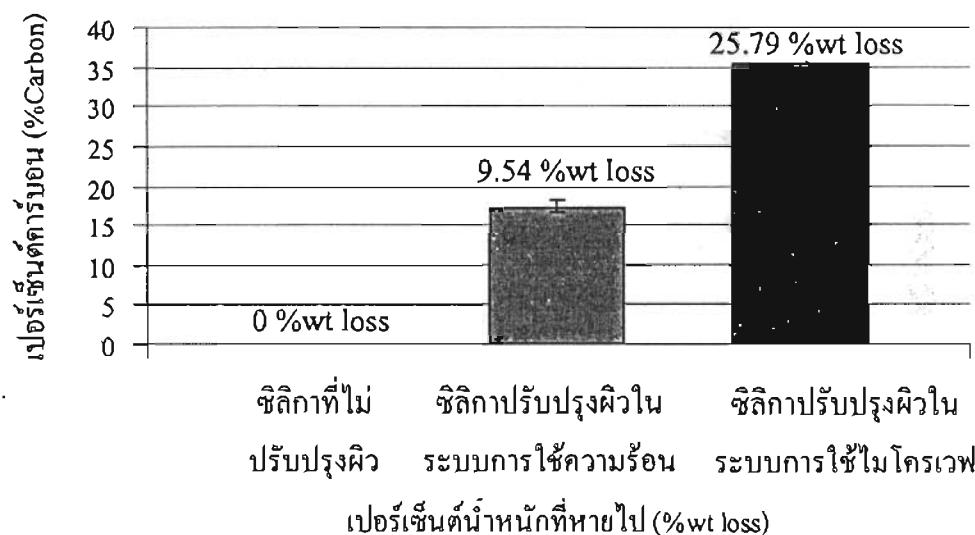
ภาพที่ 4-16 เปอร์เซ็นต์คาร์บอนของชิลิกาที่สภาวะต่างๆ (ก) ชิลิกาที่ไม่ได้ปรับปรุง (ข) ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้ความร้อน และ (ค) ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ



(ก)

ภาพที่ 4-16 (ต่อ)

จากค่าเบอร์เซ็นต์คาร์บอนบนผิวชิ้นงานในระบบต่างๆ ไม่โครสโคปเมื่อนำค่าที่ได้มาพล็อตกราฟ และเปรียบเทียบกับเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปจะได้ความสัมพันธ์ดังภาพที่ 4-17

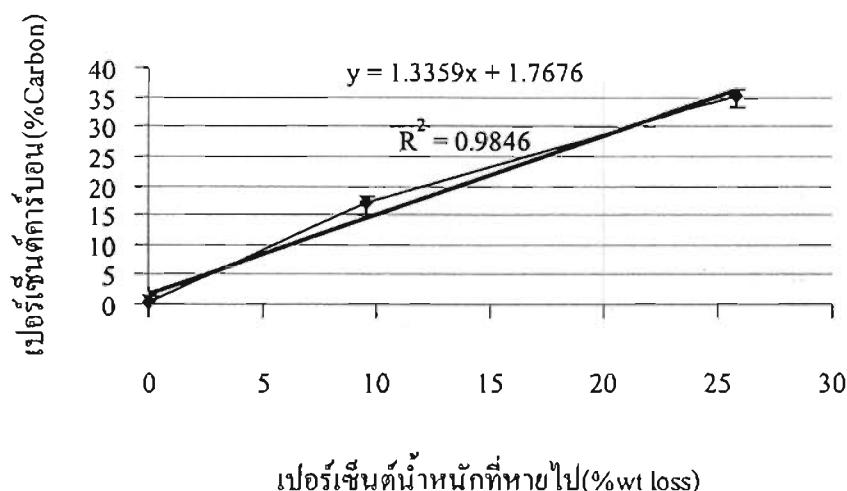


ภาพที่ 4-17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปกับเบอร์เซ็นต์คาร์บอนของชิลิกาธรรมชาติที่ไม่ปรับปรุงผิว ชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้ความร้อน และชิลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ

จากภาพที่ 4-17 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปกับเบอร์เซ็นต์คาร์บอนของชิลิกะรูบบ์ต่างๆ พบว่า เมื่อเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปเพิ่มขึ้น เบอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ได้จะมีค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเมื่อเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปมีค่าเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงปริมาณโพลีไอโซพรินที่สกัดได้มีปริมาณมากขึ้น ดังนั้นเมื่อปริมาณโพลีไอโซพรินมีมากขึ้นเบอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ได้จึงมีค่าเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างชิลิกาธรรมชาติ ที่ไม่ปรับปรุงผิว กับชิลิกาปรับปรุงผิว ทั้งในระบบการใช้ความร้อนและในระบบการใช้คลีนไมโครเวฟ พบว่า ชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว จะไม่ปราศจากเบอร์เซ็นต์คาร์บอน เนื่องจากผิวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะยังไม่ได้ผ่านกระบวนการโพลิเมอไร-เซชัน ทำให้เบอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ได้เป็นศูนย์ ซึ่งแตกต่างจากชิลิกาที่ผ่านกระบวนการแอดไดเมเซลลาร์โพลิเมอไรเซชัน ของระบบที่ใช้ความร้อนและระบบที่ใช้คลีนไมโครเวฟ โดยจะปราศจากเบอร์เซ็นต์คาร์บอน เนื่องจากผิวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเพราะถูกเคลือบด้วยพิล์มโพลีไอโซพริน โดยชิลิกาที่ผ่านกระบวนการแอดไดเมเซลลาร์ โพลิเมอไรเซชัน ของระบบที่ใช้คลีนไมโครเวฟ จะให้เบอร์เซ็นต์คาร์บอนมากที่สุดถึง 25.79%

เมื่อนำค่าเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปของชิลิกา ทั้งก่อนและหลัง จะได้ความสัมพันธ์ดังภาพที่ 4-18



ภาพที่ 4-18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปกับเบอร์เซ็นต์คาร์บอนของชิลิกาทุกๆ สภาวะ

จากภาพที่ 4-18 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปกับเบอร์เซ็นต์คาร์บอนของชิลิกาทุกๆ สภาวะ พบว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) เท่ากับ 0.9846 และได้สมการของความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปกับเบอร์เซ็นต์คาร์บอน ดังสมการ 4-1

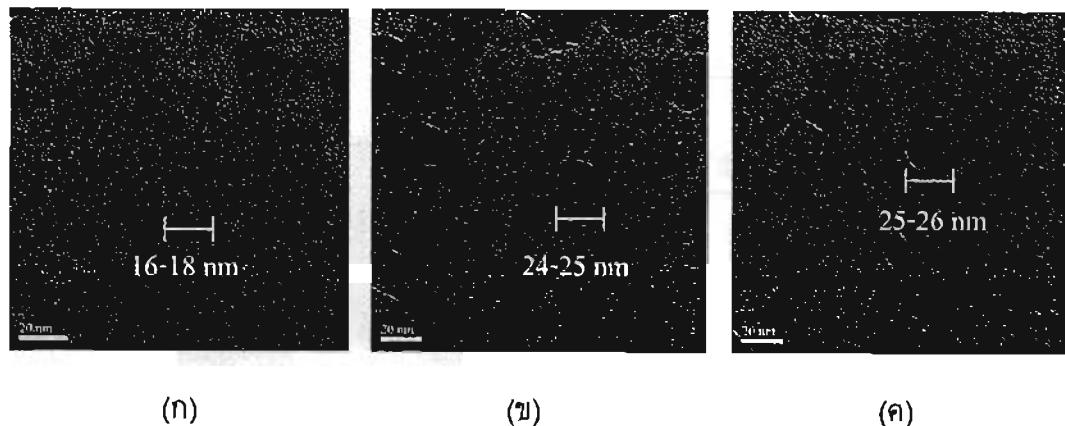
$$Y = 1.3359X + 1.7676 \quad (4-1)$$

หรือ

$$\text{เปอร์เซ็นต์คาร์บอน} = 1.3359 \text{ ของ เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไป} + 1.7676$$

4.2.5 วิเคราะห์ขนาดด้วยวิธี ทรายสมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโคป (Transmission Electron Microscopy : TEM)

การวิเคราะห์ขนาดชิลิกาด้วยวิธี ทรายสมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโคป เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาขนาดของชิลิกาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากถูกเคลือบด้วยฟลัมพอลิไอโอดีน โดยจะพิจารณาชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว ชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน ในระบบการใช้ความร้อน และชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน ในระบบการใช้คลีนไมโครเวฟ ดังแสดงในภาพที่ 4-18



ภาพที่ 4-19 ขนาดของเม็ดชิลิกา (ก) ชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว, (ข) ชิลิกาที่ปรับปรุงผิวในระบบความร้อนและ (ค) ชิลิกาที่ปรับปรุงผิวในระบบการฉายคลีนไมโครเวฟ

จากภาพที่ 4-19 แสดงถึงขนาดของเม็ดชิลิกาที่ระบบต่างๆพบว่า ขนาดชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิวจะพบขนาดโดยเฉลี่ยที่ 16 ถึง 18 nm ส่วนชิลิกาที่ปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันในระบบความร้อนและในระบบการฉายคลีนไมโครเวฟ จะพบขนาดโดยเฉลี่ยที่ 24 ถึง 26 nm ซึ่งหมายถึงชิลิกามีขนาดเพิ่มขึ้น ขนาดที่เพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการถูกเคลือบของพอลิไอโอดีน

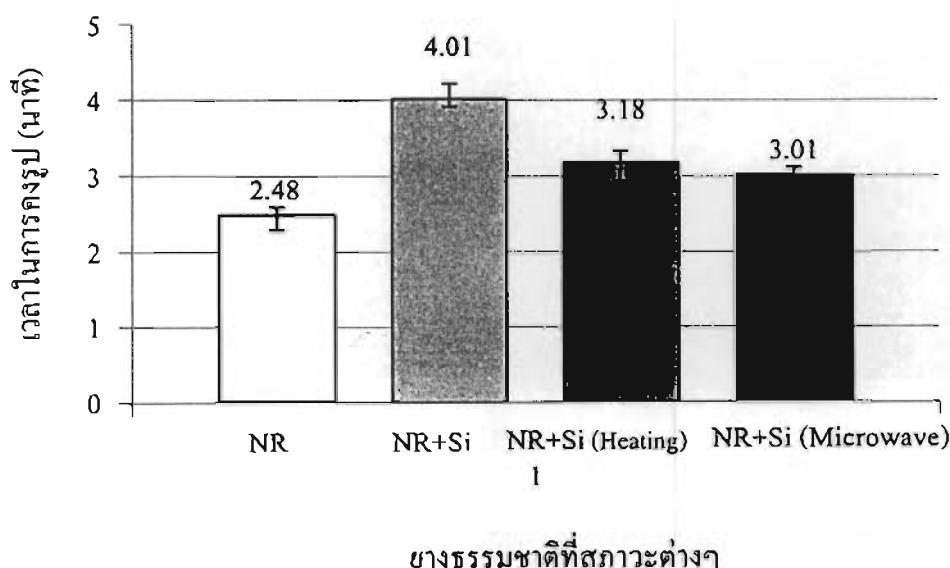
4.3 ผลของการทดสอบสมบัติจำเพาะของยางธรรมชาติ

การทดสอบสมบัติจำเพาะของยางธรรมชาติก่อน และหลังทดสอบชิลิกาปรับปรุงผิวสำหรับในการวิจัยได้ทำการทดสอบสมบัติจำเพาะต่างๆ เช่น ทดสอบระบบเวลาการคงรูป ทดสอบ

วัดแรงดึงจันชาต ทดสอบวัดการยึดดั้งน้ำหนาต ทดสอบวัดแรงดึง ณ จุดยึดที่กำหนด ทดสอบวัดแรงฉีกขาด ทดสอบการสูญเสียเนื้อยางจากการสึกหรอ และทดสอบการรวมเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างซิลิกาปรับปรุงผิว กับยางธรรมชาติตัวบีท สารเคมีที่ใช้ในการรักษาในโครงสร้างคือ สแกนนิ่งอีเลคทรอนไมโครสโคป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

4.3.1 ทดสอบระยะเวลาการคงรูป (Cure Time)

การทดสอบระยะเวลาการคงรูปของยางธรรมชาติ ได้ทำการทดลองเปรียบเทียบกับยางที่มีส่วนผสมของสารเสริมแรงเด็กต่างกันออกไปคือ ยางธรรมชาติที่ไม่ผสมซิลิกา (NR) ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว (NR+Si) ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิว ด้วยกระบวนการ แอดไไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันในระบบการใช้ความร้อน (NR+Si (Heating)) และยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิว ด้วยกระบวนการแอดไไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน ในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ (NR+Si (Microwave)) ดังแสดงในภาพที่ 4-20



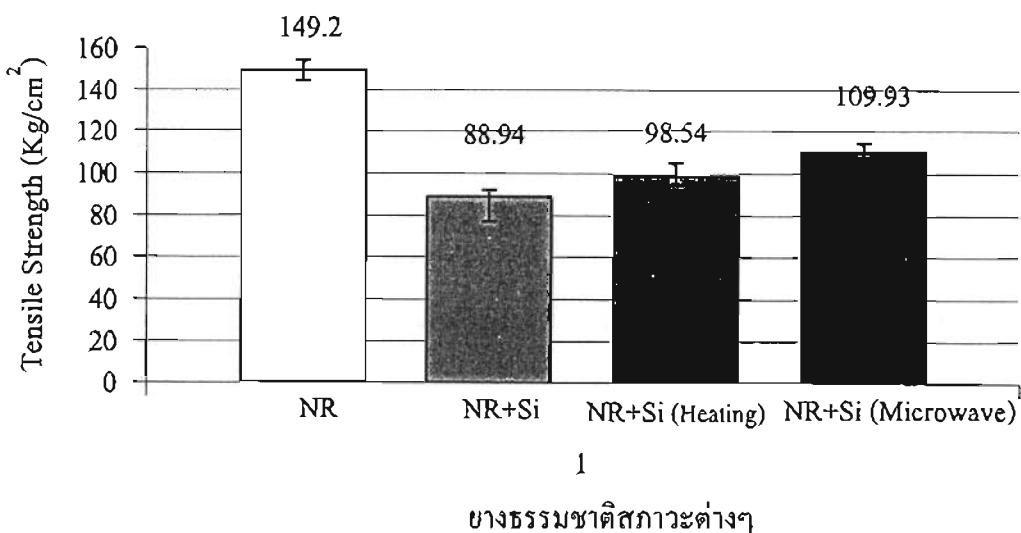
ภาพที่ 4-20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการคงรูปของยางกับยางธรรมชาติ สภาวะต่างๆ

จากภาพที่ 4-20 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างเวลาการคงรูปของยางกับยางธรรมชาติสภาวะต่างๆพบว่า ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวทั้งในระบบการใช้ความร้อนและในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟจะใช้เวลาการคงรูปของยางน้อยกว่ายางธรรมชาติที่ไม่ปรับปรุงผิว เนื่องจากการปรับปรุงผิวซิลิกาโดยการเคลือบด้วยฟิล์มพอลิไอซ์พรีนสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดบนผิวซิลิกาได้ ทำให้เกิดการยับยั้งการวัลคานิซึ่น้อยลง ซึ่งมีผลทำให้ใช้เวลาการคงรูปน้อยลงเช่นกัน จึงเป็นการแสดงถึงสมบัติ

ที่ดีขึ้นของยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิว ทั้งในระบบการใช้ความร้อนและในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ

4.3.2 ทดสอบวัดแรงดึงจนขาด (Tensile Strength)

การทดสอบวัดแรงดึงจนขาดของยางธรรมชาติ ได้ทำการทดลองเปรียบเทียบกับยางที่มีส่วนผสมของสารเสริมแรงแตกต่างกันออกไปคือ ยางธรรมชาติที่ไม่ผสมซิลิกา ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน ในระบบการใช้ความร้อน และยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน ในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ ดังแสดงในภาพที่ 4-21



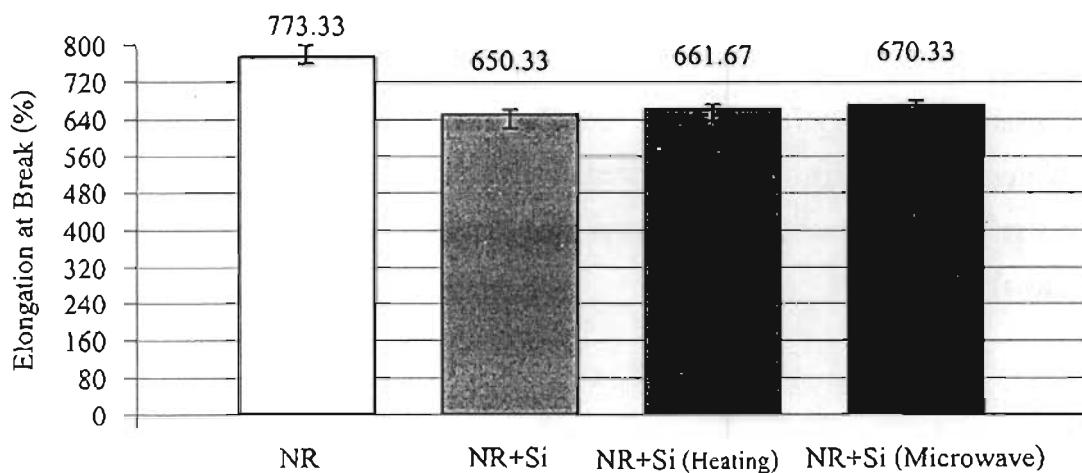
ภาพที่ 4-21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความด้านทานต่อการดึง (Tensile Strength) กับยางธรรมชาติสภาวะต่างๆ

จากภาพที่ 4-21 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างค่าความด้านทานต่อการดึงกับยางธรรมชาติสภาวะต่างๆ พบว่า ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวทั้งในระบบการใช้ความร้อนและในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ จะให้ค่าความด้านทานต่อการดึงของยางสูงกว่า ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว จึงเป็นการแสดงถึงสมบัติที่ดีขึ้นของยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวทั้งในระบบการใช้ความร้อน และในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ

4.3.3 ทดสอบวัดการยืดตัวจนขาด (Elongation at Break)

การทดสอบวัดการยืดตัวจนขาดของยางธรรมชาติ ได้ทำการทดลองเปรียบเทียบกับยางที่มีส่วนผสมของสารเสริมแรงแตกต่างกันออกไปคือ ยางธรรมชาติที่ไม่ผสมซิลิกา ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการ

แอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชันในระบบการใช้ความร้อน ปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน และยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกา ดังแสดงในภาพที่ 4-22 และยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกา ในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ



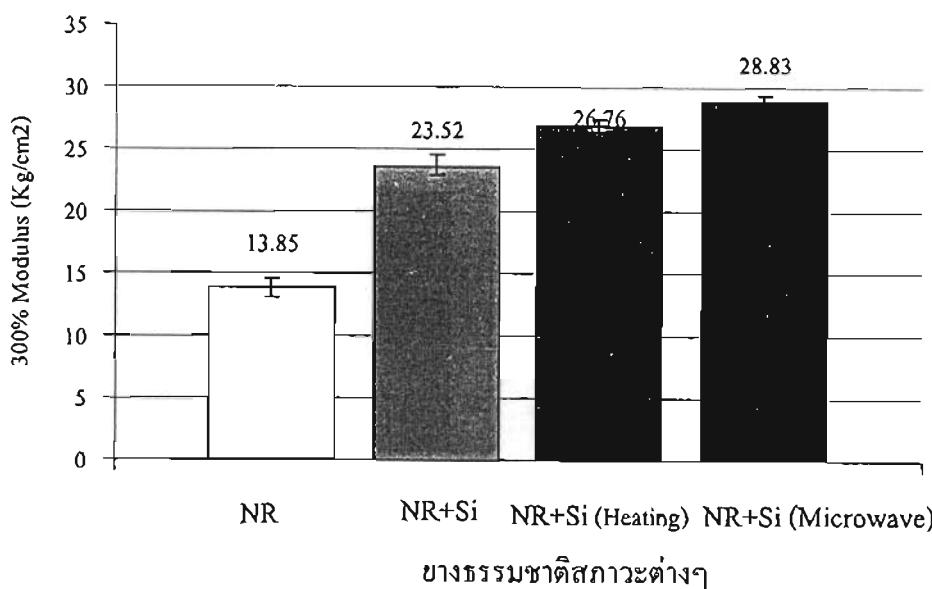
ยางธรรมชาติที่สภาวะต่างๆ

ภาพที่ 4-22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะยืดจนกระแทก (Elongation to Break) กับยางธรรมชาติสภาวะต่างๆ

จากภาพที่ 4-22 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างระยะยืดจนกระแทก กับ ยางธรรมชาติสภาวะต่างๆ พนว่า ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการใช้ ความร้อนและในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ จะให้ค่าระยะยืดจนกระแทกของยางสูงกว่า ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว จึงเป็นการแสดงถึงสมบัติที่ดีขึ้นของยางธรรมชาติ ที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการใช้ความร้อนและในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ

4.3.4 ทดสอบวัดแรงดึง ณ จุดยืดที่กำหนด (300% Modulus)

การทดสอบวัดแรงดึง ณ จุดยืดที่กำหนดของยางธรรมชาติได้ทำการทดลองเปรียบเทียบ กับยางที่มีส่วนผสมของสารเสริมแรงแตกต่างกันออกไปดังนี้ ยางธรรมชาติที่ไม่ผสมซิลิกา ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการ การแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันในระบบการใช้ความร้อน และยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุง ผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ ดังแสดง ในภาพที่ 4-23

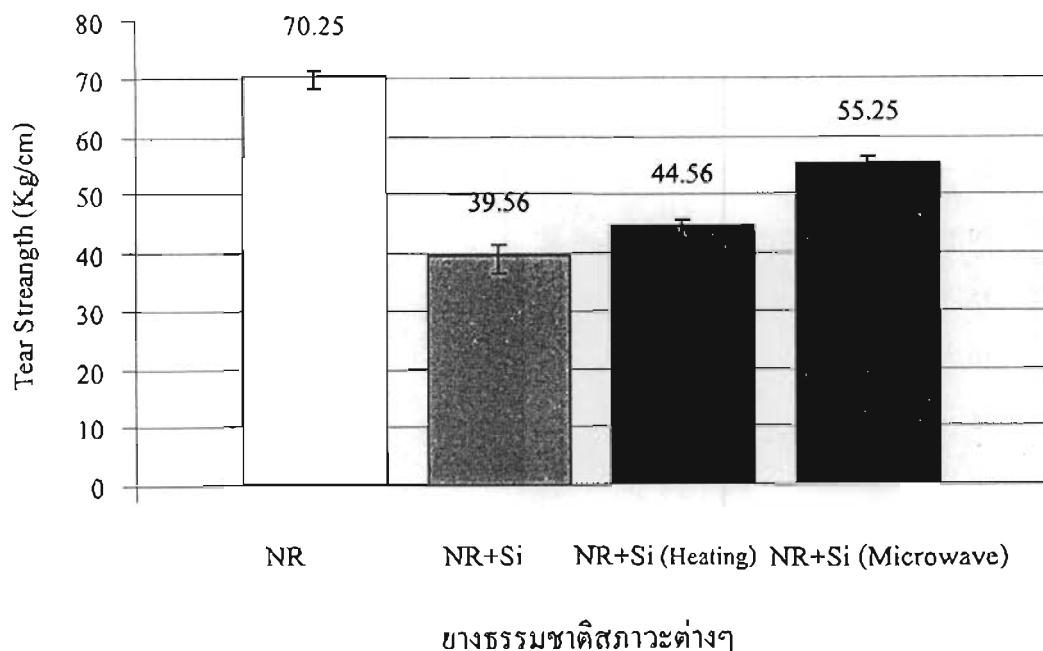


ภาพที่ 4-23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 300% โมดูลัส (300% Modulus) กับยางธรรมชาติสกาวะต่างๆ

จากภาพที่ 4-23 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างค่า 300% โมดูลัส กับ ยางธรรมชาติสกาวะต่างๆ พนวจ ยางธรรมชาติที่ผสมซีลิกาปรับปรุงผิวหั้งในระบบการใช้ ความร้อนและในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟจะให้ค่า 300% โมดูลัส ของยางสูงกว่า ยางธรรมชาติที่ผสมซีลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว แสดงให้เห็นถึงการใช้แรงในการดึงที่สูงกว่าสำหรับ การทำให้ยางยืดถึง 300% จึงเป็นการยืนยันถึงสมบัติที่ดีขึ้นของยางธรรมชาติที่ผสมซีลิกา ปรับปรุงผิวหั้งในระบบการใช้ความร้อนและในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ

4.3.5 ทดสอบวัดแรงฉีกขาด (Tear Strength)

การทดสอบวัดแรงฉีกขาดของยางธรรมชาติ ได้ทำการทดลองเปรียบเทียบกับยางที่มี ส่วนผสมของสารเสริมแรงแต่กันออกไปคือ ยางธรรมชาติที่ไม่ผสมซีลิกา ยางธรรมชาติ ที่ผสมซีลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว ยางธรรมชาติที่ผสมซีลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการ แอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชันในระบบการใช้ความร้อน และยางธรรมชาติที่ผสมซีลิกา ปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน ในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ ดังแสดงในภาพที่ 4-24

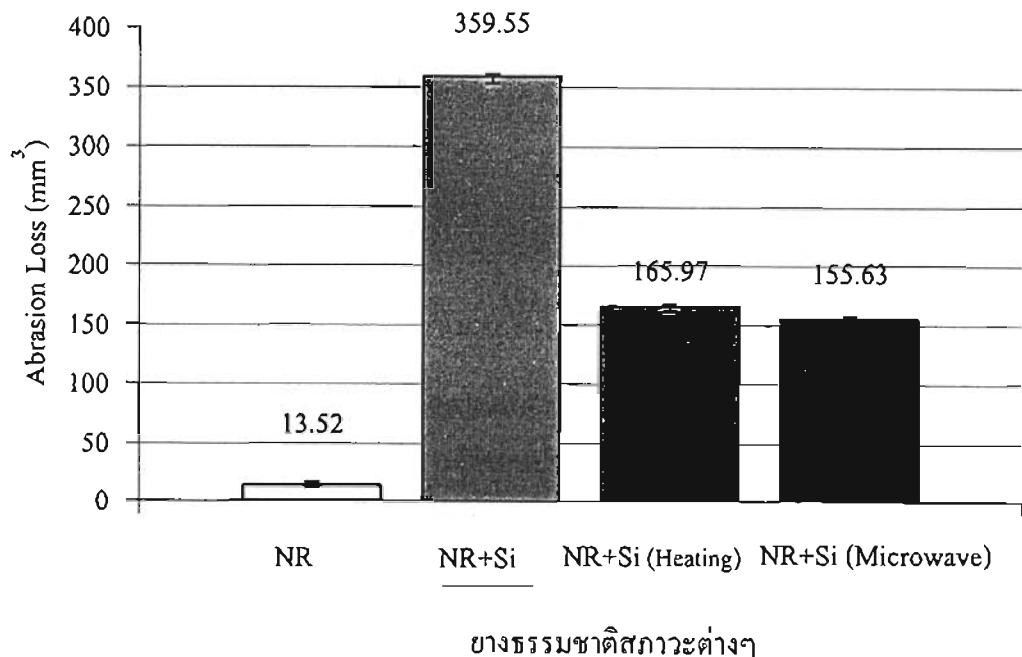


ภาพที่ 4-24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความด้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) กับยางธรรมชาติสภาวะต่างๆ

จากภาพที่ 4-24 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความด้านทานต่อการฉีกขาด กับยางธรรมชาติสภาวะต่างๆ พบว่า ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวทั้งในระบบการใช้ ความร้อนและในระบบการใช้คลีนไมโครเวฟ จะให้ค่าความด้านทานต่อการฉีกขาดของยาง สูงกว่ายางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว แสดงให้เห็นถึงการใช้แรงในการฉีกยางให้ขาด ที่สูงกว่า จึงเป็นการยืนยันถึงสมบัติที่ดีขึ้นของยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวทั้งในระบบ การใช้ความร้อนและในระบบการใช้คลีนไมโครเวฟ

4.3.6 ทดสอบการสูญเสียเนื้อยางจากการสึกหรอ (Abrasion loss)

การทดสอบการสูญเสียเนื้อยางจากการสึกหรอ เป็นการทดสอบความหนืดของ ยางธรรมชาติที่สภาวะต่างๆ ตามมาตรฐาน ตีโอลีเอ็นโดยการวิจัยได้ทำการทดลองเบรียบเทียน กับยางที่มีส่วนผสมของสารเสริมแรงแตกต่างกันออกไปคือ ยางธรรมชาติที่ไม่ผสมซิลิกา ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการ แอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์เซชันในระบบการใช้ความร้อน และยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกา ปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอร์เซชัน ในระบบการใช้คลีนไมโครเวฟ ดังแสดงในภาพที่ 4-25

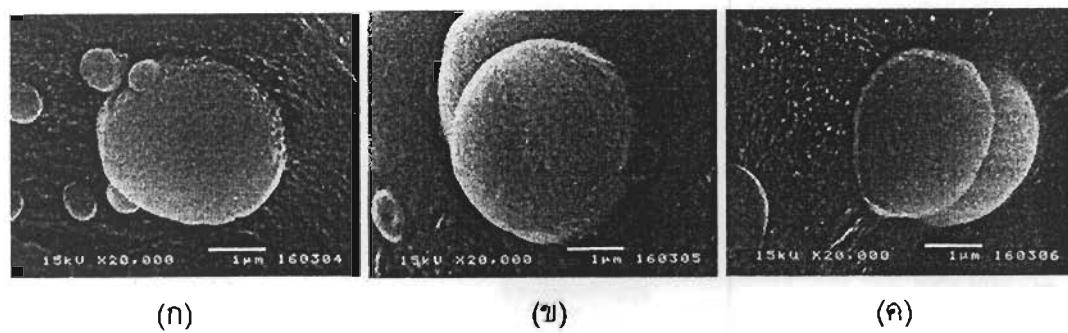


ภาพที่ 4-25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสูญเสียจากการขัดถู (Abrasion loss) กับยางธรรมชาติสภาวะต่างๆ

จากภาพที่ 4-25 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างค่าการสูญเสียจากการขัดถูกับ ยางธรรมชาติสภาวะต่างๆ พบว่า ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวหั้งในระบบการใช้ ความร้อนและในระบบการใช้คลีน์ไมโครเวฟ จะให้ค่าการสูญเสียจากการขัดถูของยางต่ำกว่า ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว แสดงให้เห็นถึงสมบัติของยางมีความเหนียวมากขึ้น ไม่เกิดการยุบได้ง่ายเมื่อทำการทดสอบ จึงเป็นการยืนยันถึงสมบัติที่ดีขึ้นของยางธรรมชาติ ที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวหั้งในระบบการใช้ความร้อน และในระบบการใช้คลีน์ไมโครเวฟ

4.3.7 ทดสอบการรวมเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างซิลิกา ปรับปรุงผิว กับยางธรรมชาติตัวยิริช สแกนนิ่งอิเล็กตรอนในโคลสโคปี (Scanning Electron Microscopy : SEM)

การทดสอบการรวมเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างซิลิกา ปรับปรุงผิว กับเนื้อยางธรรมชาติ ได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบกับยาง ที่มีส่วนผสมของสารเสริมแรงแตกต่างกันออกไปคือ ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการ แอดไมเซลลาร์พอลิเมอ-ไรเซชันในระบบการใช้ความร้อน และยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาปรับปรุง ผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอ-ไรเซชันในระบบการใช้คลีน์ไมโครเวฟ ดังแสดง ในภาพที่ 4-26



ภาพที่ 4-26 ลักษณะการยึดเกาะกันระหว่างฟิล์มพอลีไอโซพรีนบนผ้าชีลิกากับเนื้อยางธรรมชาติ (ก) ยางธรรมชาติที่ผสมชีลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว, (ข) ยางธรรมชาติที่ผสมชีลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้ความร้อน และ (ค) ยางธรรมชาติที่ผสมชีลิกาปรับปรุงผิวในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้จาก การนำเอากโนโลยีไมโครเวฟ (Microwave Technology) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน โดยเป็นตัวหนีไฟนำให้เกิดปฏิกิริยา สำหรับการเคลือบนาโนฟิล์มของพอลิไอโซพรีนบนผิวชิลิกา จากการศึกษาดึงปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการกระจายตัวของพอลิเมอร์บนผิวชิลิกาพบว่า การใช้คลื่นไมโครเวฟ ในกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันที่การใช้กำลังการกระจายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที จะให้ผลดีที่สุด โดยมีผลช่วยลดปริมาณการใช้ตัวเริ่มได้ถึง 50 เบอร์เซ็นต์ และยังสามารถลดเวลาในการเกิดปฏิกิริยาได้ถึง 360 เท่า จากนั้นมี่อนนำชิลิกาที่ผ่านกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอ-ไรเซชันมาพิสูจน์ ถึงการมีอยู่ของฟิล์มพอลิไอโซพรีนบนผิวชิลิกา ด้วยการทดสอบสมบัติความไม่ชอบน้ำโดยการลองน้ำ พนว่า ชิลิกาที่ไม่ผ่านกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันจะคงลงในน้ำทันที แต่สำหรับชิลิกาที่ผ่านกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน จะสามารถลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้นานกว่า ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณสมบัติของความไม่ชอบน้ำบนพื้นผิวชิลิกา หลังจากที่ได้รับการปรับปรุงโดยการเคลือบด้วยฟิล์มพอลิไอโซพรีน และเมื่อนำชิลิกาที่ผ่านกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน มาวิเคราะห์ด้วยวิธี ฟูเรียร์รานฟอร์มอินฟราเรดスペกโตรสโคปี (FTIR) และวิธีญี่วี สเปคโตรสโคปี (UV) พบว่า ปรากฏพิคที่เป็นลักษณะเฉพาะของพอลิไอโซพรีน และเมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธี สแกนning อิเล็กตรอนไมโครสโคปี (SEM) พบว่า ชิลิกาที่ผ่านกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน จะมีลักษณะการกระจายตัวเป็นเม็ด โดยแตกต่างจาก ชิลิกาที่ไม่ผ่านกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน ซึ่งจะมีลักษณะจับตัวเป็นกลุ่มก้อนเนื่องจากมีการดูดซับความชื้น โดยสภาวะของชิลิกาที่ผ่านกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน ในระบบการกระจายคลื่นไมโครเวฟจะให้เบอร์เซ็นต์คาร์บอนมากที่สุด คือ 25.79% wt จากนั้น เมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธี ทرانส์มิชันอิเล็กตรอนไมโครสโคปี (TEM) พบว่า ชิลิกาที่ผ่านการปรับปรุงผิวจะมีขนาดเล็กกว่าคุณย์กลางเพิ่มขึ้นจาก 16-18 nm เป็น 24-25 nm ซึ่งเป็นความหนาของฟิล์มในระดับนาโนเมตร จากนั้นเมื่อนำมาวิเคราะห์โดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย THF และ Toluene เพื่อปั่นบอกแนวโน้มปริมาณการมีอยู่ของพอลิไอโซพรีน พบว่า ที่สภาวะชิลิกา 8 กรัม ไอโซพรีน 0.8 มิลลิลิตร โดยใช้กำลังการกระจายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที จะมีปริมาณการเกิดฟิล์มพอลิไอโซพรีนมากที่สุด โดยมี%wt loss ที่ได้จากการสกัดด้วย THF เท่ากับ 35.3 % และจากการสกัดด้วย Toluene เท่ากับ 33.3%

จากนั้นเมื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพของยางที่มีส่วนผสมต่างกันคือ ยางธรรมชาติที่ไม่ผสมชิลิกา ยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาไม่ปรับปรุงผิว ยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาปรับปรุงผิว โดยการเคลือบด้วยพอลิไอโซพรีนในระบบความร้อน และยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาปรับปรุงผิวโดยการเคลือบด้วยพอลิไอโซพรีนในระบบการจ่ายคลีนไนโตรเจฟ พนว่า ค่า 300% Modulus (300% Modulus) ค่าความต้านทานต่อการดึง (Tensile Strength) ค่าระยะยืดจนแตก (Elongation to Break) ค่าความด้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) ของยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาปรับปรุงผิว โดยการเคลือบด้วยพอลิไอโซพรีนในระบบการจ่ายคลีนไนโตรเจฟ จะมีค่ามากที่สุดในทุกๆ ค่าโดยให้ค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาปรับปรุงผิวโดยการเคลือบด้วยพอลิไอโซพรีนในระบบความร้อนถึง 10% ส่วนค่าการสูญเสียจากการขัดถู (Abrasion Loss) ยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาปรับปรุงผิวโดยการเคลือบด้วยพอลิไอโซพรีนในระบบการจ่ายคลีนไนโตรเจฟ จะให้ค่าน้อยกว่ายางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิวโดยให้ค่าน้อยกว่าถึง 131% จากนั้นเมื่อนำมาทดสอบการรวมเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างชิลิกากับยางธรรมชาติตัววิธี สแกนning อิเล็กตรอนไนโตรสโกป (SEM) พนว่า ยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิวจะให้ลักษณะการยึดเกาะกัน ระหว่างพิล์มพอลิไอโซพรีนกับเนื้อยาง ไม่เป็นเนื้อเดียวกันโดยยังคงเหลือช่องว่างระหว่างชิลิกากับเนื้อยาง ซึ่งแตกต่างจากยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาปรับปรุงผิวโดยการเคลือบด้วยพอลิไอโซพรีน จะให้ลักษณะการยึดเกาะกันระหว่างพิล์มพอลิไอโซพรีนกับเนื้อยางเป็นเนื้อเดียวกัน สังเกตได้จากการไม่มีช่องว่างระหว่างชิลิกากับเนื้อยาง จากผลการทดลองทั้งหมดยืนยันได้วายางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาปรับปรุงผิวโดยการเคลือบด้วยพอลิไอโซพรีนในระบบการจ่ายคลีนไนโตรเจฟ สามารถให้สมบัติทางกายภาพของยางที่ดีกวายางธรรมชาติที่ไม่ผสมชิลิกา ยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาไม่ปรับปรุงผิว และยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาปรับปรุงผิว โดยการเคลือบด้วยพอลิไอโซพรีนในระบบความร้อน

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 จากการวิจัยในครั้งนี้ ได้ทดลองโดยการใช้คลีนไนโตรเจฟสำหรับกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชันแบบบีท (Batch) ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของการวิจัยให้เพิ่มสูงขึ้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการใช้คลีนไนโตรเจฟสำหรับกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชันแบบต่อเนื่อง (Continuous)

5.2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการเลือกใช้กำลังการจ่ายคลีนไนโตรเจฟ สำหรับกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน เนื่องจากมีผลก่อให้เกิดการ Depolymerization

5.2.3 จากการวิจัยในครั้งนี้ ได้เกิดการ Depolymerization เกิดขึ้นจากการใช้คลีนไนโตรเจฟหนียาน้ำให้เกิดกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของการวิจัยในด้านการใช้คลีนไนโตรเจฟ สำหรับกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน จึงควรมีการศึกษาผลของการ Depolymerization ให้ลลระเอียดยิ่งขึ้น

5.2.4 ความมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของปริมาณสารเสริมแรง ที่ผิดสมลงในย่างธรรมชาติ เพื่อหาสภาวะที่ดีที่สุดของปริมาณสารเสริมแรง ทั้งสารเสริมแรงที่ไม่ได้ปรับปรุงและสารเสริมแรง ที่ได้รับการปรับปรุง

เอกสารอ้างอิง

1. ชัยวัฒน์ เจนราณิชย์. เคมีพอลิเมอร์พื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2527.
2. พงษ์ธร แซ่อุย. ยาง ชนิด สมบัติ และการใช้งาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547.
3. Wagner, M. P. "Reinforcing silicas and silicates." Rubber Chemistry and Technology. 3 (1976) : 703-774.
4. Nantasorn P. Improvement of Natural Rubber Properties by Modification of Silica Surface using a Continuous Admicellar Polymerization System. Masters Thesis in Petrochemical Technology, The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, 2005.
5. Lee, C., et al. "Two site Absolubilization Model of Incorporation of Alcohols into Adsorbed Surfactant Aggregates." Langmuir. 12 (1990) : 1758-1762.
6. Rosen, M.J. Surfactants and Interfacial Phenomena. 2nd ed. New York: John Wiley and Sons, c1989.
7. Scamehorn, J.F. and Harwell, J.H. Surfactant-Based Treatment of Process Streams. In Surfactant in Chemical/Process Engineering. New York: Marcel Dekker, 1988.
8. Wu, J., Harwell, J.H. and O'Rear, E.A. "Two-Dimensional Solvents : Kinetics of Styrene Polymerization in Admicelles at or Near Saturation." The Journal of Physical Chemistry. 3 (1987) : 623-634.
9. Wu, J., Harwell, J.H. and O'Rear, E.A. "Two-Dimensional Reaction Solvents : Surfactant Bilayers in the Formation of Ultrathin Film." Langmuir. 3 (1987) : 531-537.
10. กองทัพอากาศ. Learning module on Earth Science and Astronomy. [Online] 2003. Available from E-mail : lesaclub@kirdkao.org.
11. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท). หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ว 422 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2524.

12. ชuan คล้ายปาน. โครงการพิสิกส์ และวิศวกรรม. [Online] 2545. Available from E-mail : chuan@mail.dss.go.th.
13. วีรเดช พิณเสนะ และคณอื่นๆ. "อิทธิพลของปริมาณสารตัวเดิม ซิลิกา แคลเซียม คาร์บอเนต และสารตัวเดิมผสม ที่มีต่อสมบัติยางฟองธรรมชาติ". วารสาร วิทยาศาสตร์ส่งข่านครินทร์. 1 (ม.ค.-ก.พ. 46) : 75-90.
14. พงษ์ธร แซ่ดุย. การเสริมแรงของซิลิกาในยางพอลิคลอโรพرنและยางผสมระหว่าง พอลิคลอโรพرنและยางธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ วัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, พ.ศ. 2548.
15. Song S. A. and Park S. B. "Hydrophobic Modification of Silica Nanoparticle by Using Aerosol Spray Reactor." Colloids and Surfaces A: Physicochemical Engineering. 236 (2004) : 623-634.
16. Sheng E., et al. "Effects of alkylation of silica on Interfacial Interaction and Molecule Motions Between silicas and Rubber." Journal of Applied Polymer Science. 9 (1996) : 1321-1328.
17. Nah C., et al. "Natural Rubber Composite Reinforced with Silica or Carbon Black." Polymer International. 8 (2003) : 1382-1389.
18. Kim, S., et al. "Surface Modification of Silica Nanoparticles by UV-Induced Graft Polymerization of Methyl Methacrylate." Journal of Colloid and Interface Science. 292(1) (2005) : 93-98.
19. O'Haver, J.H., et al. "Polar Copolymer-Surface-Modified Precipitated Silica." Journal of Applied Polymer Science. 59(9) (1996) : 1427-1435.
20. Che, J., et al. "Graft Polymerization onto Nano-Sized SiO₂ Surface and its Application to The Modification of PBT." Journal of Materials Letters. 59 (2005) : 1603-1609.
21. Jeon, B. J., Hah, H.J and Koo, S.M. "Surface Modification of Silica Particles With Organoalkoxysilane Through Two-step (acid-base) Process in Aqueous Solution." Journal of Ceramic Processing Research. 3(3) (2002) : 216-221.
22. O'Haver, J.H., et al. "Organic Polymer-Surface Modified Precipitated Silica." Journal of Applied Polymer Science. 55(2) (1995) : 1627-1641.
23. Chinpan, N. Comparison of Rubber Reinforcement using Various Surface Modified Silica. Masters Thesis in petrochemical technology, The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, 1996.

24. Pongprayoon T., Yanumet N. and Edgar A. O'Rear. "Admicellar Polymerization of Styrene on Cotton." Journal of Colloid and Interface Science. 249 (2002) : 227-234.
25. Chaisirimahamorakot, S. Modification of Silica Surface for Rubber Reinforcement Using A Continuous Admicellar Polymerization System. Masters Thesis in Petrochemical Technology, The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, 2001.
26. Sam Hom N. Surface Modification and Characterization of Polystyrene Formed via Admicellar Polymerization on Precipitated Silica : Water Soluble vs. Insoluble Initiator and Application of RAFT Agent via Admicellar Polymerization. Masters Thesis in Petrochemical Technology, The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, 2002.
27. Aurmsuvan, N. Characterization of Polystyrene Foemed via Admicellar Polymerization : The Effect of Initiator Concentration. Masters Thesis in Petrochemical Technology, The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, 2002.
28. Nantasorn P. "Admicellar Polymerization Modified Silica via A Continuous Stirred Tank Reactor System : Comparative Properties of Rubber Compounding." Chemical Engineering Journal. 108 (2005) : 213-218.
29. Zhu, X. "Emulsion Polymerization of Methyl Methacrylate under Pulsed Microwave Irradiation." European Polymer Journal. 39 (2003) : 1187-1193.
30. Zhu, X. "Emulsion Polymerization of Styrene under Pulsed Microwave Irradiation." Journal of Applied Polymer Science. 89 (2003) : 28-35.
31. Chen, G. "Controlled "living" Radical Polymerization of Methyl Methacrylate using AIBN As The Initiator Under Microwave Irradiation." Radiation Physics and Chemistry. 69 (2004) : 129-135.
32. Klun, U. and Krzan, A. "Rapid Microwave Induce Depolymerization of Polyamide-6." Journal of Applied Polymer Science. 41 (2000) : 4361-4365.
33. Liu, P. and Su, Z. "Thermal Stabilities of Polystyrene/Silica Hybrid Nanocomposites via Microwave-Assisted in situ Polymerization." Materials Chemistry and Physics. 94(2-3) (2005) : 412-416.

34. Zhu, X., et al. 2006. Microwave-Assisted Nitroxide Mediated Miniemulsion Polymerization of Styrene. Radiation Physics and Chemistry, In Press, Corrected Proof. Available Online at <http://www.sciencedirect.com>.
35. Correa, R., Gonzalez, G. and Dougar, V. "Emulsion Polymerization in a Microwave Reactor." Journal of Applied Polymer Science. 39 (1998) : 1471-1474.
36. ASTM DESIGNATION : D2084-93, Standard test method for rubber property-vulcanization using oscillating disk cure meter.
37. ASTM DESIGNATION : D412-92, Standard test method for vulcanized rubber and thermoplastic rubber and thermoplastic elastomers-tension.
38. ASTM DESIGNATION : D624, Standard test method for vulcanized rubber and thermoplastic rubber and thermoplastic elastomers- tear.
39. DIN DESIGNATION : 53516, Standard test method for vulcanized rubber and thermoplastic rubber and thermoplastic elastomers-abrasion resistance.

ภาคผนวก ก

การศึกษาการดูดซึบของสารละจาย
เชกิลไดรเมทซิลแอมโมเนียมในรั่มเด็บนผิวชิลิกา

ตารางที่ ก-1 ค่าการดูดซับของสารละลายน้ำมันในเมทิลเอติленโดยใช้ชีวิกลิ่น Hi-Sil 255 เมื่อใช้ชีวิกลิ่น 1 กรัม ในระบบของสารละลายน้ำมัน 20 มิลลิกรัม ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 8 (pH 8) [27]

ครั้งที่	ความเข้มข้น CTAB เริ่มต้น (ไมโครโมลาร์)	ความเข้มข้น CTAB สุดท้าย (ไมโครโมลาร์)	CTAB ที่ดูดซับ (ไมโครโมล / กรัม)
1	30000	3550	529
2	27000	1785	504
3	24000	810	464
4	21000	165	417
5	15000	95	298
6	12000	90	238
7	9000	80	178
8	25000	905	482
9	22500	425	442
10	17500	125	348
11	15000	100	298
12	12500	90	248
13	20000	330	393
14	18000	145	357
15	16000	100	318
16	14000	90	278
17	10000	80	198
18	8000	80	158
19	6000	70	119
20	59600	31400	564
21	46100	18300	556
22	59600	30800	576
23	47000	18500	570
24	24500	885	472
25	53000	25250	555

ตารางที่ ก-1 (ต่อ)

ครั้งที่	ความเข้มข้น CTAB เริ่มต้น (ไมโครโมลาร์)	ความเข้มข้น CTAB สุดท้าย (ไมโครโมลาร์)	CTAB ที่ถูกดูดซับ (ไมโครโมล / กรัม)
26	40500	12550	559
27	17800	123	354
28	3550	7050	569
29	31500	3950	551
30	27500	1650	517

ภาคผนวก ข

วิธีคำนวณการเตรียมปริมาณสารเคมี

การคำนวณหาปริมาณการใช้สารเคมีเริ่มต้น [8]

คำนวณหาปริมาณการใช้ CTAB โดยคิดจาก Bulk Concentration Below CMC (900 μM-920 μM) ซึ่งในที่นี้เลือกใช้ที่ความเข้มข้น 25000 μM โดยใช้น้ำ 1 ลิตรต่อการดูดซึมของ CTAB 482 μmol/g. silica

$$\text{CTAB}_{\text{Adsorp}} = \frac{[([CTAB]_i - [CTAB]_E) / 1000] \times V_{\text{Sol}}}{W_{\text{Silica}}}$$

โดยที่ $\text{CTAB}_{\text{Adsorp}}$ = Adsorption of CTAB (μmol/g)

$[CTAB]_i$ = Initial Concentration of CTAB Solution (μM)

$[CTAB]_E$ = Equilibrium Concentration of CTAB (μM)

V_{Sol} = Volume of Solution (ml)

W_{Silica} = Weight of Silica (g)

ตั้งนั้น $\text{CTAB}_{\text{Adsorp}}$ = 482 μmol/g. silica

$[CTAB]_E$ = 905 μM

V_{Sol} = 100 ml.

W_{Silica} = 8 g

เพรากะฉะนั้น $[CTAB]_i$ = 0.04 M

หมายถึง มี CTAB 1.456 g ในน้ำ 100 ml หรือประมาณ 1.4 g

คำนวณหาปริมาณการใช้ดัลวิเริม ($K_2S_2O_8$)

จากการวิจัยที่ผ่านมาของ Jonh H.O'Haver ใช้ ชิลิกา 160 g ต่อ CTAB 15 g ต่อ น้ำ 2000 ml ต่อ AIBN 1.15 g ต่อ Ethanol 100 ml ต่อ Monomer 6 g หรือ ใช้ ชิลิกา 8 g ต่อ CTAB 0.75 g ต่อ น้ำ 100 ml ต่อ AIBN 0.06 g ต่อ Ethanol 5 ml ต่อ Monomer 0.30 g

โดยที่ CTAB มีน้ำหนักโมเลกุล เท่ากับ 364 g/mol

$K_2S_2O_8$ มีน้ำหนักโมเลกุล เท่ากับ 270 g/mol

Isoprene มีน้ำหนักโมเลกุล เท่ากับ 68.12 g/mol และมีความหนาแน่น 0.681 g/ml

Ethanol มีน้ำหนักโมเลกุล เท่ากับ 46.07 g/mol และมีความหนาแน่น 0.791 g/ml

ตั้งนั้นปรับอัตราส่วนเชิงโมลจะได้

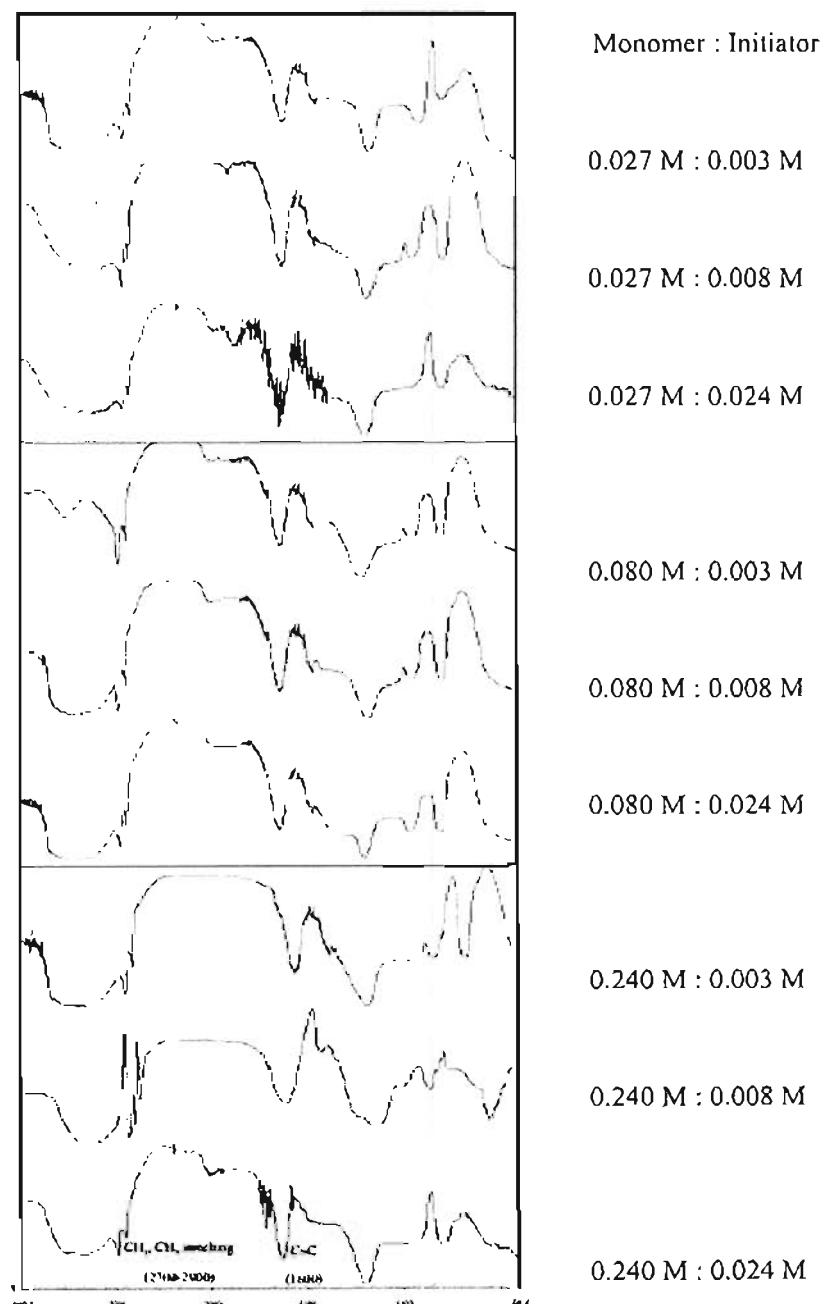
CTAB	AIBN	Ethanol	Monomer
$0.75/364 = 0.002$	$0.06/164 = 0.0004$	$(5 \times 0.791)/46.07 = 0.086$	$0.3/68.12 = 0.004$
อัตราส่วนคือ 1	: 0.2	: 43	: 2
โดยที่ CTAB 1 mol จะใช้ AIBN ในปฏิกิริยา 0.2 mol			
ซึ่งถ้าใช้ CTAB 0.004 mol จะต้องใช้ AIBN ในปฏิกิริยา $0.2 \times 0.0004 = 0.0008$ mol			
แต่ในทางปฏิบัติใช้ $K_2S_2O_8$ จึงต้องเปลี่ยน AIBN ไปเป็น $K_2S_2O_8$			
โดยที่ $K_2S_2O_8$ 1 mol จะเท่ากับ 270 g			
ถ้า $K_2S_2O_8$ 0.0008 mol จะเท่ากับ $270 \times 0.0008 = 0.22$ g			

คำนวณหาปริมาณการใช้ Ethanol
 โดยที่ CTAB 1 mol จะใช้ Ethanol ในปฏิกิริยา 43 mol
 ซึ่งถ้าใช้ CTAB 0.004 mol จะต้องใช้ Ethanol ในปฏิกิริยา $43 \times 0.004 = 0.172$ mol
 หรือ $(0.172 \times 46.07) / 0.791 = 10.02$ ml

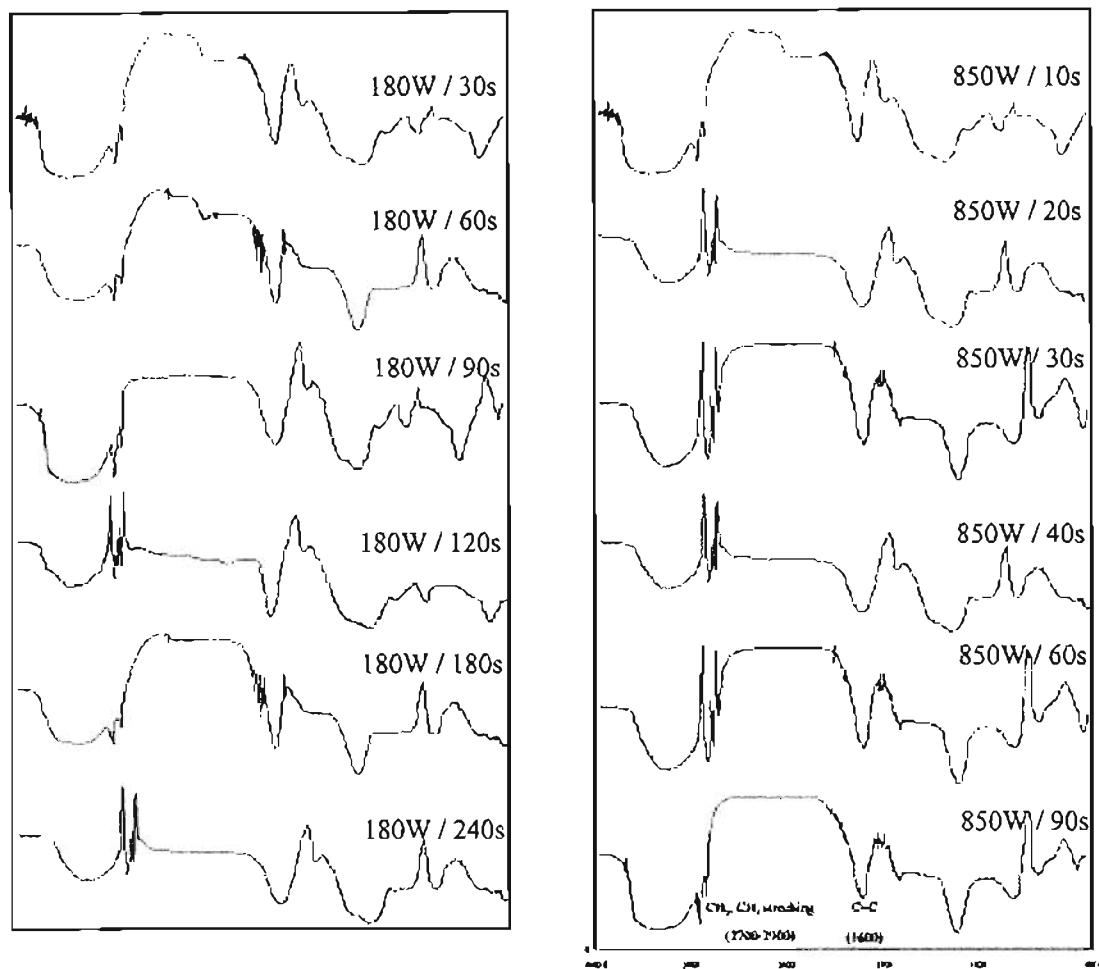
คำนวณหาปริมาณการใช้ Isoprene
 โดยที่ CTAB 1 mol จะใช้ Isoprene ในปฏิกิริยา 2 mol
 ซึ่งถ้าใช้ CTAB 0.004 mol จะต้องใช้ Isoprene ในปฏิกิริยา $2 \times 0.004 = 0.008$ mol
 หรือ $(0.008 \times 68.12) / 0.681 = 0.80$ ml
 ดังนั้นปริมาณสารเริ่มต้นที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา ในน้ำ 100 ml ที่อุณหภูมิ 80
 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง มีดังนี้
 ปริมาณ Silica = 8 g
 ปริมาณ CTAB = 1.4 g
 ปริมาณ $K_2S_2O_8$ = 0.22 g
 ปริมาณ Isoprene = 0.80 ml หรือ 0.008 mol
 ปริมาณ Ethanol = 10.02 ml หรือ 0.172 mol

ภาคผนวก ๓

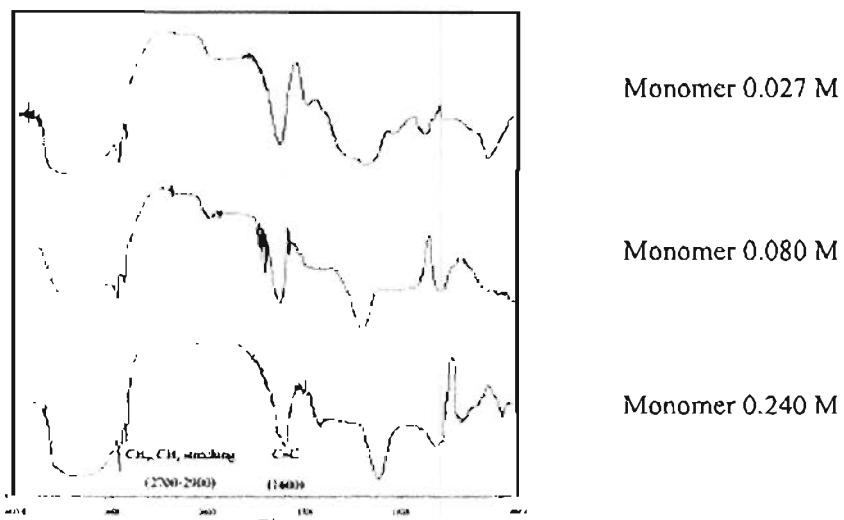
ข้อมูลจากการทดลอง



ภาพที่ ค-1 FTIR Spectra ของชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซ็นในระบบความร้อน



ภาพที่ ค-2 FTIR Spectra ของชิ้นก้าปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมเนซลาร์ พอดิเมอไรเซชันในระบบการฉ่ายคลื่นไมโครเวฟ



ภาพที่ ค-3 FTIR Spectra ของชิ้นก้าปรับปรุงผ้าด้วยกระบวนการแอดไนเซลลาร์ พอกลิเมอไรเซชันในระบบกำลังการฉายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที

ตารางที่ ค-1 แสดงค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่สภาวะต่างๆ ของระบบการใช้ความร้อน

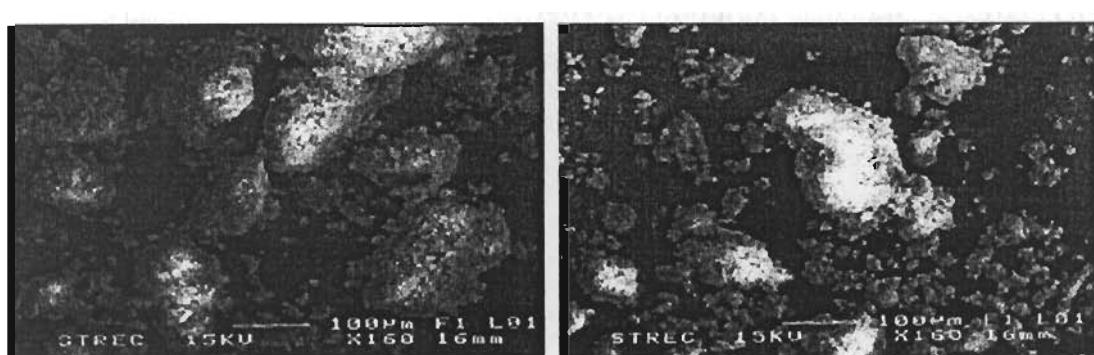
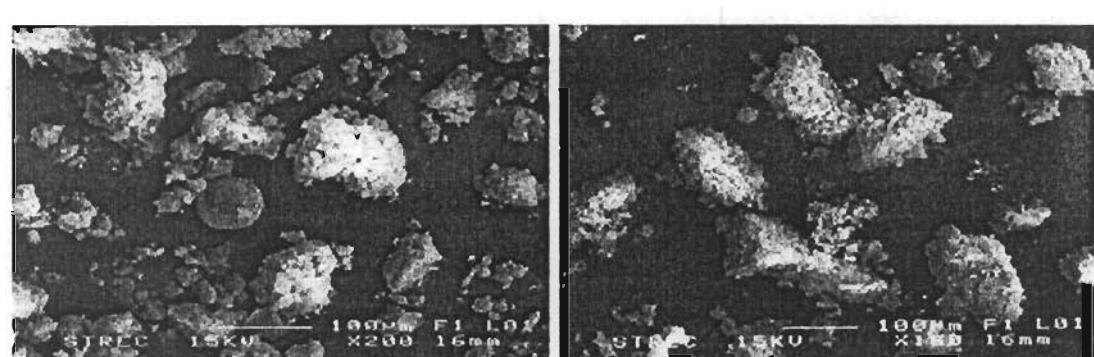
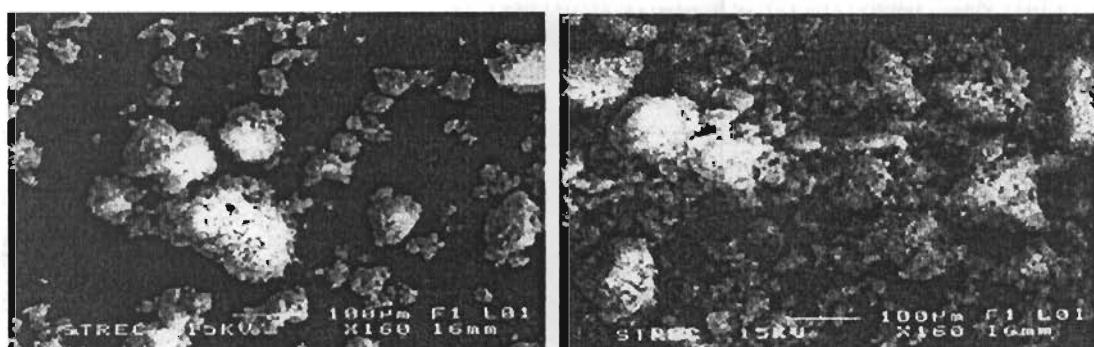
สภาวะ	ค่าการดูดกลืนแสง (cm^{-1})
Monomer : Initiator ; 0.027 M : 0.003 M	0.1500
Monomer : Initiator ; 0.027 M : 0.008 M	0.3156
Monomer : Initiator ; 0.027 M : 0.024 M	0.3121
Monomer : Initiator ; 0.080 M : 0.003 M	0.3686
Monomer : Initiator ; 0.080 M : 0.008 M	0.5977
Monomer : Initiator ; 0.080 M : 0.024 M	0.6000
Monomer : Initiator ; 0.240 M : 0.003 M	0.3645
Monomer : Initiator ; 0.240 M : 0.008 M	0.5878
Monomer : Initiator ; 0.240 M : 0.024 M	0.5898

ตารางที่ ค-2 แสดงค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่สภาวะต่างๆ ของระบบการใช้คลีนไมโครเวฟ

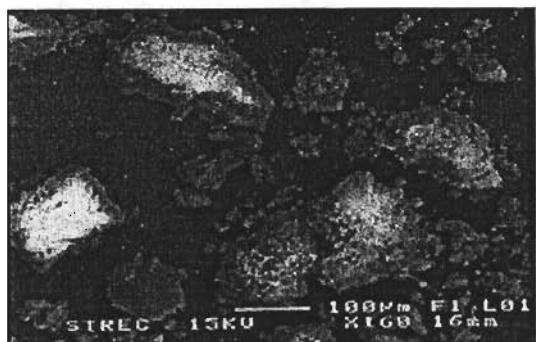
สภาวะ	ค่าการดูดกลืนแสง (cm^{-1})
180W / 30s	0.4982
180W / 60s	0.5977
180W / 90s	0.6569
180W / 120s	0.7282
180W / 180s	0.9469
180W / 240s	1.0469
850W / 10s	0.6569
850W / 20s	1.0880
850W / 30s	1.6882
850W / 40s	1.4686
850W / 60s	1.2586
850W / 90s	0.9889

ตารางที่ ค-3 แสดงค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่สภาวะต่างๆ ของระบบการใช้กำลังการฉายคลีนไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที

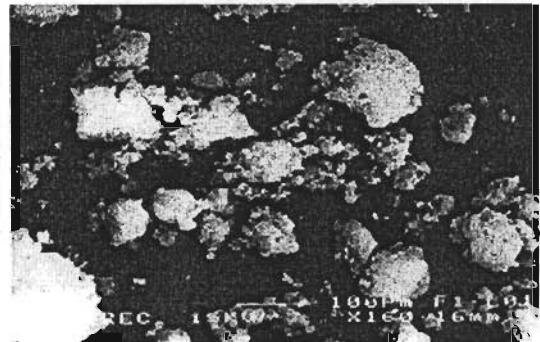
สภาวะ	ค่าการดูดกลืนแสง (cm^{-1})
Monomer : Initiator ; 0.027 M : 0.008 M	1.4897
Monomer : Initiator ; 0.027 M : 0.004 M	1.3672
Monomer : Initiator ; 0.027 M : 0.000 M	0.5456
Monomer : Initiator ; 0.080 M : 0.008 M	1.6882
Monomer : Initiator ; 0.080 M : 0.004 M	1.5252
Monomer : Initiator ; 0.080 M : 0.000 M	0.6682
Monomer : Initiator ; 0.240 M : 0.008 M	1.6820
Monomer : Initiator ; 0.240 M : 0.004 M	1.5623
Monomer : Initiator ; 0.240 M : 0.000 M	0.6891



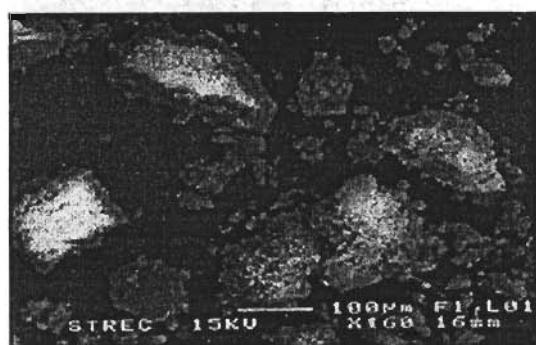
ภาพที่ ค-4 SEM Photogram ของชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไนเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชันในระบบความร้อน



Monomer : Initiator ; 0.240 M : 0.003 M

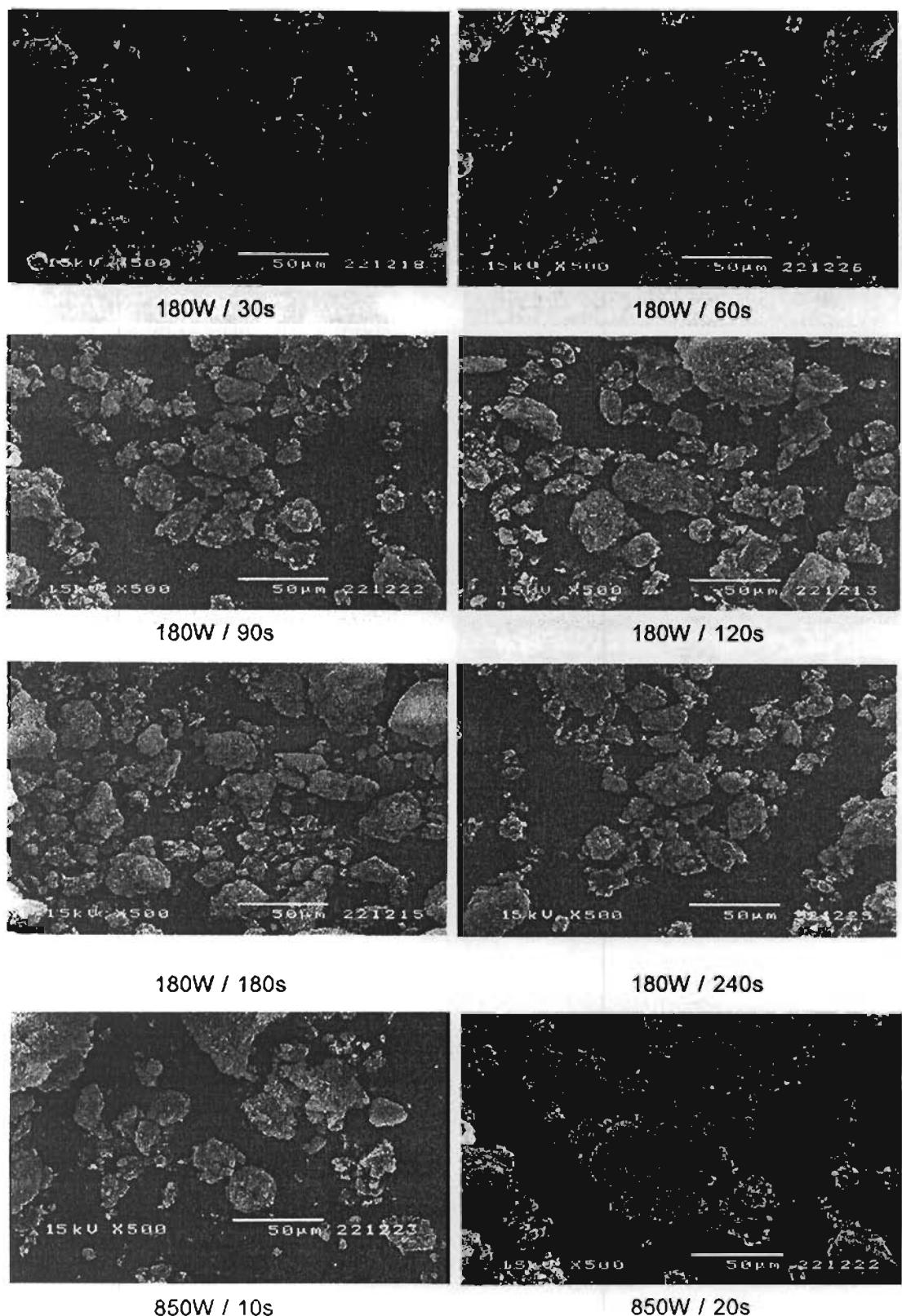


Monomer : Initiator ; 0.240 M : 0.008 M

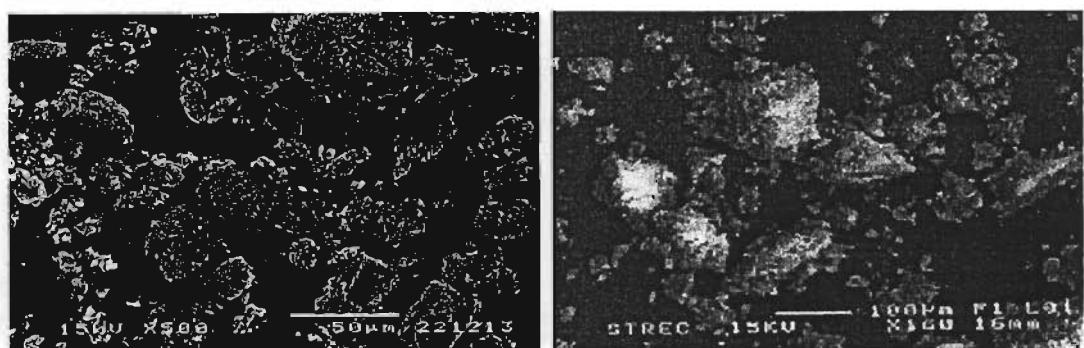


Monomer : Initiator ; 0.240 M : 0.024 M

ภาพที่ C-4 (ต่อ)

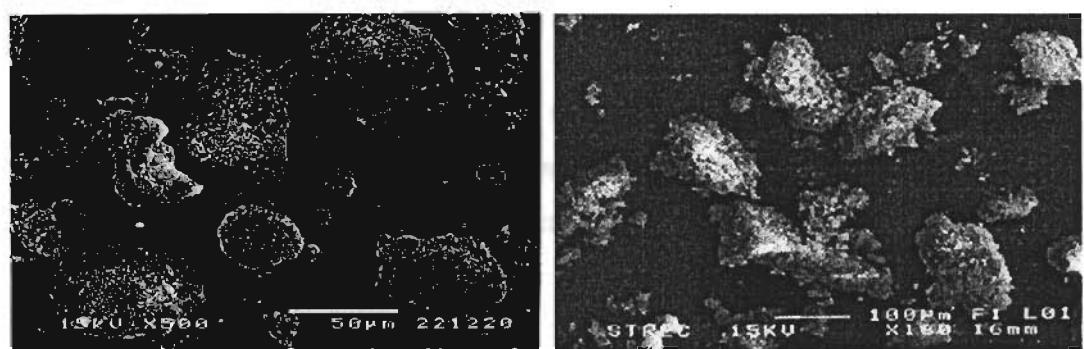


ภาพที่ ค-5 SEM Photogram ของชิลิก้าปรับปูรุ่งผิวด้วยกระบวนการเผาไม้เชลลาร์ พอลิเมอไรเซนในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ



850W / 30s

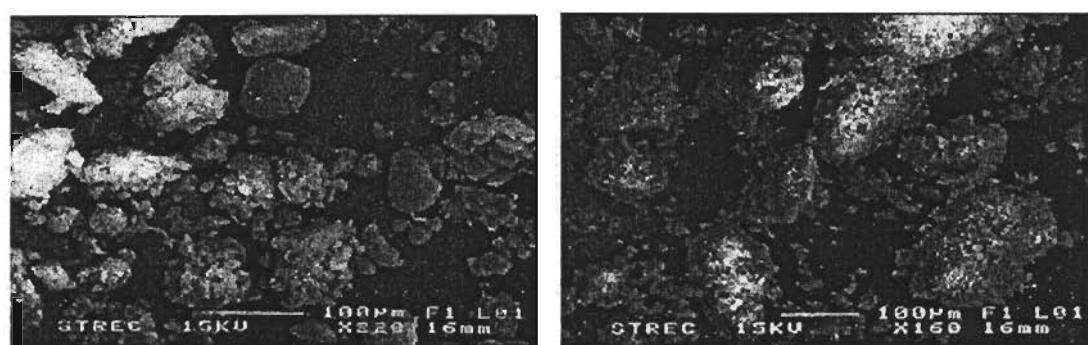
850W / 40s



850W / 60s

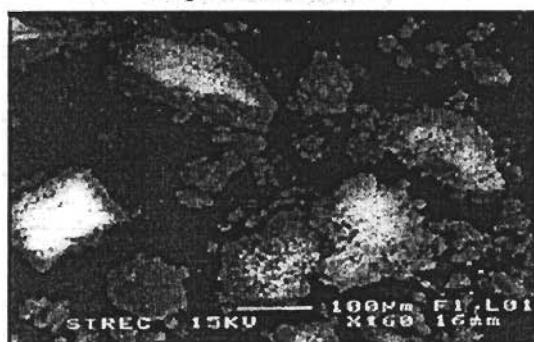
850W / 90s

ภาพที่ ค-5 (ต่อ)



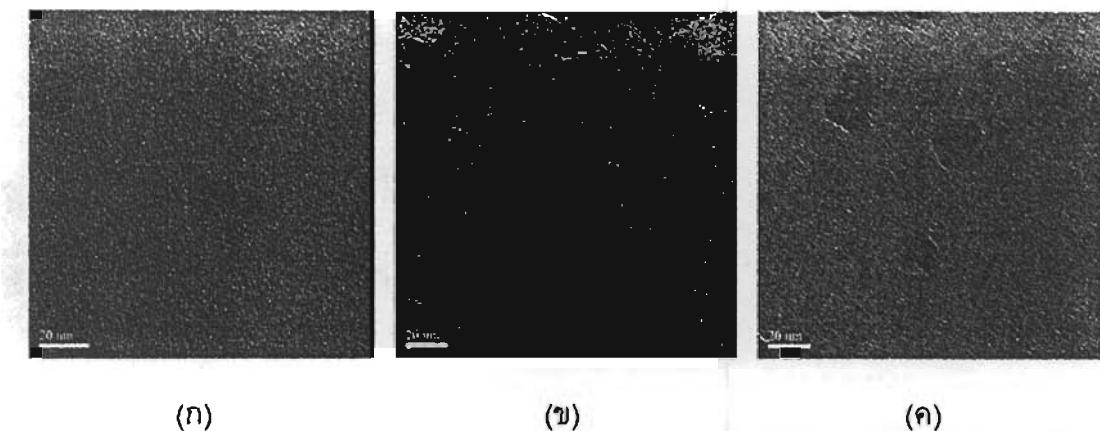
Isoprene 0.027 M

Isoprene 0.240 M



Isoprene 0.080 M

ภาพที่ ค-6 SEM Photogram ของชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไมนีเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันในระบบการใช้กำลังการฉายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาที



ภาพที่ ค-7 TEM Photogram ของชิลิกา (ก) ไม่ปรับปรุงผิว, (ข) ชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไนเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันในระบบการใช้ความร้อน และ (ค) ชิลิกาปรับปรุงผิวด้วยกระบวนการแอดไนเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันในระบบการใช้คลื่นไมโครเวฟ

ตารางที่ ค-4 แสดงผลการทดสอบสมบัติการคงรูปของยางที่ส่วนผสมต่างๆ

ชนิดของยาง	เวลาในการคงรูป (Cure Time, นาที)
ยางธรรมชาติที่ไม่ผสมชิลิกา	2.48
ยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาธรรมด้า	4.01
ยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาที่ถูกเคลือบด้วยพอยล์ไอโซพรีนในระบบความร้อน	3.18
ยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาที่ถูกเคลือบด้วยพอยล์ไอโซพรีนในระบบการฉายคลื่นไมโครเวฟ	3.01

ตารางที่ ค-5 แสดงผลการทดสอบความด้านทานต่อการขัดถูของยางที่ส่วนผสมต่างๆ

ชนิดของยาง	ค่าการสูญเสียจากการขัดถู (Abrasion Loss, mm ³)
ยางธรรมชาติที่ไม่ผสมชิลิกา	13.52
ยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาธรรมด้า	359.55
ยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาที่ถูกเคลือบด้วยพอยล์ไอโซพรีนในระบบความร้อน	165.97
ยางธรรมชาติที่ผสมชิลิกาที่ถูกเคลือบด้วยพอยล์ไอโซพรีนในระบบการฉายคลื่นไมโครเวฟ	155.63

ตารางที่ ค-6 แสดงผลการทดสอบสมบัติความต้านทานแรงดึงของยางที่ส่วนผสมต่างๆ

ชนิดของยาง	300% Modulus (kg/cm ²)	Elongation (%)	Tensile Strength (kg/cm ²)
ยางธรรมชาติที่ไม่ผสมซิลิกา	13.85	773.33	149.2
ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาธรรมชาติ	23.52	650.33	88.94
ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ถูกเคลือบด้วยโพลีไอโซพรีนในระบบความร้อน	26.76	661.67	98.54
ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ถูกเคลือบด้วยโพลีไอโซพรีนในระบบการฉายคลื่นไมโครเวฟ	28.83	670.33	109.93

ตารางที่ ค-7 แสดงผลการทดสอบสมบัติความต้านทานต่อการฉีกขาดของยางที่ส่วนผสมต่างๆ

ชนิดของยาง	ค่าความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength , kg/cm ²)
ยางธรรมชาติที่ไม่ผสมซิลิกา	70.25
ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาธรรมชาติ	39.56
ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ถูกเคลือบด้วยโพลีไอโซพรีนในระบบความร้อน	44.56
ยางธรรมชาติที่ผสมซิลิกาที่ถูกเคลือบด้วยโพลีไอโซพรีนในระบบการฉายคลื่นไมโครเวฟ	55.25

ตารางที่ ค-8 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปของชิ้นสาก่อนการรีบูตในเมล็ดลาร์พอยต์เมล็ดที่ซับในระบบการร้อนโดยอัตโนมัติ

การสกัดด้วยตัวทำละลาย THF และ ไฮคลอริน		ตัวทำละลาย			
ส่วน率	น้ำหนัก หล่อด	น้ำหนัก ตัวสกัดก่อน หดลง (กรัม)	น้ำหนักรวม ก่อนสกัด (กรัม)	น้ำหนักรวม หลังสกัด (กรัม)	ตัวทำละลาย THF %
ปริมาณ น้ำยา溶媒 (กรัม)	ปริมาณ ตัวเริ่ม (กรัม)			น้ำหนักตัวสกัด หลังสกัด (กรัม)	Toluene %
0.27	0.07	42.156	1	43.156	42.256
	0.22	42.095	1	43.095	42.231
	0.66	42.267	1	43.267	42.407
0.8	0.07	42.202	1	43.202	42.397
	0.22	42.295	1	43.295	42.553
	0.66	42.265	1	43.265	42.525
2.4	0.07	42.248	1	43.248	42.441
	0.22	42.342	1	43.342	42.602
	0.66	42.231	1	43.231	42.485
ซิลิกา	42.305	1	42.305	42.305	1

ตารางที่ ค-9 แสดงค่าเบปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปของชิลิกาที่ผ่านกระบวนการแยกไมโครสโลร์เพลเมอเรซซันในระบบการชนกตเลื่อนไมโครเวฟ โดยอาศัยการสกัดด้วยทำละลาย THF และโซลูวิน

สภาวะ	น้ำหนัก หลอด	น้ำหนัก ชิลิกาอะม สกัด (กรัม)	น้ำหนักรวม ก้อนสกัด (กรัม)	น้ำหนักรวม หลังสกัด (กรัม)	น้ำหนักชิลิกา หลังสกัด (กรัม)	ตัวกำลังเสีย THF	ตัวกำลังเสีย Toluene	ตัวกำลังเสีย weight loss
180W / 30 sec	42.964	1	43.964	43	0.964	3.6	2.6	
180W / 60 sec	42.008	1	43.008	42.098	0.91	9	6	
180W / 90 sec	42.23	1	43.23	42.3548	0.8752	12.78	10.4	
180W / 120 sec	42.248	1	43.248	42.406	0.842	15	12.8	
180W / 180 sec	42.342	1	43.342	42.55	0.792	18.1	18.2	
180W / 240 sec	42.231	1	43.231	42.471	0.76	19.07	21.9	
850W / 10 sec	42.156	1	43.156	42.289	0.867	13.3	10.3	
850W / 20 sec	42.095	1	43.095	42.372	0.723	27.7	25.2	
850W / 30 sec	42.267	1	43.267	42.62	0.647	35.3	33.3	
850W / 40 sec	42.202	1	43.202	42.521	0.681	31.9	29.3	
850W / 60 sec	42.295	1	43.295	42.597	0.698	30.2	28	
850W / 90 sec	42.265	1	43.265	42.511	0.754	24.6	22.7	
ชิลิกา	42.365	1	43.365	43.365	1	0	0	

ตารางที่ C-10 แสดงค่าเบนซ์ต์โน๊ตที่หนักที่สุดที่ผ่านกระบวนการแยกไขมันเชลลาร์พอลิเมอร์ในระบบที่เปลี่ยนความเข้มข้น
ของอะมอร์ฟและตัวเร่งพลาสติกการละลายคลื่นไมโครเวฟ 850 วัตต์ เป็นเวลา 30 วินาทีโดยอาศัยการสะท้อนด้วยการทำลาย THF
และไกส์อิน

ปริมาณ อะมอร์ฟ (กรัม)	ปริมาณ ตัวเร่ง (กรัม)	สภาวะ		น้ำหนัก	น้ำหนักชิลล์	น้ำหนักรวม	น้ำหนักคริสติก	ตัวทำลาย	ตัวทำลาย
		หลอด	ภาชนะ	หลอด	ภาชนะสักดิ์	หลังสักดิ์	หลังสักดิ์	THF	Toluene
กติกา	กติกา	กติกา	กติกา	กติกา	กติกา	กติกา	กติกา	กติกา	กติกา
0.27	0.07	42.267	1	43.267	42.62	0.647	35.3	33.3	
	0.03	42.964	1	43.964	43.294	0.67	33	32	
	0	42.267	1	43.008	42.1328	0.8752	29.5	28.74	
0.8	0.07	42.248	1	43.248	42.406	0.842	30	29	
	0.03	42.342	1	43.342	42.44	0.902	28	27.5	
	0	42.156	1	43.156	42.18	0.976	25	23.5	
2.4	0.07	42.231	1	43.231	42.304	0.927	8	7.45	
	0.03	42.095	1	43.095	42.165	0.93	7	6.8	
	0	42.23	1	43.23	42.266	0.964	5	4.2	
ซึลิกา		42.305	1	42.305	42.305	1	0	0	

ภาคผนวก ง

มาตราฐานการทดสอบยางวัลค่าในซ์

การทดสอบวัดแรงดึง ณ จุดยึดที่กำหนด (Percentage Modulus)

วัสดุที่ทดสอบ : ยาง, พลาสติก หรือ เทอร์โมพลาสติก

อุปกรณ์

1. เครื่องทดสอบแรงดึง
2. Micrometer (Guage)
3. มีดปั๊มชิ้นงาน
4. เครื่องปั๊มชิ้นงาน

วิธีการ

1. เตรียมชิ้นงานตามแบบวิธีทดสอบของแต่ละวัสดุ
2. ตั้งรายละเอียดของเครื่องดามวิธีทดสอบของแต่ละวัสดุ
3. นำชิ้นงานยึดดิบกับเครื่องทดสอบแรงดึง
4. เปิดเครื่องดึงชิ้นงานจนถึงจุดที่กำหนด ค่าแรงดึงของชิ้นงานที่ระยะห่างต่างๆ ในขณะที่ชิ้นงานยึดตัวออกจากเดิม 2 เซนติเมตร ดังนี้

- 4.1 100 % Modulus วัดที่ระยะชิ้นงานยึดได้ 4 เซนติเมตร
- 4.2 200 % Modulus วัดที่ระยะชิ้นงานยึดได้ 6 เซนติเมตร
- 4.3 300 % Modulus วัดที่ระยะชิ้นงานยึดได้ 8 เซนติเมตร
- 4.4 400 % Modulus วัดที่ระยะชิ้นงานยึดได้ 10 เซนติเมตร
- 4.5 500 % Modulus วัดที่ระยะชิ้นงานยึดได้ 12 เซนติเมตร
- 4.6 600 % Modulus วัดที่ระยะชิ้นงานยึดได้ 14 เซนติเมตร

5. คำนวณค่าการทดสอบ

$$\text{Modulus} = \frac{\text{แรงที่ใช้ดึงชิ้นงานจนถึงระยะที่กำหนด (kg)}}{\text{พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงาน (cm^2)}}$$

การทดสอบวัดการยืดตัวจนขาด (Elongation at Break)

วัสดุที่ทดสอบ : วัสดุทุกชนิด

อุปกรณ์

1. เครื่องทดสอบแรงดึง
2. Micrometer (Guage)
3. มีดปั๊มชิ้นงาน
4. เครื่องปั๊มชิ้นงาน

วิธีการ

1. เตรียมชิ้นงานตามแบบวิธีทดสอบของแต่ละวัสดุ
2. ดึงรายละเอียดของเครื่องคิดคำนวณวิธีทดสอบของแต่ละวัสดุ (เช่นเดียวกับการทดสอบวัสดุแรงดึง伸長)
3. นำชิ้นงานยึดติดกับเครื่องทดสอบแรงดึง
4. เปิดเครื่องดึงชิ้นงานจนขาด อ่านค่าระยะยืดที่ได้
5. คำนวณค่าการทดสอบ

$$\% \text{ Elongation at Break} = \frac{\text{ระยะการยืดจนขาด} - \text{ระยะที่กำหนดไว้}(2 \text{ cm})}{\text{ระยะที่กำหนดไว้}} \times 100$$

การทดสอบวัสดุแรงดึง伸長 (Tensile Strength)

วัสดุที่ทดสอบ : ยาง, ผ้า, หนัง, พลาสติก, EVA และกระดาษ

อุปกรณ์

1. เครื่องทดสอบแรงดึง
2. Micrometer (Guage)
3. มีดปืนชิ้นงาน
4. เครื่องปืนชิ้นงาน

วิธีการ

1. เตรียมชิ้นงานตามแบบวิธีทดสอบของแต่ละวัสดุ
2. ดึงรายละเอียดของเครื่องคิดคำนวณวิธีทดสอบของแต่ละวัสดุ
3. นำชิ้นงานยึดติดกับเครื่องทดสอบแรงดึง
4. เปิดเครื่องดึงชิ้นงานจนขาด อ่านค่าแรงดึงที่ได้
5. คำนวณค่าแรงดึงในหน่วยของการทดสอบแต่ละวัสดุ

กรณีของยาง, พลาสติก, โพม และ EVA

วิธีการ (ASTM D 412)

1. เตรียมชิ้นงานโดยใช้มีดปืนรูป Dumbbell ความหนา 4 mm.
2. ทำเครื่องหมาย Bench Marks ที่ชิ้นงาน ความยาว 2 เซนติเมตร ระหว่างคอดอรูป Dumbbell
3. วัดความหนาของชิ้นงาน
4. ดึงความเร็วของเครื่องทดสอบ 300 มิลลิเมตร/นาที (ดึงระบบห่างของ Clamp 4 นิ้ว) นำชิ้นงานยึดติดกับเครื่องดึง เปิดเครื่องดึงจนชิ้นงานขาด บันทึกค่าแรงดึง (วิธีทดสอบนี้สามารถทดสอบหาค่า % Modulus และค่า Elongation at Break ไปพร้อมๆ กันได้)

5. การคำนวณหาค่าแรงดึงและค่า % Modulus

$$\text{ค่าแรงดึง} = \frac{\text{แรงที่ใช้ดึงชิ้นงานจนขาด (kg)}}{\text{พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงาน (cm}^2\text{)}}$$

การทดสอบการทนต่อการสึกหรอแบบ ดี ไอ เอ็น (DIN Abrasion : DIN 53516)

วัสดุที่ทดสอบ : ยางธรรมชาติ และ ยางสังเคราะห์ ต่างๆ

อุปกรณ์

1. เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบ ดี ไอ เอ็น
2. ชุดสว่านเตรียมชิ้นงานและชิ้นทดสอบ
3. ชิ้นงานทดสอบมาตรฐานเปรียบเทียบ

ข้อกำหนดของอุปกรณ์และการทดสอบ

1. แท่น Abrasive แบบ Roller ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 ± 0.2 มิลลิเมตร และ ขนาดความยาว 500 มิลลิเมตร
2. กระดาษทรายเบอร์ 60
3. ความเร็วรอบของแท่น Abrasive คือ 40 ± 1 รอบ/นาที
4. มุมองศาการทดสอบ คือ 3° องศา
5. แรงกดชิ้นงานขณะทดสอบ 10 ± 0.2 นิวตัน
6. ระยะทางของการทดสอบ 40 ± 0.2 เซนติเมตร
7. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงานและชิ้นงานทดสอบมาตรฐานเปรียบเทียบ 16 ± 0.2 มิลลิเมตร
8. ความหนาของชิ้นงานและชิ้นงานทดสอบมาตรฐานเปรียบเทียบ 6 มิลลิเมตร
9. ความยาวของชิ้นงานที่ໂผลยื่นจากแท่นจับชิ้นงาน 2 ± 0.2 มิลลิเมตร

วิธีการ

1. เตรียมชิ้นงานและชิ้นงานทดสอบมาตรฐานเปรียบเทียบ ด้วยชุดสว่านเตรียมชิ้นงาน อย่างน้อย 3 ชิ้นงาน ชิ้นงานที่เหลือนำไปหาค่าความหนาแน่น (ชิ้นงานก่อนนำไปทดสอบให้ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่ต่ำกว่า 16 ชั่วโมง หลังจากอัดเข็นรูปเสร็จสิ้น (Vulcanized))
2. ชั่งน้ำหนักชิ้นงานและชิ้นงานทดสอบมาตรฐานเปรียบเทียบ
3. หาค่าเปรียบเทียบอ่านจากการขัดของ Abrasive ก่อนการทดสอบชิ้นงาน โดยการนำชิ้นงานทดสอบมาตรฐานเปรียบเทียบไปปั๊ดดิตกับแท่นจับชิ้นงานแล้วตั้งโปรแกรมการทดสอบของเครื่อง

4. เปิดเครื่องทดสอบให้ชิ้นงานทดสอบเคลื่อนที่เป็นระยะทาง 40 เซนติเมตร ปิดเครื่องทดสอบพร้อมทำความสะอาดแล้วนำชิ้นงานซึ่งน้ำหนัก
5. นำชิ้นงานยึดติดกับเครื่องทดสอบ ปฏิบัติการเช่นเดียวกับการทดสอบชิ้นงานทดสอบ มาตรฐานเบรียบที่บัน ปฏิบัติจนครบ 3 ชิ้นงาน หรือตามจำนวนที่ต้องการ โดยมีข้อ ปฏิบัติอย่างที่สำคัญอีก คือ
 - 5.1 กรณีที่ชิ้นงานมีน้ำหนักหายไปหลังขัดคราบระยะ 40 เซนติเมตร มากกว่า 400 มิลลิกรัม แต่ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม ให้หยุดเครื่องทดสอบที่ประมาณ $\frac{1}{2}$ ของระยะทางที่กำหนด ทำการปรับตั้งชิ้นงานใหม่ (ให้ชิ้นงานผลลัพธ์จากแท่นจับ ชิ้นงาน 2 ± 0.2 มิลลิเมตร แต่ชิ้นงานต้องเหลือความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร) เปิดเครื่องทดสอบต่อจนครบระยะทางที่กำหนด
 - 5.2 กรณีที่ชิ้นงานมีน้ำหนักหายไปหลังขัดคราบระยะ 40 เซนติเมตร มากกว่า 600 มิลลิกรัม ให้หยุดเครื่องทดสอบที่ประมาณ $\frac{1}{2}$ ของระยะทางที่กำหนด และ คำนวณค่าการทดสอบกลับให้เป็นระยะทางเทียบเท่า 40 เซนติเมตร (คูณ 2)
6. หาค่าเบรียบที่บันสำเนาจากการขัด Abrasive ด้วยชิ้นงานทดสอบมาตรฐาน เบรียบที่บันหลัง การทดสอบชิ้นงานทุกรัง โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3 และ 4
7. รายงานค่าการทดสอบเป็นปริมาตรที่หายไป จาก

$$\text{Abrasion} = \frac{200 (m_1 - m_2) \times 1000}{d \times g}$$

m_1 คือ น้ำหนักของชิ้นงานก่อนทดสอบ (กรัม)

m_2 คือ น้ำหนักของชิ้นงานหลังทดสอบ (กรัม)

d คือ ความหนาแน่นของชิ้นงานทดสอบ

g คือ ค่าความคงของกระดาษทราย

การทดสอบวัดแรงนีกขาด (Tear Strength)

วัสดุที่ทดสอบ : ยาง, พลาสติก หรือ เทอร์โมพลาสติก

อุปกรณ์

1. เครื่องทดสอบแรงดึง
2. Micrometer (Guage)
3. มีดปั๊มชิ้นงาน
4. เครื่องปั๊มชิ้นงาน

วิธีการ (ASTM D 624)

1. เตรียมชิ้นงานตามแบบวิธีทดสอบของแต่ละวัสดุ
2. วัดความหนาของชิ้นงาน ตรงตัวแทนรูปปัมมูลาก
3. นำชิ้นงานยึดติดกับเครื่องทดสอบแรงดึง
4. ตั้งความเร็วของเครื่อง เปิดเครื่องดึงชิ้นงานจนขาด อ่านค่าแรงดึงที่ได้
5. คำนวนค่าการทดสอบ

$$\text{ค่าแรงฉีกขาด} = \frac{\text{แรงที่ใช้ดึงชิ้นงานจนฉีกขาด (kg)}}{\text{ความหนาของชิ้นงาน (cm)}}$$

ผลงานทางวิชาการ

การใช้คลื่นไมโครเวฟเหนี่ยวนำให้เกิดการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน

ของพอลิไอโซพรีนสำหรับการดัดแปลงผิวซิลิกา

MICROWAVE RADIATION INDUCED ADMICELLAR
POLYMERIZATION OF POLYISOPRENE FOR SILICA SURFACE
MODIFICATION

ธีรศักดิ์ ใจชื่อดรง¹, ทิราวดุ พงศ์ประยูร¹, พิริยาธร สุวรรณมาลา²

Theerasak Jaisuetong¹, Thirawudh Pongprayoon¹, Phiriyatorn Suwanmala²

¹Department of Chemical Engineering, King Mongkut's Institute of Technology North
Bangkok, Bangkok 10800, Thailand

²Chemistry and Material Science Research Program, Office of Atoms for Peace

บทคัดย่อ: ชิลิกานิยมใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ เชิงกลผิวของซิลิกาประกอบด้วยหมู่ไซโลกเซนและไซเลนอล มีคุณสมบัติเป็นกรดและสามารถทำปฏิกิริยากับดัวเรงที่มีคุณสมบัติเป็นเบส ทำให้ยับยั้งการวัลค่าในซี นอกจากนี้ ผิวของซิลิกา เป็นข้าวและชอบน้ำจึงมีแนวโน้มอย่างสูงที่จะดูดความชื้น ซึ่งจะมีผลทำให้เวลาที่ใช้ในการบ่มช้าลง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ได้ทำการเคลือบพอลิไอโซพรีนบนผิวของซิลิกาโดยใช้คลื่นไมโครเวฟเหนี่ยวนำให้เกิด แอดไมเซลลาร์ พอลิเมอไรเซชัน ทำการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของซิลิกาที่ได้รับการดัดแปลงโดยใช้ FT-IR และการทดสอบ Hydrophobicity ผลการทดลองยืนยันว่า คลื่นไมโครเวฟสามารถเหนี่ยวนำให้พอลิไอโซพรีนเคลือบบนผิวของซิลิกาโดยการเกิด แอดไมเซลลาร์ พอลิเมอ-ไรเซชัน

Abstract: Silica is generally used as filler for natural rubber products in order to improve the mechanical properties. Silica surface posses siloxane and silanol groups. The silanol groups are acidic and interact with the basic accelerators, leading to deactivate vulcanization. Moreover, silica surface is polar and hydrophilic, it has a strong tendency to adsorb moisture, which adversely retards cure time. These affect the compatibility between silica and natural rubber. As a solution to this problem, polyisoprene was coated on silica surface by microwave radiation induced admicellar polymerization. The modified silica was characterized by FT-IR and hydrophobicity test. The results confirm that polyisoprene was successfully coated on silica surface by microwave radiation induced admicellar polymerization.

Introduction: The use of microwave radiation for the preparation and processing of polymers has received increasing interest due to significant advantages over the conventional methods. Microwave radiation can transfer energy uniformly and quickly, and complete the synthesis of polymer within a short time [1,2]. The in-situ polymerization on substrate surface within the bilayer surfactant aggregates, called "admicellar polymerization", was successfully used in many applications [3,4,5,6,7]. Fundamentally, the process of admicellar polymerization consists of three main steps, admicelle

formation, monomer adsolubilization, and polymer formation as illustrated in Figure 1. After the polymerization is complete, the upper layers of surfactant on polymeric film are washed off to expose the polymeric film coating on substrate surface. Modification of the silica surface by coating of copolymer has been accomplished by admicellar polymerization. Silica has been coated by reaction with styrene-co-isoprene [8]. The results proved that modified silica can enhance the good performance of rubber products. In this work, polyisoprene film was coated on silica surface by microwave radiation induced admicellar polymerization in order to enhanced the silica/natural rubber compatibility and therefore can use for improving rubber product performance.

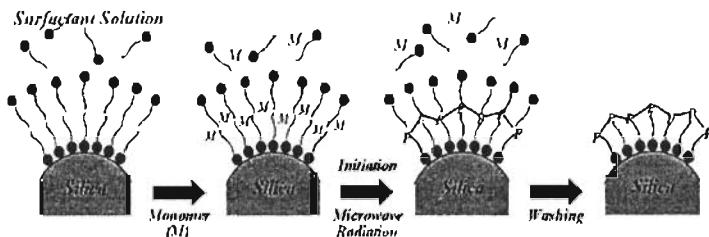


Figure 1. Admicellar polymerization process.

Methodology: Cetyltrimethylammonium bromine (CTAB) 0.7 g was added to 50 ml of distilled water. The solution was adjusted to pH 8 using 0.01 M sodium hydroxide (NaOH). 4 g of precipitated silica was added to CTAB solution and stirred for 24 hr at room temperature. Then, isoprene was added at a 1:2 mole ratio vs. adsorbed surfactant along with 4.93 ml ethanol. Then, 0.11 g of potassium persulfate was added to the reaction mixture and the reaction mixture was subjected to microwave radiation at 850 watts for 30 seconds. After admicellar polymerization, the sample was filtered, washed with distilled water to remove surfactant until the wash water no longer foamed on agitation. The modified silica was then dried at 40°C in the oven for 2 days. The modified silica was characterized by hydrophobicity test. The modified silica was soxhlet extracted with THF for 24 hr. After the solution was evaporated off, the remaining polymer was characterized by FT-IR.

Results, Discussion and Conclusion: The hydrophobicity of the modified silica was determined by dispersing modified silica and unmodified silica on the water surface. The modified silica floated on the water surface while the unmodified silica sank immediately (Figure 2). This supported that polyisoprene was coated on silica surface by microwave radiation induced admicellar polymerization. An FT-IR spectrum of the extract from modified silica was taken and compared to that of standard polyisoprene and the extract from the unmodified silica. The extract from the admicellar-treated sample shows characteristic peaks of an aliphatic carbon double bond (C=C) peak at 1600 cm^{-1} , and CH_2, CH_3 stretching peaks at $2700\text{-}2900\text{ cm}^{-1}$. These peaks are absent from the extract from unmodified silica. The spectra provide evidence of the presence of polyisoprene on the silica surface. It can be concluded that polyisoprene has been successfully coated on silica surface via microwave radiation induced admicellar polymerization.

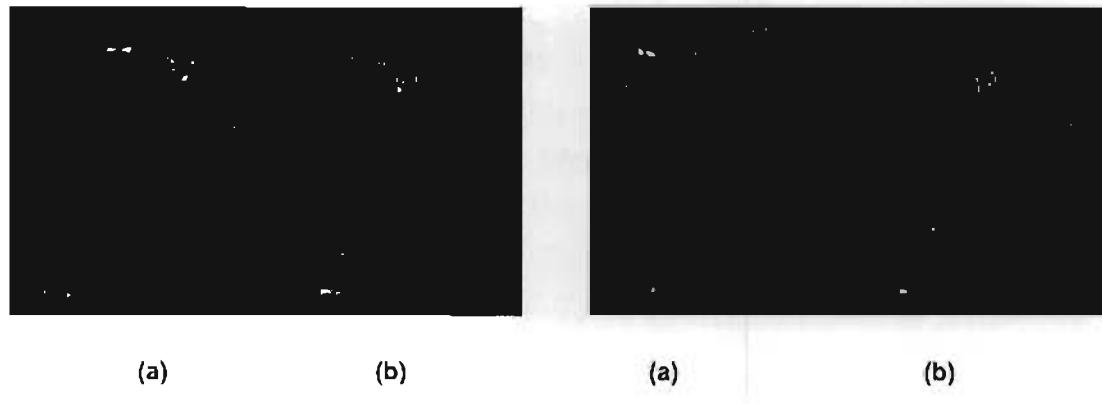


Figure2. Demonstration of hydrophobicity of modified silica and unmodified silica by floating test at side and top views; (a) modified silica and (b) unmodified silica

References:

- (1) Zhu, X. (2003) European Polymer Journal, **39**, 1187-1193
- (2) R. Correaa; G. Gonzalez; and V. Dougar (1998) Journal of Applied Polymer Science, **39**, 1471-1474
- (3) Pongprayoon, T. (2002) Journal of colloid and Interface Science, **249**, 227-234
- (4) O'Haver, J.; Harwell, J. H.; Evans, L. R.; and Waddell, W. H. (1996) Journal of Applied Polymer Science, **59**, 1427-1435
- (5) Lai, C.; Harwell, J. H.; and O'Rear, E. A., Langmuir (1995), **11**, 905
- (6) O'Haver, J.; Harwell, J. H.; O'Rear, E. A.; Snodgrass, L. J.; and Waddell, W. H., Langmuir (1994), **10**, 2588
- (7) Wu, J.; Harwell, J. H.; and O'Rear, E. A. (1987) The Journal of Physical Chemistry, **91**(3), 623-634
- (8) Nontasorn, P.; Chavadej, S.; Rangsuvigit, P.; John H.; O'Haver, J.; Chaisirimahamorakot, S.; and Na-Ranong, N. (2005) Chemical Engineering Journal, **108**, 213-218

Keywords: Admicellar Polymerization, Microwave radiation, polyisoprene, silica

Polyisoprene Coated Silica via Microwave Induced Admicellar Polymerization

¹Thirawudh Pongprayoon and ¹Theerasak

Jaisuetong

Department of Chemical Engineering, King Mongkut's

Institute of Technology North Bangkok,
Bangkok 10800, Thailand

ABSTRACT

Silica is a basic filler for natural rubber products in order to enhance the mechanical properties. The siloxane and silanol groups of silica deactivate the vulcanization of natural rubber and make the mixing difficult because of the incompatibility between the polar silica surface and the hydrophobic natural rubber surface. To solve these problems, polyisoprene, which has a similar chemical property to the main component of natural rubber (*cis*-polyisoprene), was coated on the silica surface. Admicellar polymerization is a technique to form a nanometer-thick polymeric film on a substrate surface. The technique is based on the *in-situ* reaction within bilayer adsorbed surfactant. In this study microwave was induced to initiate the admicellar polymerization in order to shorten the reaction time and uniformly generate heat in the system. The UV Spectrophotometer was an appliance to prove the presence of polyisoprene film coated on silica, and FTIR was also utilized to identify the polyisoprene film. Moreover, SEM micrographs provided the different morphologies of the modified and unmodified silica. All results obviously show that the

silica surface was completely coated by microwave induced admicellar polymerization. The optimum of microwave power and retention time for film formation, studied by UV absorbance at 236 nm, was 850 Watt for 30 min.

KEYWORDS: Admicellar Polymerization, Microwave Radiation, Modified Silica

1 INTRODUCTION

Silica is generally used as the reinforcement in order to the improvement of mechanical properties with a neutral color for commercial rubber products. However, silica lacks the compatibility of silica-rubber interface. This cause affects the poor dispersion of silica inside the rubber compound. In order to achieve the compatibility, several methods have been considerable to improve the interaction between hydrocarbon surface of rubber and inorganic silica surface. The methods consisting of bifunctional organosilanes, grafting, and *in situ* polymerization are available for silica surface modification. Within the recent, admicellar polymerization has also been proposed to be a competition method and successfully improved the mechanical properties of rubber products by coating the copolymer of styrene-butadiene and styrene-isoprene on silica surface using batch (O'Haver et al, 1996; Thammathadanukul, 1996) and continuous (Nontasorn et al, 2005) process. The mechanism of admicellar polymerization was first explained by Wu et al in 1987, and later other researchers have employed this technique to several applications using different polymers coating on different substrates (Wu et al, 1987A, 1988B; Sakhalkar et al, 1995; Gladys et al, 2000; Yaun et al,

2001; Pongprayoon et al, 2001). This process consists of three main steps: the formation of bilayer adsorbed surfactant on solid surface called "admicell", the solubilization of monomer into the inner core of admicell, and the reaction for polymer formation inside the admicell. After finishing all steps, the outer layer of surfactant must be removed to represent the polymeric film on the surface.

Fig. 1 shows the admicellar polymerization steps to modify the silica surface

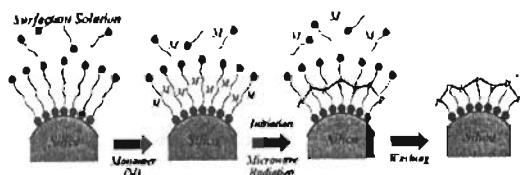


Figure 1. Admicellar polymerization process.

In this work polyisoprene, which has a similar chemical property to the main component of natural rubber (*cis*-polyisoprene), was selected to coat on the silica surface particularly for improvement of the natural rubber product. The ultra-thick polyisoprene film was synthesized on the silica surface to enhance the interaction of the interface. The thickness of polymeric film formed by admicellar polymerization determined by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) (Wei et al, 2003; Pongprayoon et al, 2005) and atomic force microscopy (AFM) (Yuan et al, 2002) was lower than 10 nm.

Microwave radiation was interested to apply for admicellar polymerization system in this work. The use of microwave for polymer synthesis has achieved in many researches. They showed the significant advantages compared with the conventional thermal heating method. Microwave radiation can provide efficiency, selective and fast polymerization method

by heating the molecular directly through the interaction between the microwave energy and molecular dipole moments of chemicals in the system. The emulsion polymerization was also successfully conducted under high power microwave radiation (Klum et al, 2000; Zhu et al, 2003A, 2003B). Using microwave as an alternative method for various polymerization reactions has been increased in the last decade.

2 EXPERIMENTAL

2.1 MATERIAL

The amorphous precipitated silica, Hi-Sil^{®255} with the specific area of $170 \pm 15 \text{ m}^2/\text{g}$, was purchased from Siam Silica Co. Ltd. Cetyltrimethylammonium Bromine (CTAB) 98% purity and Isoprene 98% purity were purchased from Fluka. Potassium persulfate ($\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$) 98% purity and tetrahydrofuran (THF) were purchased from Merck and Fisher Scientific, respectively. All materials were used without further purification

2.2 MICROWAVE INDUCE ADMICELLAR POLYMERIZATION

Cetyltrimethylammonium bromine (CTAB) 0.7 g was added to 50 ml of distilled water. The solution was adjusted to pH 8 using 0.01 M sodium hydroxide (NaOH). 4 g precipitated silica was added to CTAB solution and stirred for 24 hr at room temperature. Then, isoprene was added at the 1:2 mole ratio vs. adsorbed surfactant along with 4.93 ml ethanol. Then, 0.11 g potassium persulfate was added to the mixture for initiation and subjected to microwave radiation at 180 watt and 850 watt with varying the reaction time.

After admicellar polymerization step, the sample was filtered, washed with distilled water to remove surfactant until the wash water no longer foamed on agitation. The modified silica was then dried at 40°C in the oven for 2 days.

2.3 CHARACTERIZATION OF THE MODIFIED SILICA

The modified silica was simply examined by floating on the water surface for hydrophobicity test. The polymeric film coated on the silica modified was soxhlet extracted with THF for 24 hr. for UV observation examination to characterize and study film formation (UV-Vis500, Unicam Analtech Co.,Ltd.). Fourier Transform Infrared Spectrometer (spectrum 2000, Perkin Elmer) and Scanning Electron Microscope (JSM-5410LV, JEDL) were utilized to identify the polyisoprene film and investigate the morphology of unmodified and modified silica.

3 RESULTS AND DISCUSSIONS

3.1 SURFACE CHARACTERIZATION

After modifying silica surface by admicellar polymerization induced with microwave, the modified silica was surface tested by flotation. It was found that modified silica floated on water surface whereas the unmodified silica sank to the bottom immediately. The UV absorption of extracted THF solution of unmodified silica, modified silica and synthetic polyisoprene were measured to study the polyisoprene film formation. The results are shown in Figure 2.

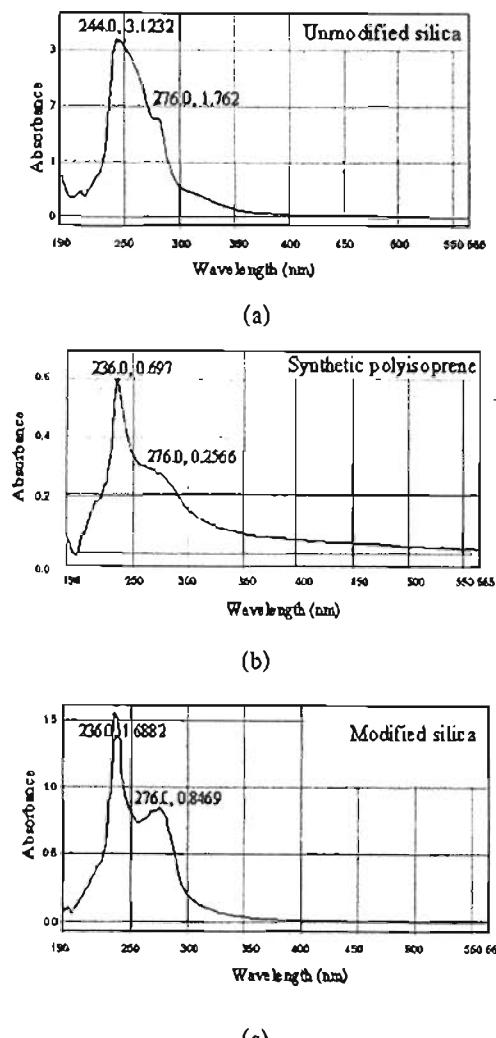


Figure 2. UV Characteristic peaks of (a) unmodified silica, (b) Synthetic Polyisoprene, (c) modified silica

The figure shows that the UV peaks of synthetic polyisoprene (Figure 2b) and the modifying silica (Figure 2c) were present at 236 nm wavelength whereas the UV peaks of unmodified silica was present at the wavelength of 244 nm. In order to confirm the success of polyisoprene film formed on silica surface by microwave induced admicellar polymerization, FTIR was also used for identification of polyisoprene film shown in Figure 3.

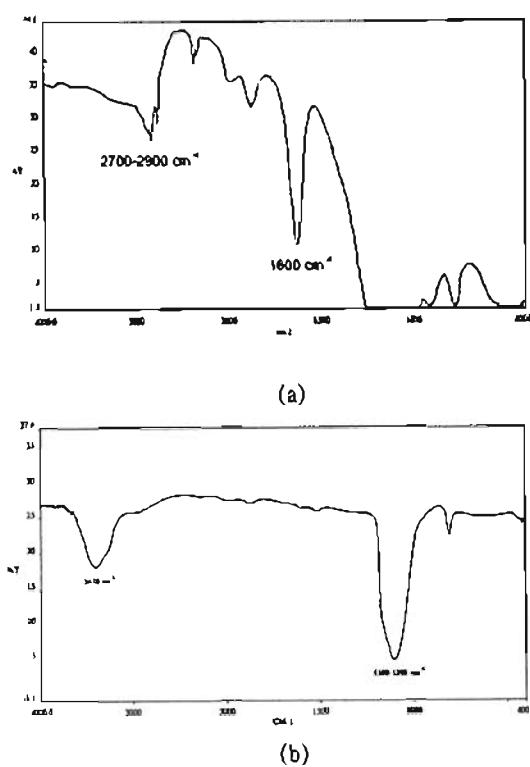


Figure 3. FTIR spectrum of (a) modified silica and (b) unmodified silica

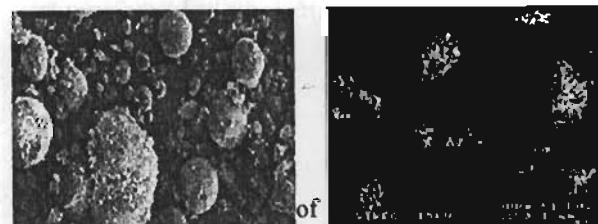
The FTIR Spectrums of the unmodified silica and the modified silica are clearly different. The sample of the modified silica shows the characteristic peaks of polyisoprene of an aliphatic carbon double bond ($C=C$) peak at 1600 cm^{-1} , and CH_2 , CH , stretching peaks at $2700\text{-}2900\text{ cm}^{-1}$, whereas the peaks of unmodified silica had no signal of polyisoprene peak. These supported the success of polyisoprene film formed on silica surface.

3.2 SEM MICROGRAPH

The SEM micrograph of the unmodified silica and the modified silica are shown in Figure 4. Comparisons between the unmodified and modified silica images showed that the surface of most modified silica sample appeared rough as compared to the surface of the unmodified silica.

3.3 THE EFFECT OF MICROWAVE POWER AND RADIATION TIME ON FILM FORMATION

The results in Table 1 show the relative effect of microwave power and radiation times on film formation observed by UV absorbance at the wavelength of $\lambda = 236\text{ nm}$.



and (b) modified silica

TABLE 1. The effect of microwave power and times on UV absorbance at the wavelength of $\lambda = 236\text{ nm}$.

Power (Watt)	Time for radiation (Sec.)	Absorbance (%)
180	30	0.4982
	60	0.5977
	90	0.6569
	120	0.7282
850	30	1.6882
	60	1.2586
	90	0.9889

The UV absorbance of using 180 w microwave power increased with the longer reaction time. This means that longer reaction time can produce higher polyisoprene film formation. For the experiment at 850 w microwave, the UV absorbance reaction were

reverse from the former experiment UV absorbance decreased when the reaction time increased. However, UV absorbance are mostly higher than that of using 180 w. The results meant the formed film was depolymerized with high microwave power and over reaction time. This behavior was similar to the study by U. Klum and A. Krzan. The results showed that the optimum condition of microwave induced admicellar polymerization was 850 w for 30 sec.

4 CONCLUSION

Microwave radiation was successfully employed to modify silica surface using admicellar polymerization in the optimum condition of 850 w microwave power and 30 s radiation time. Surface characterization by UV, FTIR and SEM were confirmed that polyisoprene film coated on silica surface.

REFERENCES

- O'Haver, J. H., Harwell, J. H., Evans, L. R., and Waddell, W. H. (1996). *J. Appl. Polym. Sci.*, 59(9), 1427-1435
- Thammathadanukul, V., O'Haver, J. H., Harwell, J. H., Osuwan, S., Na-Ranong, N., and Waddell, W. H. (1996). *J. Appl. Polym. Sci.*, 59(11), 1741-1750
- Nontasorn, P., Chavadej, S., Rangsuvigit, P., O'Haver, Chaisirimahoramakot, S., and Na-Ranong, N. (2005). *Chem. Eng. J.*, 108, 213-218
- Wu, J., Harwell, J. H., and O'Rear, E. A. (1987A). *J. Phys. Chem.*, 91, 623-634
- Wu, J., Harwell, J. H., and O'Rear, E. A. (1987B). *Langmuir* 3, 531-537
- Sakhalkar, S. S., and Hirt, D. E. (1995). *Langmuir* 11, 3369-3373
- Glady, B. P., O'Rear, E. A., Penn, L. S., and Pedicini, A. (1998). *Polymer Composites* 19, 579-587
- Cho, G., Glatzhofer, D. T., Fung, B. M., Yuan, W., and O'Rear, E. A. (2000). *Langmuir* 16, 4424
- Yuan, W., O'Rear, E. A., Cho, G., Funkhouser, G. P., and Glatzhofer, D. T. (2001). *Thin Solid Films* 358, 96-108
- Pongprayoon, T., Yanumet, N., and O'Rear, E. A. (2001). *J. Colloid Interface Sci.* 249, 227-234
- Wei, X., Carswell, A. D.W., Alvarez, W. E., and Grady, B. (2003). *J. Colloid Interface Sci.* 264, 296-300
- Pongprayoon, T., Yanumet, N., O'Rear, E. A., Alvarez, W. E., and Resasco, D. E. (2005). *J. Colloid Interface Sci.* 281, 307-315
- Yuan, W.L., O'Rear, E. A., Grady, B. P., and Glatzhofer, D. T. (2002). *Langmuir*. 18, 3343-3351
- Klum, U. and Krzan, A. (2000). *Rapid microwave induced depolymerization of polyamide-6*, *J. Appl. Polym. Sci.*, 41, 4361-4365
- Zhu, X. Chen, J. Zhou, N. Cheng, Z. and Lu, J. (2003A). *Emulsion Polymerization of Methyl Methacrylate under Pulsed Microwave Irradiation*, *European Polymer Journal*. 39, 1187-1193
- Zhu, X. Chen, J. Zhou, N. Cheng, Z. and Lu, J. (2003B). *Emulsion Polymerization of Styrene under Pulsed Microwave Irradiation*, *J. Appl. Polym. Sci.*, 89, 28-35.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ : นายธีรศักดิ์ ใจสืบธรรม
 ชื่อวิทยานิพนธ์ : การใช้คลื่นไมโครเวฟเหนี่ยวนำให้เกิดการแอดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์ไซซ์ัน
 ของพอลิไอโซพรีนสำหรับการปรับปรุงผิวซิลิค้า
 สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี

ประวัติ

ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2523 สถานที่ติดต่อ ภาควิชาเคมี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม
 เมืองบางปะอู จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 8236, 8230
 โทรสาร 0-2587-0024

ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2541-2544 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์
 บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประวัติการฝึกงาน เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2543 เข้าฝึกงานที่ บริษัท Global Utilities Services Co., Ltd.

ผลการวิจัย

1. Theerasak Jaisuetong, Thirawudh Pongprayoon and Phiriyatorn Suwanmala.
 Microwave Radiation Induced Admicellar Polymerization of Polyisoprene for Silica Surface Modification. In 31st Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2005, Nakhonrachasima.

2. Theerasak Jaisuetong and Thirawudh Pongprayoon. Polyisoprene Coated Silica via Microwave Induced Admicellar Polymerization. งานประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 ปี พ.ศ. 2549